

整理 No.	タイトル	著者	巻	号	ページ	発行年	記事の種類	分野 - 1	キーワード
5347	巻頭言: 表面技術文化への期待	沖 猛雄	46	1	1	1995	1:巻頭言		
5348	血漿分離と膜	酒井清孝	46	1	2	1995	3:解説	その他	血漿分離, ろ過, 血液ろ過, ろ過膜
5349	固体表面の構造と反応性	内藤周弼	46	1	7	1995	3:解説		表面, 構造, 触媒, 反応
5350	ウェットプロセスから見ためっき皮膜の密着性	平松 実, 日野 実	46	1	13	1995	3:解説	無電解めっき	密着性, めっき皮膜, 母材, 界面, ウェットプロセス
5351	合金めっき開発と用途展開	榎本英彦	46	1	19	1995	3:解説	電気めっき・電鍍	合金めっき, Sn-Ni合金めっき, Zn-Ni合金めっき
5352	合金電気めっき鋼板の機能	渋谷敦義	46	1	24	1995	3:解説	電気めっき・電鍍	電気めっき, 自動車用合金めっき, Zn-Ni合金, Zn-Fe合金
5353	高濃度シアン含有めっき廃液処理技術	小嶋隆司, 中田 淳, 河野 誠, 大西彬, 横山一男	46	1	28	1995	3:解説		シアン化合物, めっき廃液, 熱加水分解法, 微生物処理
5354	重ね蒸着膜の内部応力を用いた付着力測定方法	金原 燦, 近藤市治, 神谷豊晴, 竹中 修, 小早川紘一, 森下和晃, 佐藤祐一, 富士元英二	46	1	33	1995	11:アカデミック研究会シリーズ	物理蒸着(PVD)	薄膜, 密着性, 測定法
5355	EQCMのめっきモニターへの応用	伊藤和生, 久米道之	46	1	37	1995	6:技術論文	電気めっき・電鍍	EQCM, 電気めっき膜厚モニター
5356	1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸溶液からのSn-Sb合金の電析	河野 誠, 永田 淳, 小嶋隆司, 大西彬, 横山一男	46	1	42	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	電析, Sn-Sb合金, 酸化HEDP溶液
5357	めっき廃液の熱加水分解処理	榎 永康, 沖 猛雄	46	1	47	1995	5:原著論文		熱加水分解法, シアン化合物, 硫化物
5358	光沢非シアン化銀めっきのアノード挙動	榎 永康, 沖 猛雄	46	1	52	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	非シアン化銀電気めっき, アノード溶解, 添加剤, 硫酸
5359	光沢非シアン化銀めっきの電析挙動	赤司澄夫, 小泉達也, 広渡和緒, 松田虫明, 克彦, 松坂菊生, 増子 昇, 額賀栄二, 秋葉幸男, 黒須植生, 飯田昌盛, 広瀬洋一, 吉村俊一, 吉原佐知雄, 白樫高史, 佐藤栄一	46	1	64	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	非シアン化Ag-Znめっき浴, 亜鉛イオン, 分極, チオ硫酸
5360	酸性地熱水中の1,4-ジ(チオシアナトメチル)ベンゼンによる鋼の腐食抑制	赤司澄夫, 小泉達也, 広渡和緒, 松田虫明, 克彦, 松坂菊生, 増子 昇, 額賀栄二, 秋葉幸男, 黒須植生, 飯田昌盛, 広瀬洋一, 吉村俊一, 吉原佐知雄, 白樫高史, 佐藤栄一	46	1	64	1995	5:原著論文		腐食抑制, 鋼, 1,4-ジ(チオシアナトメチル)ベンゼン, 二相流体
5361	触媒塗布液へのシリカゾル添加によるチタン基体イリジウム電極の長寿命化	額賀栄二, 秋葉幸男, 黒須植生, 飯田昌盛, 広瀬洋一, 吉村俊一, 吉原佐知雄, 白樫高史, 佐藤栄一	46	1	70	1995	5:原著論文		IrO ₂ /Ti電極, 寿命, シリカゾル, 寿命, 酸素発生
5362	CVDダイヤモンド薄膜合成における水の添加効果	額賀栄二, 秋葉幸男, 黒須植生, 飯田昌盛, 広瀬洋一, 吉村俊一, 吉原佐知雄, 白樫高史, 佐藤栄一	46	1	75	1995	7:速報論文	化学蒸着(CVD)	CVDダイヤモンド, 水添加, 成長速度, 膜厚, 抵抗
5363	フラッシュ焼鈍による鉄電析膜の磁気挙動と物性	青木公二, 鷹野 修, 金 東賢, 青木公二, 鷹野 修	46	1	77	1995	8:Letters	熱処理(酸化・窒化・炭化)	鉄皮膜, 電析, 磁気特性, フラッシュ焼鈍, 結晶粒径サイズ
5364	無電解Ni-Pt-P合金めっきについて	青木公二, 鷹野 修, 金 東賢, 青木公二, 鷹野 修	46	1	79	1995	8:Letters	無電解めっき	無電解めっき, Ni-Pt-P合金, 析出速度, 組成, 構造
5365	無電解Ni-Co-Fe-P合金系軟質磁性膜の作製	青木公二, 鷹野 修, 大坂敏明	46	1	81	1995	8:Letters	無電解めっき	無電解めっき, 軟磁性膜, Ni-Co-Fe-P合金, 保磁力
5366	巻頭言: 価値の容認	川本武史	46	2	87	1995	1:巻頭言		
5367	日本の省エネルギー対策について	川本武史	46	2	88	1995	2:総説		地球環境問題, 長期エネルギー供給と需要の見通し, 省エネルギー, エコマテリアル, 環境問題, リサイクル, ライフサイクル分析
5368	表面技術とエコマテリアル化	原田幸明	46	2	91	1995	3:解説		省エネルギー, 省資源, 湿式めっきにおける省エネ・省資源
5369	各種表面処理の省エネ・省資源 - 湿式めっきにおける省エネ・省資源	星野芳明	46	2	98	1995	3:解説		省エネ・省資源, 乾式めっきにおける省エネ・省資源
5370	各種表面処理の省エネ・省資源 - 乾式めっきにおける省エネ・省資源	池永 勝	46	2	105	1995	3:解説		直接浸炭法と低歪焼入油槽
5371	各種表面処理の省エネ・省資源 - 直接浸炭法と低歪焼入油槽	川村敏行	46	2	112	1995	3:解説	熱処理(酸化・窒化・炭化)	変成炉除去, 浸炭, 低歪め, 省コスト
5372	各種表面処理の省エネ・省資源 - 化成処理における省エネ・省資源	西澤嘉彦	46	2	118	1995	3:解説	化成処理	りん酸処理, 省エネルギー
5373	各種表面処理の省エネ・省資源 - 溶射における省エネ・省資源	仲川政宏, 佐々木光正	46	2	124	1995	3:解説	溶射	溶射, 省エネルギー, 省資源, 堆積効率
5374	各種表面処理の省エネ・省資源 - 省エネ・省資源と粉体塗装	小林照二, 五十嵐博	46	2	132	1995	3:解説	塗布・塗装	パウダーコーティング, VOC, 省資源
5375	部品加工プロセスの省エネ・省資源 - 半導体・液晶工場における排水回収再利用	桐生草平	46	2	138	1995	3:解説		再生利用, 半導体製造工場, LCD製造工場
5376	部品加工プロセスの省エネ・省資源 - 雰囲気熱処理における省エネルギー	松井勝幸	46	2	144	1995	3:解説	熱処理(酸化・窒化・炭化)	省エネルギー, 雰囲気制御, 熱処理
5377	氷の空気搬送法による高密度熱輸送 "小特集 / 省エネ・省資源と表面処理" によせて	梁取美智雄, 岩淵邦寺門一佳	46	2	149	1995	3:解説		氷, エネルギー輸送, 空気搬送法
5378	イオン窒化法によるニッケル合金の表面硬化化に及ぼす窒化条件の影響	真喜志隆, 中田一博, 松田福久	46	2	155	1995	5:原著論文	熱処理(酸化・窒化・炭化)	窒化, プラズマ窒化, 表面硬化, ニッケル, Ni合金
5380	SUS310Sステンレス鋼の機械的性質に及ぼすアルミニウム拡散被覆の影響	佐々木雅啓, 井形直弘	46	2	162	1995	5:原著論文	拡散皮膜	アルミニウム拡散皮膜, SUS310Sステンレス鋼, Fe-Al金属間化合物, 機械的特性
5381	トリエタノールアミン浴からの無電解銅めっきに及ぼす添加剤的作用	小谷野英勝, 吉川明, 加藤正義, 牧野英司, 川勝由美	46	2	170	1995	5:原著論文	無電解めっき	無電解銅めっき, 銅 - トリエタノールアミン浴からのめっき
5382	レーザーブレーティングによるAuのライン状パターンの形成	柴田隆行, 池田正幸	46	2	177	1995	5:原著論文	物理蒸着(PVD)	レーザーブレーティング, 金ライン状パターン, アルゴンレーザー, ビームスキャン, 析出速度
5383	非シアンAgめっき浴における電析物の表面形態及び構造に対する亜鉛イオン添加	榎 永康, 沖 猛雄	46	2	183	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	電析物の表面形態および構造, 亜鉛イオン, チオ硫酸
5384	1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸溶液からの電析したスズ-アンチモン合金	伊藤和生, 久米道之	46	2	190	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	電析, Sn-Sb合金構造, アモルファス
5385	巻頭言: "表協誌"のあゆみ	大野 涼	46	3	203	1995	1:巻頭言		
5386	エレクトロニクス実装技術の現状と今後の	二瓶公志	46	3	204	1995	2:総説		電子部品技術, 表面実装技術
5387	基板材料と表面処理技術 - ポリイミド基板	小笠原修一	46	3	210	1995	3:解説	無電解めっき	ポリイミド, 無電解めっき, 電気めっき, 密着性, 応力
5388	電子部品の搭載方式と表面処理技術	高木 清	46	3	216	1995	3:解説		LSI実装技術, 多層配線板, ビルドアッププロセス
5389	実装形態と接合技術	畑田賢造	46	3	223	1995	3:解説		実装技術, 接合技術, 集積技術
5390	表面実装上の不具合と解析の実例	野末正仁, 堀井宏裕, 渡部泰暁	46	3	230	1995	3:解説		表面実装技術, 窒素リフロー, ウィッキング, ディウェッティング, 自動光学検査
5391	金属皮膜固定抵抗器	進藤泰宏, 岡田義夫	46	3	235	1995	トピックス	無電解めっき	めっき, 電気抵抗, 抵抗器
5392	小型電子機器の実装部品	奥田武文	46	3	239	1995	トピックス		電子部品, 電子機器
5393	"小特集 / 電子部品の表面実装" によせ	増田良一	46	3	215	1995			
5394	高潤滑防錆鋼板	山下正明	46	3	244	1995	5:原著論文	化成処理	無潤滑油, 潤滑, 無脱脂, プレス成
5395	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(35) - 昇温脱離分析のシリコン表面評価への応用	飯本周邦	46	3	249	1995	9:シリーズ-2		シリコン, LSI, 絶縁体, 酸化, 昇温脱離分析

5396	非シアン化浴からのAg - La2O3分散めっき	稽 永康, 沖 猛雄	46	3	253	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	非シアン化浴, 分散めっき, ランタン酸化物, 添加剤
5397	ろう接による窒化ケイ素セラミックス / 活性金属Tiの接合界面の変化挙動	王 立録, 沖 猛雄	46	3	260	1995	5:原著論文		活性金属接合, 窒化ケイ素セラミックス, Ti反層, TiN, 結合力
5398	クロレート皮膜の高分化に及ぼすシリカの影響	須田 新, 川口 純, 荻野陸雄	46	3	265	1995	5:原著論文	塗布・塗装	塗布型クロレート皮膜, シリカ, 熱分析, 質量分析
5399	電位制御によるアルミニウム箔の交流エッチングに及ぼす塩酸濃度と溶液温度の影響	鐘 暉, 沖 猛雄	46	3	270	1995	5:原著論文	化学エッチング・電解エッチング	交流エッチング, アルミニウム箔, 電位制御, 温度, HCl濃度
5400	ガス吸着による多孔質アルミニウム陽極酸化の異常細孔形の推定	野中 昭	46	3	276	1995	13:研究ノート	アノード酸化	アルミニウム陽極酸化, 孔形状, 蒸気吸着, 吸着ヒステリシス, n-ブチルベンゼン蒸気吸着
5401	酸性溶液中における無電解ニッケルめっき皮膜の水素発生挙動	王 為, 仲村太一	46	3	278	1995	8:Letters	無電解めっき	水素発生, 酸性溶液, 無電解Ni析出, 濃度
5402	巻頭言: 表面技術について	今井八郎	46	4	285	1995	1:巻頭言		
5403	"小特集 / 電極表面修飾とその応用"によせて	湯浅 真	46	4	286	1995	2:総説	?	電解重合法, 機能性電極, イオンセンサー, 高分子電池
5404	(有機)導電材料 - 電解重合による電極表面修飾	門間聰之, 逢坂哲彌	46	4	287	1995	3:解説		電解重合, 機能性電極, 高分子電池, イオンセンサー
5405	(有機)導電材料 - 電子機能分子の表面修飾	西原 寛	46	4	292	1995	3:解説		炭素膜, フラレーン, 電解重合法, 共役金属錯体
5406	電極触媒 - 貴金属関連化合物(Piなどの)の表面修飾 - リン酸燃料電池用電極触媒の開発動向	真岡忠則, 上野三司	46	4	297	1995	3:解説		燃料電池, 電極触媒, Pt合金, 触媒活性, 結晶構造
5407	電極触媒 - 電極触媒としての大環状化合物の表面修飾	湯浅 真	46	4	303	1995	3:解説		表面修飾, 電極触媒, 大環状化合物
5408	デバイス関連 - 分子配向膜を用いた電極表面修飾	相樂隆正, 中嶋直敏	46	4	311	1995	3:解説		配向, チオール, 自己集合単層, 脂質二分層
5409	デバイス関連 - 感光性タンパク質の電極修飾とデバイスへの応用	宮坂 力, 小山行一	46	4	317	1995	3:解説		分子エレクトロニクス, タンパク質, バクテリオロドプシン, 光電変換, イメージセンサー
5410	センサ - ハイドロゲルの相転移と電極表面修飾	渡辺正義	46	4	324	1995	3:解説		ハイドロゲル, 体積相転移, 電極修飾
5411	センサ - 生体分子による電極表面の修飾	末永智一, 河西奈保子, 内田 勇	46	4	331	1995	3:解説		機能性バイオセンサー, Redox Euzymes, 抗原 - 抗体, (Electrochemical Immunoassay)
5412	シリーズ / 表面物性評価技術 - 表面状態の解析(36) - 反射高速電子線回路(RHEED)とエビタキシャル成長	坂本邦博	46	4	336	1995	9:シリーズ-2	物理蒸着(PVD)	RHEED, 表面分析, エビタキシャル成長, MBE
5413	シリーズ開始にあたって	*	46	4	341	1995	9:シリーズ-2		?
5414	シリーズ / 現場管理技術 - 湿式法(1) - 亜鉛めっきの前処理	高木幹晴, 鈴木征夫	46	4	342	1995	9:シリーズ-2	洗浄	アルカリ洗浄, 自動フィードシステム, 前処理, 亜鉛めっき
5415	シリーズ / くらべてみよう(1) - 記録・記憶	松原 浩	46	4	348	1995	10:比べてみよう	?	記録, 記憶媒体, 記録方式
5416	ホウ素のプラズマ化学輸送を用いた窒化ホウ素薄膜の作製	瀧 優介, 賀曾利裕, 伊藤 滋, 明石和夫	46	4	351	1995	5:原著論文	化学蒸着(CVD)	窒化ホウ素膜, RFプラズマ, CVD, プラズマ化学輸送, ボロンパウ
5417	置換スズめっき処理によるはんだめっきの改質	小谷野英勝	46	4	358	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	電気はんだめっき, 置換スズ, 再生利用
5418	耐食性チタン合金Ti - 0.5%Ni - 0.05%Ru(ASTM-Grade13)の塩酸水溶液を用いた腐食面の観察	滝 千博, 作山秀夫	46	4	365	1995	5:原著論文		腐食表面, Ti2Ni, チタン合金, 微細構造, 腐食速度
5419	電着ダイヤモンド砥石におけるニッケル膜の単粒に対する保持力	佐藤金司, 横山俊雄, 鈴木数夫	46	4	371	1995	5:原著論文	泳動電着	ダイヤモンド砥石, 電着, 単粒, 研磨力
5420	レーザー照射によるパラジウムの無電解めっき	佐藤祐一, 梁瀬正和, 吉田昌弘, 西山卓, 小早川純一, 天楠 文代, 大江慶司, 石原正道, 高村喜代	46	4	375	1995	8:Letters	無電解めっき	レーザー照射無電解めっき, 無電解Pdめっき, 添加剤, トリウムイオン
5421	人工唾液中複方ヨドグリセリンによる歯科用Ni - Cr合金からのNiイオンの溶出	浦尾亮一	46	5	389	1995	1:巻頭言	?	歯科用Ni - Cr合金, ニッケル溶出, 人工ヨドグリセリン
5422	巻頭言: 表面技術が俵せ色に染まるとき	高橋英明	46	5	390	1995	2:総説	アノード酸化	アノード酸化皮膜, アルミニウム, バルブ金属
5423	最近のアノード酸化皮膜の研究動向と応用	高橋英明	46	5	390	1995	2:総説	アノード酸化	多孔質シリコン, 陽極酸化, 可視光発光
5424	多孔質シリコンの陽極酸化	伊藤利道, 平木昭夫	46	5	396	1995	3:解説	アノード酸化	バルブ金属, 陽極酸化, イオン移動過程
5425	バルブ金属のアノード酸化	清水健一, 小林健三	46	5	402	1995	3:解説	アノード酸化	マグネシウム, 表面処理, 陽極酸化, 皮膜組成
5426	マグネシウムの陽極酸化	高谷松文	46	5	410	1995	3:解説	アノード酸化	陽極酸化皮膜, 着色法, 電解発色, 自然発色, 干渉発色
5427	陽極酸化皮膜の着色	黒田孝一	46	5	415	1995	3:解説	アノード酸化	陽極酸化アルミナ, メタルポーラスメンブレン
5428	陽極酸化アルミナを用いた高規則性メタルポラスメンブレンの作製と応用	益田秀樹	46	5	420	1995	トピックス	アノード酸化	触媒, 陽極酸化, 調整方法
5429	アルミニウム陽極酸化皮膜による連続触媒体の開発	亀山秀雄, 村田 究, 寺井 聡, 豊嶋勇作	46	5	425	1995	トピックス	アノード酸化	
5430	"小特集 / アノード酸化 - 製法, 機能及び応用"によせて	堀口 誠	46	5	428	1995	?	?	
5431	シリーズ / 現場管理技術 - 湿式法(2) - 亜鉛めっき浴の管理のポイント	青江徹博	46	5	429	1995	9:シリーズ-2	電気めっき・電鍍	光沢, トラブルシューティング, シアン化浴, ジンケート浴, 亜鉛めっき
5432	シリーズ / くらべてみよう(2) - STMとAFM	堀口 誠	46	5	435	1995	10:比べてみよう		走査型トンネル顕微鏡, 原子間力顕微鏡
5433	塗布型クロメートの耐食性に及ぼすシリカの添加効果	須田 新, 川口 純, 荻野陸雄	46	5	437	1995	5:原著論文	塗布・塗装	塗布型クロレート皮膜, シリカ, 耐食性, 交流インピーダンス, 光電子
5434	RFプラズマで窒化したTiの特性と窒化層の破壊強さ	南部俊和, 竹本幹男	46	5	442	1995	5:原著論文	熱処理(酸化・窒化・炭化)	アコースティックエミッション, 薄膜, 破壊強さ, 窒化チタン, RFプラズマ
5435	白金電極上での次亜リン酸イオンの酸化反応	王 為, 仲村太一	46	5	450	1995	5:原著論文	無電解めっき	H2PO2-, 陽極酸化, 無電解めっき, 酸化機構
5436	負荷中に発生する弾性波の定量解析による気相蒸着Ti(C,N)膜の力学特性と内部応力	小川真吾, 深井利嗣, 二木 崇, 竹本幹男	46	5	456	1995	5:原著論文	物理蒸着(PVD)	Ti(C,N), アコースティックエミッション, 内部応力, ARE, Source Inversion
5437	シリカを添加したクロレート皮膜の断面構造	高橋 彰, 仲澤真人	46	5	464	1995	13:研究ノート	塗布・塗装	クロレート, シリカ, 亜鉛めっき鋼板
5438	巻頭言: 協会財政の危機	橋本康彦	46	6	475	1995	1:巻頭言		
5439	"小特集 / 環境による構造物の劣化とその対策"によせて	茅根道生	46	6	476	1995	?	?	環境, 構造物劣化, 維持管理
5440	酸性雨による屋外構造物の被害状況	馬飼野信一	46	6	477	1995	3:解説	?	酸性雨, 被害, 銅, 亜鉛, コンクリート
5441	自動車工業における環境汚染対策(1) - 酸性雨による塗膜劣化とその対策	上村純二	46	6	481	1995	3:解説	塗布・塗装	酸性雨, エッチング, 加水分解, Auxuary Cross-
5442	自動車工業における環境汚染対策(2) - 融雪剤による錆劣化とその対策	坂内恒雄	46	6	487	1995	3:解説		自動車の錆劣化, 融雪剤
5443	建築外装の劣化と維持保全	近藤照夫	46	6	496	1995	3:解説	?	維持保全, 建築外装, 劣化

5444	プラント材料の大気側腐食における最新の防食技術	中村寿和	46	6	498	1995	3:解説		腐食,腐食防食
5445	鉄筋コンクリート構造物の劣化及び補修	平松和嗣	46	6	504	1995	3:解説	?	劣化,補修,鉄筋コンクリート
5446	鋼構造物の防食 - 実施例を中心とした表面技術	増田一広	46	6	509	1995	3:解説		皮膜,腐食,構造,表面処理
5447	塗膜劣化の評価技術の現状と問題点	山本 隆	46	6	515	1995	3:解説		有機皮膜,電気化学技術,???(Service Life),???(Field Monitoring Method),???(Anti-Corrosive Pigment)エポキシ樹脂,ポリウレタン樹脂,ガラスフレーク,ビニルエステル樹脂,超厚膜塗装
5448	超厚膜塗装技術の現状と問題点	山崎 曜	46	6	522	1995	3:解説		超厚膜塗装,酸性土壌,酸性湖沼,バクテリア,アルミニウム
5449	湖沼・土壌の酸性化とその対策	惚田晃夫	46	6	525	1995	トピックス	?	腐食防食,鋼構造物,防食塗装システム,腐食塗装
5450	ISO/TC35/SC14(構造物の防食塗装システム)制定の経緯	中尾義一	46	6	529	1995	トピックス		泳動電着法,湿式法,皮膜,機能性材料,粒子
5451	泳動電着法による機能性材料の成膜化	小浦延幸 塚本桓世 荏司浩雅 根岸	46	6	533	1995	2:総説		泳動電着
5452	シリーズ/現場管理技術 - 湿式法(3) - クロメート処理の管理のポイント	青江徹博	46	6	539	1995	9:シリーズ-2	?	光沢クロメート,有色クロメート,黒色クロメート,緑色クロメート,亜鉛めっき,トラブルシューティング
5453	シリーズ/くらべてみよう(3) - 金と銀	八木 裕	46	6	546	1995	10:比べてみよう	?	金,銀,貴金属
5454	Ti合金上のNiめっき皮膜密着性及び熱処理の効果	黒澤一吉,平井英次,松村由男,氏平	46	6	547	1995	5:原著論文		チタンの表面改質,ニッケル電気めっき,真空熱処理
5455	電子シャワー - 法によるステンレス基板へのCuの高密着性膜	湯本久美,樋貝和彦,山 堯	46	6	553	1995	5:原著論文		物理蒸着(PVD)
5456	クリプトンガスとn-ブチルベンゼン蒸気吸着による表面多孔性シリコンの孔径の決	野中 昭	46	6	558	1995	5:原著論文	?	界面,ESCA,PVD,銅皮膜,密着性
5457	紫外線処理による有機性汚濁指標としてのCOD除去	渡辺秀人,本間英夫	46	6	563	1995	5:原著論文		多孔質シリコン,孔径評価,ブチルベンゼン蒸気吸着,クリプトン吸着
5458	無電解Ni - Fe系合金めっき浴中のFe ³⁺ イオンの抑制	金 東賢,青木公二,鷹野 修	46	6	567	1995	5:原著論文		COD,紫外線,光照射,第一鉄イオン,第二鉄イオン,過酸化水素,無電解めっき,Ni-Fe合金,軟磁性皮膜
5459	テトラエトキシシランの加水分解物による抗菌剤表面被覆の耐熱性	富岡敏一,富田勝己,岡 弘章,西野	46	6	573	1995	13:研究ノート		抗菌剤表面被覆,耐熱性
5460	電解ニッケルめっきに及ぼす磁場の影響 - 水晶振動子マイクロバランス法による検	浜野 学,吉原佐知雄,佐藤栄一,千葉	46	6	576	1995	13:研究ノート		電解ニッケル,磁場,電析,水晶振動子マイクロバランス
5461	電析によるPt/Co多層膜の作製	柏原 智,常光幸美,林 安德	46	6	578	1995	7:速報論文		電析,Pt/Co多層膜,TEM
5462	エポキシ樹脂のスルホン化を利用する導電性皮膜の形成	縄舟秀美,久後行平,水本省三,清田	46	6	580	1995	8:Letters	?	エポキシ樹脂,硫化,銅イオン吸着,導電性皮膜
5463	巻頭言:めっき業の新たな旅立ちにあたって	優 今成真明	46	7	585	1995	1:巻頭言	?	?
5464	PVD及びCVDによる最近のセラミックスコーティング	高井 治	46	7	586	1995	2:総説	?	PVD,CVD,セラミックス皮膜
5465	反応性スパッタリングによる酸化物薄膜の作製	畑 朋延	46	7	590	1995	トピックス		反応性スパッタリング,YSZ,ZrO ₂ ,スパッタリング
5466	クリーン化技術による磁性金属薄膜のナノ構造制御 - スパッタ磁気メディアを通して	高橋 研	46	7	594	1995	トピックス		ウルトラクリーンプロセス,記録メディア,保磁力,メディアノイズ,粒間交換相互作用
5467	エレクトロルミネセンス(EL) - 発光素子膜	竹内 学	46	7	603	1995	トピックス	?	エレクトロルミネッセンス,有機EL,ZnS:Mn,8-キノリールアルミニウム,有機薄膜
5468	半導体膜の低温成長	針生 尚	46	7	607	1995	トピックス		低温エピタキシ,プラズマエピタキシ,光励起給エピタキシ,半導体層機能ブロック
5469	触媒膜	角田達朗,早川 孝,亀山哲也	46	7	611	1995	トピックス		触媒膜,PVD,固体電解質
5470	位相差膜	多賀康訓	46	7	616	1995	トピックス		光学位相差膜,??????
5471	透明バリアー膜の形成技術	稲川幸之助	46	7	620	1995	トピックス		透明バリアー膜,酸素透過率,水蒸気透過率,光透過率,ロール
5472	メカニカルセンサ - 膜	篠原謙司,国京利一	46	7	624	1995	トピックス		センサー,薄膜センサー,ホットフィルムセンサー,ストレインゲージ
5473	形状記憶合金薄膜	石田 章,武井 厚,宮崎修一	46	7	628	1995	トピックス		マイクロマシン,Ti-Ni,スパッタリング,形状記憶,超弾性
5474	固体潤滑膜	西村 允	46	7	632	1995	トピックス	?	MoS ₂ ,DLC,固体潤滑,固体潤滑
5475	シリーズ/現場管理技術 - 湿式法(4) - ニッケルめっきの前処理 - 電解洗浄のポ	天田 徹	46	7	636	1995	9:シリーズ-2		亜鉛めっき,脱脂,組成制御,前処理,めっき
5476	シリーズ/くらべてみよう(4) - ガスの爆発	寺門一住	46	7	641	1995	10:比べてみよう	?	ガス,爆発
5477	磁気記録媒体用金属磁性粉の低エネルギー光電子放射測定法による耐候性の評	渡辺春夫,佐藤文彦,今井 潤,森 誠	46	7	643	1995	5:原著論文	?	磁気金属微粒粒子,低エネルギー光電子放射,耐候性
5478	SUS310Sステンレス鋼に処理したアルミニウム拡散被覆層の破壊挙動	佐々木雅啓,井形直弘	46	7	646	1995	5:原著論文		アルミニウム拡散皮膜,SUS310Sステンレス鋼,クラック発生,破壊
5479	カチオン交換膜を用いる電気Ni - P合金めっきプロセスの検討	森河 務,横井昌幸,中出卓男,福本幸男,岩倉千秋	46	7	653	1995	5:原著論文		Ni-P合金,電気めっき,カチオン交換膜
5480	ポリビニール被覆半導体マイクロアレイ電極を用いた光機能デバイス	洪谷真生,西澤松彦,末永智一,内田	46	7	659	1995	5:原著論文		ポリビニール,マイクロアレイ電極,光メモリ,半導体電極
5481	Pd - Ag合金の電析とその接点への応用	久米道之,沖 猛雄	46	7	663	1995	5:原著論文		Pd-Ag合金めっき,接点めっき,接点抵抗
5482	自己触媒型無電解スズめっきの析出速度に及ぼす添加剤の効果	千田厚生,上林義弘,高野良比古,森	46	7	667	1995	13:研究ノート		無電解めっき
5483	ガラス上に形成したPTFE皮膜上の水滴のESEMIによる観察	斎藤博之,高井健一,高沢寿佳	46	7	670	1995	7:速報論文		物理蒸着(PVD)
5484	Ni - Y金属間化合物薄膜の相制御及び多孔質化	立岩健二,多田正行,伊藤靖彦	46	7	672	1995	7:速報論文	?	相制御,Ni,Y,金属間化合物,多孔質
5485	CVDダイヤモンド薄膜表面からの電子放出と欠陥密度との関係	秋葉幸男,広瀬洋一,黒須橋生,飯田	46	7	674	1995	7:速報論文		CVDダイヤモンド,SEM画像,二次電子放出,ESR信号,欠陥密度
5486	巻頭言:智恵と工夫	昌盛,庄 善之,和泉山口重裕	46	8	681	1995	1:巻頭言	?	知恵,工夫
5487	短時間微小重力環境を利用した材料合成	奥谷 猛	46	8	682	1995	3:解説		短時間微小重力,材料合成
5488	S ₁ 単結晶/SiO ₂ 多層薄膜の合成	柴田典義,石川由加	46	8	688	1995	3:解説		SOI,酸素注入,シリコン,薄膜
5489	表面吸着種の光化学	大橋勝文,川崎昌博	46	8	692	1995	3:解説		励起過程,有機金属化合物,半導体,光MOCVD,絶縁体
5490	STM/AFMによる半導体電極表面反応の追跡	魚崎浩平,鯉沼陸央	46	8	697	1995	3:解説		STM,AFM,半導体,電極反応

5491	固体高分子電解質への電極触媒の接合	竹中啓恭	46	8	702	1995	3:解説		固体高分子電解質,電極触媒,膜-電極複合物
5492	シリーズ/現場管理技術-湿式法(5)-Ni-Crめっきのポイント	遠藤豊春	46	8	707	1995	9:シリーズ-2	電気めっき・電鍍	亜鉛めっき,Ni-Crめっき,トラブルシューティング
5493	シリーズ/くらべてみよう(5)-SEMとTE	松原 浩	46	8	713	1995	10:比べてみよう		SEM,TEM,顕微鏡
5494	高出力YAGレーザーによる鋼の表面焼入れに及ぼすアシストガスの影響	日野 実, 栢野康彦, 西田典秀, 平松 実, 秋山光一	46	8	715	1995	6:技術論文	熱処理	YAGレーザー,レーザー表面処理,アシストガス,硬化
5495	スパッタリング法によるTa ₂ O ₅ 薄膜の諸特性に及ぼす成膜条件の影響	福島 誠, 滝沢貴久, 山下嗣人	46	8	720	1995	6:技術論文	物理蒸着(PVD)	Ta ₂ O ₅ 膜,スパッタリング,スパッタリング条件,析出速度,透過率
5496	含CuAl合金の陽極酸化皮膜特性に及ぼす熱処理の影響	前嶋正受, 石禾和夫, 猿渡光一, 平田近藤, 市治, 近藤憲司, 竹中 修, 白井誠, 太田 実, 金原	46	8	724	1995	6:技術論文	熱処理	Al-Cu合金,熱処理,固溶金属間化合物,陽極酸化皮膜,硬さ
5497	Ti接着層によるPt膜/TiO ₂ 間の密着性向上及びPt膜の抵抗特性への影響	岡田哲朗	46	8	730	1995	5:原著論文	物理蒸着(PVD)	密着性,薄膜,チタン,白金,接着効果
5498	エッチング液によるタングステン溶解速度	鐘暉, 市野良一, 興戸正純, 沖 猛雄	46	8	739	1995	5:原著論文	化学エッチング・電解エッチング	反応速度,タングステン溶解,アルカリエッチング溶液
5499	電位制御によるアルミニウム箔の交流エッチングに及ぼす周波数の影響	竹内典子, 西田秀来, 小浦延幸, 満田直樹, 遠藤 巧, 伊藤 小島 仁, 上田成行, 小笠原一秀, 佐藤武満, 米田芳之	46	8	745	1995	5:原著論文	化学エッチング・電解エッチング	ACエッチング,アルミニウム箔,電位制御,周波数
5500	電子部品の水系洗浄における平衡濃度		46	8	745	1995	5:原著論文	洗浄	水洗浄,平衡濃度,水系洗剤,蒸着
5501	常温型溶融塩浴からのCo-Zn合金の電析		46	8	752	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	水洗浄,平衡濃度,水系洗剤,蒸着Co-Zn合金,電析,常温型溶融塩浴
5502	HCD-ARE法によるCrNx膜の作製	須田 新, 荻野陸雄	46	8	757	1995	7:速報論文	物理蒸着(PVD)	窒化クロム,HCD,反応性蒸着
5503	シリカ粒子によるCr(VI)の減圧下における還元挙動	林 安德	46	8	759	1995	7:速報論文	塗布・塗装	シリカ,クロム,塗布型クロムめっき,XPS,XANES
5504	巻頭言:第92回講演大会を前にして	梅田 章	46	9	769	1995	1:巻頭言		
5505	マイクロマシンとLIGA	渡辺秀人, 本間英夫	46	9	770	1995	3:解説	微細加工プロセス	マイクロマシン,LIGA,リソグラフ,電気めっき,鋳型
5506	マイクロバンプ形成とめっき	駒野博司	46	9	778	1995	3:解説	電気めっき・電鍍	表面実装技術,マイクロバンプ形成,電気めっき,無電解ニッケル
5507	フォトリソグラフィ(1)-レジスト材料	佐野尚武	46	9	784	1995	3:解説	微細加工プロセス	フォトリソグラフィ,フォトレジスト,フォトファブ리케이션
5508	フォトリソグラフィ(2)-エッチング技術	西澤松彦, 末永智一, 内田 勇	46	9	789	1995	3:解説	?	フォトリソグラフィ,フォトマスク,ウエットエッチング,ドライエッチング,マイクロセンサ,マイクロアレイ電極
5509	マイクロセンサ[マイクロアレイ電極]	澤井秀夫	46	9	794	1995	3:解説	微細加工プロセス	導電性高分子,酵素,プリントヘッド,ディスプレイデバイス,スクリーンプリント,サンドブラ
5510	大面積デバイスにおける微細加工技術	篠浦 治, 小柳 勤	46	9	798	1995	3:解説	微細加工プロセス	薄膜,磁気記録ヘッド,微細加工技
5511	薄膜磁気ヘッドにおける微細加工技術	荒井邦夫	46	9	804	1995	3:解説	微細加工プロセス	ブラインドホール,スルーホール,レーザー加工
5512	レーザーによるプリント基板の微細加工技術	斉藤昌弘, 中山郁雄	46	9	809	1995	9:シリーズ-2	無電解めっき	無電解Niめっき,ハードディスク下地,溶液管理システム
5513	シリーズ/現場管理技術-湿式法(6)-無電解Niめっき液の管理技術	浅富士夫	46	9	815	1995	10:比べてみよう	電気めっき・電鍍	金めっき,シアン浴,非シアン浴
5514	シリーズ/くらべてみよう(6)-金めっきシアン浴とシアンフリー浴	紺谷智則, 浦尾亮一, 村野井徹夫, 菊間 勲, 竹内 学	46	9	817	1995	5:原著論文	物理蒸着(PVD)	チタン,フタロシアニン,光電導性,真空蒸着,結晶構造
5515	チタンフタロシアニン蒸着膜の結晶性と光電導性に及ぼす基板温度の影響	久米道之, 沖 猛雄	46	9	822	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	電析,Zn-Co合金,ジンケート浴,耐食性
5516	アルカリジンケート型浴からのZn-Co合金の電析	久米道之, 沖 猛雄	46	9	829	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	Cu-Sn合金,トリポリリン酸塩浴,ニッケルアレルギー,装飾めっき
5517	トリポリリン酸塩浴からのCu-Sn合金の電析	縄秀美, 福田順成, 水本省三, 芳賀 齊藤いほえ, 吉田裕道, 上野武司, 水元 和成	46	9	834	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	電析Cu,エチレンジアミン錯体浴,包含物,室温軟化,結晶粒径
5518	エチレンジアミン錯体浴からの電析Cu皮膜の常温軟化に及ぼす包含物の影響	道 上野武司, 水元 和成	46	9	840	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍	有孔度,ニッケルめっき,パルスめっき
5519	鉄鋼上のニッケルめっきの有孔度と電流波形	前嶋正受, 猿渡光一, 平田昌範, 石禾和夫, 高谷松文, 岡原治男, 上田栄治, 香西道雄, 松田好晴, 計良善也, 鎌前嶋正受, 猿渡光一, 石禾和夫, 高谷 英 敬信, 上宮成之, 小島紀徳	46	9	846	1995	5:原著論文	アノード酸化	陽極酸化,断続電流,耐摩耗性,電流波形,硬さ
5520	アルミニウム陽極酸化皮膜の耐摩耗性と電解電流波形	秋葉幸男, 広瀬洋一, 黒須橋生, 飯田津留壽昭, 高木 健, 小林繁夫	46	9	862	1995	7:速報論文	?	ポリ-4-ビニルピリジン塩酸塩による抑制,軟鋼および純鉄の腐食,塩酸
5521	軟鋼及び純鉄の腐食に対するポリ-4-ビニルピリジン塩酸塩の抑制効果	黒田孝一	46	9	856	1995	13:研究ノート	アノード酸化	陽極酸化皮膜,ソリ変形,内部応力,多孔質層
5522	アルミニウム陽極酸化皮膜のソリ変形	黒田孝一	46	9	860	1995	7:速報論文	化学蒸着(CVD)	CVD,薄膜コーティング,プラズマ,SiC
5523	プラズマCVD法による粒子のSiC薄膜コーティング	小島紀徳	46	9	860	1995	7:速報論文	?	lbダイヤモンド,スクラッチ処理,欠陥電子放出,SEM画像
5524	lb単結晶ダイヤモンド(111),(100)面からの電子放出	黒田孝一	46	9	862	1995	7:速報論文	?	電析,Cr-Ni合金,50vol%-DMF浴,組成分析
5525	50vol%-DMF浴からのCr-Ni合金皮膜の組成と析出電位の関係	黒田孝一	46	9	864	1995	7:速報論文	電気めっき・電鍍	電析,Cr-Ni合金,50vol%-DMF浴,組成分析
5526	アノード酸化アルミナメンブレンの水和劣化防止処理	黒田孝一	46	9	866	1995	7:速報論文	アノード酸化	多孔質アルミナ膜,水和劣化,封孔,りん酸
5527	巻頭言:大学院教育における学協会の役	渡辺邦洋	46	10	873	1995	1:巻頭言	?	?
5528	医療材料の表面処理	伐 義人	46	10	874	1995	2:総説	?	?
5529	血液と接触する表面の新しい処理	岩崎泰彦, 石原一彦, 中林宣男	46	10	880	1995	3:解説	?	?
5530	人工肺材料と表面処理	萩原和彦	46	10	887	1995	3:解説	?	人工肺,ガス交換,生体適合性,?
5531	人工関節と表面処理	立石哲也, 伊藤敦夫	46	10	893	1995	3:解説	物理蒸着(PVD)	人工関節,セラミックス皮膜,チタン合金,生体適合性
5532	歯科材料における表面処理	埴 隆夫, 浅岡憲三	46	10	898	1995	3:解説	?	?
5533	眼科材料と表面処理-コンタクトレンズを中心として	栗秋政光	46	10	903	1995	3:解説	?	歯科材料,歯,表面処理,眼科材料,表面処理,コンタクトレンズ
5534	人工心臓と表面処理	井街 宏	46	10	907	1995	3:解説	?	人工心臓,血液ポンプ,生体適合性,セグメント化ポリウレタン
5535	新しい人工皮膚-体表面の再建	黒柳能光	46	10	912	1995	3:解説	?	人工皮膚,?
5536	血管カテーテルの表面処理	長岡昭二	46	10	916	1995	3:解説	?	血管カテーテル,表面処理,抗血栓性,易滑性
5537	薬物の持続放出と表面処理	近藤 保	46	10	920	1995	3:解説	?	薬物の持続放出,拡散制御,溶解制御,浸透性
5538	ウ食予防膜形成ならびに魚鱗及び貝殻表面へのマイクロ刻印のためのマイクロスパッタリング技術	杉田利男, 森主宣延, 西川英一, 渡部一史	46	10	924	1995	トピックス	物理蒸着(PVD)	スパッタリング,ウ蝕,予防,マイクロ刻印,魚鱗,貝殻
5539	プラスチック人工筋肉	金藤敬一	46	10	929	1995	トピックス	?	人工筋肉,導電性高分子,電気化学,?

5540	"小特集 / 生体の医用材料と表面処理" によせて	*	46	10	933	1995	?	?
5541	シリーズ / 現場管理技術 - 湿式法(7) - 化成処理における管理のポイント	相沢謙次	46	10	934	1995	9:シリーズ-2	化成処理
5542	シリーズ / くらべてみよう(7) - リンゴ	堀口 誠	46	10	939	1995	10:比べてみよう	?
5543	マイクロ電極を用いる有機電解液中でのリチウム析出・溶解挙動の評価	王 献明,仁科辰夫,内田 勇	46	10	941	1995	5:原著論文	電析応用
5544	無電解ニッケルめっきによるアルミニウム上へのマイクロバンプ形成	渡辺秀人,本間英夫	46	10	946	1995	5:原著論文	無電解めっき
5545	DMAB を還元剤とする無電解ニッケル - ホウ素合金めっきの物質収支及び析出機	縄舟秀美,小橋康人,水本省三	46	10	951	1995	5:原著論文	無電解めっき
5546	走査トンネル顕微鏡による銀電析過程の観察	中村高士,田辺正幸,本間敬之,逢坂	46	10	956	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍
5547	アルミニウム合金ダイカストADC12のバルスアノード酸化中におけるバリエー層の電気化学的性質	三田郁夫,重盛正樹	46	10	960	1995	5:原著論文	アノード酸化
5548	リンとリチウムを共添加したZnSe薄膜のアクセプター準位	村野井徹夫,石井伸直	46	10	964	1995	13:研究ノート	物理蒸着(PVD)
5549	アルミニウム陽極酸化皮膜のリングオンデ	前嶋正受,猿渡光一,中川三紀夫,高	46	10	966	1995	13:研究ノート	アノード酸化
5550	アルミニウム陽極酸化皮膜のアプレッシュ	前嶋正受,猿渡光一,石木和夫,高谷	46	10	968	1995	13:研究ノート	アノード酸化
5551	巻頭言:我が表面技術協会は今何色だと皆様は思いますか - 未完の大器表面技	渡辺 徹	46	11	975	1995	1:巻頭言	
5552	繊維の高機能化 - 序論	中島利誠	46	11	976	1995	3:解説	?
5553	消臭菌繊維と表面処理	白井汪芳	46	11	977	1995	3:解説	?
5554	帯電防止のための繊維の表面改質	内田恵美子	46	11	983	1995	3:解説	?
5555	抗菌防臭加工繊維	奥 章祐	46	11	988	1995	3:解説	?
5556	染色のための繊維の表面処理	小林文夫	46	11	993	1995	3:解説	?
5557	エキシマレーザーによる繊維表面改質	渡辺博佐,高田忠彦	46	11	997	1995	3:解説	?
5558	低温プラズマ及びスパッタエッチングによる繊維の表面改質	脇田登美司,解野誠司	46	11	1003	1995	3:解説	気相エッチング
5559	染料移行昇華防止のための繊維表面の化学処理	天野慈朗	46	11	1009	1995	3:解説	?
5560	環境対応型繊維	竹内一郎,小関智樹	46	11	1013	1995	トピックス	?
5561	温度変色繊維素材	島田雅人	46	11	1017	1995	トピックス	?
5562	VP加工による形状記憶シャツ	伊藤 博	46	11	1019	1995	トピックス	?
5563	シリーズ / 現場管理技術 - 湿式法(8) - 硫酸銅めっきの管理のポイント	森 義樹	46	11	1024	1995	9:シリーズ-2	電気めっき・電鍍
5564	シリーズ / くらべてみよう(8) - 水とフッ酸	飯本周邦	46	11	1028	1995	10:比べてみよう	洗浄
5565	紫外線照射併用電解法によるシアン含有水の処理方法	松本幸英,関本正生,吉田泰樹	46	11	1031	1995	6:技術論文	化成処理
5566	無電解銅めっきへの精密ろ過の応用	萩原 謙,渡辺城司,本間英夫	46	11	1035	1995	6:技術論文	無電解めっき
5567	反応性DCスパッタリングによるTi-6Al-4V合金基板へのTi/O傾斜皮膜の形成	園田 勉,加藤 誠	46	11	1039	1995	5:原著論文	物理蒸着(PVD)
5568	Alイオン照射したナイロン粘土複合材料の表面特性	伊藤由彦,東 博純,伊藤 忠,野田正治	46	11	1044	1995	5:原著論文	イオン注入
5569	ポリプロピレン表面の塗装のための表面処理方法	平山良司,前野又五郎,橋本嗣夫	46	11	1050	1995	5:原著論文	?
5570	STMによる亜鉛デンドライト電析初期過程の観察とそのコンピュータシミュレーション	田村早苗,小浦延幸	46	11	1054	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍
5571	溶融Zn鋼ストリップへのロールコーティング機構	藤原俊朗,金丸辰也,中山元宏	46	11	1060	1995	5:原著論文	溶融
5572	アゾベンゼン修飾界面活性剤を用いたニッケル / 銅フタロシアニンの複合めっき	ナビ・ソ・K・シュレタ,佐治哲夫	46	11	1066	1995	8:Letters	?
5573	巻頭言:北の大地では今	成田敏夫	46	12	1073	1995	1:巻頭言	
5574	表面処理の新しい展開 - 特殊な条件での表面処理	馬場宣良	46	12	1074	1995	2:総説	?
5575	バルス電流による表面処理	松永守央	46	12	1079	1995	3:解説	電気めっき・電鍍
5576	レーザーを用いた表面処理 - レーザブレイティングとレーザーエッチング	牧野英司	46	12	1083	1995	3:解説	?
5577	溶融塩浴からの金属ならびに合金の電析	小浦延幸	46	12	1088	1995	3:解説	電気めっき・電鍍
5578	希土類金属の非水溶液からの電析	佐藤祐一	46	12	1094	1995	3:解説	電気めっき・電鍍
5579	表面処理における磁場の効果	千葉 淳	46	12	1100	1995	3:解説	?
5580	表面技術における超音波の効果	山下嗣人	46	12	1105	1995	3:解説	?
5581	表面処理における電解重合	直井勝彦,大浦 靖	46	12	1110	1995	3:解説	?
5582	液中放電によるアバタイトの析出	伊部幸雄	46	12	1115	1995	トピックス	?
5583	低温溶融塩法によるクロム炭窒化物被覆	杉本義彦,太田幸夫,新井 透	46	12	1119	1995	6:技術論文	溶融
5584	超音波照射下で作製した無電解ニッケル - リン皮膜との耐食性	千葉 淳,倉光秀和,呉 文昌,小林勝義	46	12	1125	1995	5:原著論文	無電解めっき
5585	有機溶媒浴からのモリブデンの電析	津留壽昭,高木 健,小林繁夫	46	12	1130	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍
5586	アンモニア性酒石酸浴からの電析Ni-Mo合金の構造と共析挙動	秋山徹也,福島久哲,湯瀬文雄,津留壽昭,友清芳二	46	12	1130	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍
5587	溶融電解法によるニッケル上へのLaNi5の生成	田村隆介,市野良一,興戸正純,沖 猛	46	12	1139	1995	5:原著論文	溶融
5588	クエン酸系電析金めっき浴のカチオン高分子添加物の影響とその金めっき膜の耐食性.高分子添加物の構造と機能の相関	湯浅 真,大谷 豊,塘 健夫,関根 功	46	12	1144	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍
5589	クエン酸系電析金めっき浴での有機添加物及びバルスめっき法の相乗効果と金めっき膜耐食性 - 添加物構造と耐食性のニッケル粉末の焼結による微細孔をもつ多孔体の作製	湯浅 真,塘 健夫,宮館康夫,大原 誠,関根 功,葛島俊夫,木村彰夫,横 寛,佐藤 啓,菅沼栄一	46	12	1150	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍
5590	常温型溶融塩浴からのNb-Sn合金の電析	小浦延幸,凌 国平,伊藤兵衛	46	12	1157	1995	5:原著論文	?
5591	塩化物溶融塩浴からのAl-Ti合金電析	内田淳一,瀬戸宏久,渋谷敦義	46	12	1162	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍
5592	塩化物溶融塩浴からのAl-Ti合金電析	内田淳一,瀬戸宏久,渋谷敦義	46	12	1167	1995	5:原著論文	電気めっき・電鍍

5593	溶融塩電気化学プロセスによるSiの注入とシリサイドの形成	上田剛史,後藤琢也,伊藤靖彦	46	12	1173	1995	5:原著論文	?	電気化学注入,シリサイド,?
5594	塩化物浴からのCu/Ni多層膜の電析	三宅猛司,久米道之	46	12	1180	1995	13:研究ノート	電気めっき・電鍍	定電流パルス,電析,Cu/Ni多層膜,塩化物浴
5595	ポリアクリル酸によって感受性化したポリイミド上の無電解Niレーザプレーティング	牧野英司,川勝由美子,柴田隆行,池田正幸	46	12	1182	1995	7:速報論文	無電解めっき	レーザー無電解めっき,ポリイミド皮膜,ポリアクリル酸,ニッケルライオン
5596	非水溶液からのAu電析皮膜の特性	山下嗣人,岩城泰彦,荒巻芳幸	46	12	1185	1995	13:研究ノート	電気めっき・電鍍	非水溶液,金析出,硬さ,接触抵抗,接続材料
5597	リチウム負極のサイクル特性に及ぼす添加材の影響	中村博吉,王 叢笑,三谷栄作,藤田利美,芳尾真幸	46	12	1187	1995	7:速報論文	?	リチウム有機電解物,交流インピーダンス,リチウム電池
5598	アルミニウムのアルカリエッチングにおける超音波の影響	前嶋正受,猿渡光一,石永和夫,高谷	46	12	1189	1995	7:速報論文	化学エッチング・電解エッチング	アルミニウム,アルカリエッチング,超音波,エッチング重量,粗さ
5599	常温溶融塩浴からの非晶質Co-Zn合金電析	小浦延幸,遠藤 巧	46	12	1191	1995	7:速報論文	電気めっき・電鍍	アモルファス,Co-Zn合金,電析,常温溶融塩電解物
5600	有機溶媒からの電析によるイットリウム複合酸化物の作製	松田好晴,山谷 学,吉本信子,森田昌行,石川正司,芳賀	46	12	1193	1995	8:Letters	電気めっき・電鍍	イットリウム酸化物,電析,DMF溶液,蛍光材料,複合皮膜
5601	周期的反転電流電解によるニッケルめっき膜の内部応力の低減	津野 豊,玉井智和	46	12	1195	1995	8:Letters	電気めっき・電鍍	電気めっき,Ni析出,内部応力,ストレーンゲージ,PRめっき
5602	シリーズノくらべてみよう(9) - CVDとPVD	佐々木恒	46	12	1197	1995	10:比べてみよう	?	CVD,PVD
5603	50周年に向けて	岸 富也	47	1	1	1996	1:巻頭言	B09:その他	168 基礎
5604	ステンレス鋼の局部腐食	八代 仁,丹野和夫	47	1	2	1996	3:解説	B09:その他	ステンレス鋼,局部腐食,孔食,隙間腐食
5605	塗覆装鋼板の動向とポリエステル樹脂フィルム被覆化粧鋼板の開発	神田勝美	47	1	7	1996	4:技術解説	A:05塗布・塗装	PCM,化粧鋼板,亜鉛めっき鋼板,ポリエステルフィルム,塗覆物理蒸着,イオンプレーティング,スパッタリング,複合皮膜,形状記憶合金薄膜
5606	PVDによる機能膜の創製	武井 厚	47	1	12	1996	12:武井記念シリーズ	A01:物理蒸着	
5607	表面状態の解析(37) - ラマン分光法による表面・薄膜の構造評価	吉川正信,石田英之	47	1	18	1996	9:シリーズ-2	A10:その他	ラマン,表面構造,薄膜
5608	表面状態の解析(38) - 非弾性電子トンネル分光法(ETS)による表面の状態分析	鎌田薩男	47	1	24	1996	9:シリーズ-2	A10:その他	非弾性電子トンネル分光法,接合,単分子層,トンネル電流,振動スペクトル
5609	スズ及びスズ - 鉛合金めっきのポイント	藤村一正	47	1	29	1996	9:シリーズ-2	B02:電気めっき・電鍍	スズめっき,スズ・亜鉛めっき,はんだめっき,不良対策
5610	ドライプロセスとウェットプロセス	浅富士夫	47	1	35	1996	10:比べてみよう	A01:物理蒸着	PVD, CVD, 電気めっき, 無電解めっき, 溶融めっき
5611	超音波洗浄による異物除去メカニズム - 共振気泡による摩擦作用	阿座上瑞美,菊池廣	47	1	37	1996	5:原著論文	C06:洗浄	超音波洗浄,共振気泡,不純物除去,粒子除去,振動数
5612	抗菌成分としての銀錯体Rp[Agq(S2O3)r](R=Na,K)の熱安定性	富岡敏一,富田勝己,岡 弘章,西野	47	1	42	1996	5:原著論文	B05:熱分解・ソル・ゲル法	抗菌物質,銀錯体,熱安定性,カチオン,チオスルファト/銀比率
5613	硫酸マグネシウム溶液中で処理されたAl-Mg-Si合金の耐食性	佐藤文博,浅川義彦,坂田真理子	47	1	46	1996	5:原著論文	B08:化成処理	耐食性,アルミニウム マグネシウム ケイ素 アルミニウム合金,硫酸マグネシウム,転換被覆
5614	自動車外板でパネルのチップングに及ぼす要因の解析	金丸辰也,山崎一正,新井勝利,山下行秀	47	1	51	1996	5:原著論文	A:05塗布・塗装	チップング,有限要素法,摩擦力,チップングクライマー,グラベロメーター
5615	有機複合被覆鋼板の電着塗装後の鮮映性に及ぼす濡れ性の影響	筋田成子,浜原京子,向 亮一,望月一望,森戸延行	47	1	56	1996	5:原著論文	A:05塗布・塗装	鮮映性,電着塗装,親水性樹脂,濡れ性,水素ガス気泡
5616	缶用表面処理鋼板の動的接触抵抗と溶接性	菊池利裕,望月一雄,久々湊英雄	47	1	62	1996	5:原著論文	C07:その他	溶接缶,溶接性,缶材料,接触抵抗,シーム溶接
5617	有機アルカリ性浴(ベンジルアミン・フッ化物基液)中でのアルミニウムの陽極酸化における有機酸塩添加の効果	野口駿雄,吉村長蔵	47	1	67	1996	5:原著論文	B07:アノード酸化	陽極酸化,ベンジルアミンアルカリ浴,有機アルカリ浴
5618	熱フィラメントCVD法による合成されたダイヤモンド薄膜への紫外線照射による酸	石川 豊,吉見英人,広瀬洋一	47	1	74	1996	7:速報論文	B01:化学蒸着	ダイヤモンド薄膜,グラファイト,紫外線,酸化,エッチング
5619	SUS444鋼とテフロン球すきまのすきま腐食再不動電位	今井八郎,長島英也,増子 昇	47	1	76	1996	7:速報論文	C07:その他	再不動電位,隙間腐食,SUS444ステンレス鋼,テフロン球隙間
5620	スズめっきした無電解ニッケル-リン合金めっき皮膜の耐食性	園田 司,林 行信,松田好晴	47	1	78	1996	7:速報論文	B03:無電解めっき	耐食性,無電解ニッケルめっき,スズめっき,熱拡散
5621	電析Ni-P合金皮膜の形態	清川 肇,高橋美香,米沢 晋,堀田紀好,清川 忠,高島正之,高谷松文	47	1	80	1996	8:Letters	B02:電気めっき・電鍍	ニッケル-リン合金皮膜,析出形態,高電流密度,原子間力顕微鏡
5622	協会事業への参加		47	2	103	1996	1:巻頭言	B09:その他	166環境
5623	いまトライボロジーが面白い	森 誠之	47	2	104	1996	3:解説	A10:その他	トライボロジー,境界潤滑,潤滑剤,薄膜,表面処理
5624	超硬質膜トライボロジー	三宅正二郎	47	2	109	1996	3:解説	B01:化学蒸着	トライボロジー,超硬質膜,ダイヤモンド,立方晶窒化ホウ素
5625	レーザ表面改質によるトライボロジー特性の改善	水谷嘉之,志村好男	47	2	113	1996	3:解説	A10:その他	表面改質,レーザーアイロニング,レーザークラッディング,トライボロジー,耐摩耗性
5626	塑性加工のトライボロジーと表面処理	中村安宏	47	2	117	1996	3:解説	A10:その他	冷間鍛造,リン酸処理,反応型石けん
5627	トライボコーティング	加藤康司	47	2	121	1996	3:解説	A10:その他	トライボコーティング,真空,潤滑
5628	固体潤滑膜	青木岩夫	47	2	124	1996	3:解説	A10:その他	固体潤滑処理,トータルコスト
5629	プラスチックの表面改質とトライボロジー特性	広中清一郎	47	2	128	1996	3:解説	A10:その他	プラスチック,トライボロジー,表面改質,摩擦,摩耗
5630	磁気ディスク円板の表面潤滑制御	渡辺正博	47	2	131	1996	3:解説	A10:その他	トライボロジー,潤滑剤,潤滑性制御,潤滑剤の吸着,磁気ディスク媒体
5631	エンドコートとエビコート	増子 昇,津田哲明	47	2	136	1996	12:武井記念シリーズ	B09:その他	表面被覆,エビコート,エンドコート,皮膜成長速度,速度制御
5632	現場管理技術 - 湿式法(10) - 金及び合金めっきの管理(1)	古藤田哲哉	47	2	142	1996	9:シリーズ-2	B02:電気めっき・電鍍	金,合金めっき
5633	くらべてみよう(11) - 白金とパラジウム	八木 裕,五百井俊宏,高谷松文,松永正久,富田好之	47	2	146	1996	10:比べてみよう	C07:その他	60白金, 63パラジウム
5634	めっき鋼板打抜き品のエッジ仕上げ法	石原正統,湯本久美,土谷敏雄,明石	47	2	147	1996	6:技術論文	C01:機械研磨・研削	パレル処理,メカニカルプレーティング,バリ,めっき加工品
5635	電子シャワ - 法によるAIN薄膜の作製		47	2	152	1996	5:原著論文	A01:物理蒸着	窒化アルミニウム,配向,基板電圧,物理蒸着,表面弾性波

5636	ボ - ラス S ₂ の微細構造と発光挙動に及ぼす HF 濃度と S ₂ 基板抵抗の影響	執行和浩, 瀬尾真浩, 安住和久, 高橋英明, Maher-AL-DAN, William, H. SMY 上条幹人, 有泉直子, 日原政彦, 児嶋川口明廣, 馬飼野信一, 山崎龍一, 森 修	47	2	157	1996	5:原著論文	C03:化学エッチング・電解エッチング	多孔性シリコン、電解エッチング、フッ化水素溶液、微細構造、発光挙動
5637	高周波イオンプレーティングによる Au・Al 合金薄膜の形成	須田新, 川口純, 荻野隆雄	47	2	163	1996	5:原著論文	A08:イオン注入	イオンプレーティング、金 アルミニウム合金、金 アルミニウム合金超音波洗浄、インピーダンス、音圧、電気透析
5638	電気化学的測定による超音波洗浄の評価	村田 究, 亀山秀雄	47	2	168	1996	5:原著論文	C06:洗浄	陽極酸化、ポアワイドニング、白金・アルミナ触媒、シクロヘキサノ脱水素化
5639	触媒材料としての陽極酸化アルミナ層の調整	李 鍾楽, 増田正孝, 林 安德	47	2	178	1996	5:原著論文	B07:アノード酸化	皮膜の欠陥、液晶、臨界電流密度、ダイナミックスキャタリング、RFマグネトロンスパッタリング
5640	ステンレス鋼上に成膜された酸化皮膜の欠陥評価 - 電気化学的手法と光学的手法の比較	須田新, 川口純, 荻野隆雄	47	2	183	1996	5:原著論文	A10:その他	シリカ、吸脱着、乾燥下のクロメート、クロムイオンインヒター
5641	クロメート皮膜中におけるシリカ粒子の防食作用	斎藤博之, 高井健一, 高沢寿佳	47	2	189	1996	7:速報論文	A04:吸着	はっ水性、濡れ性、水の付着特性、TFE
5642	はっ水性皮膜中における水の付着力と表面粗さに関する一検討	猿渡光一, 前嶋正受, 平田昌範, 岡田美浦, 隆	47	2	191	1996	7:速報論文	C07:その他	陽極酸化皮膜、膜厚、クリープ、クラック
5643	陽極酸化処理したアルミニウム線のクリープ特性	海老名延郎, 古賀孝昭, 小林道雄, 千田厚生, 珍田 聡, 芦田	47	3	197	1996	1:巻頭言	B07:アノード酸化	260電気めっき、322無電解めっき、166環境
5644	講演大会をチャ - ミングにしようとしていま	金子吉一	47	3	198	1996	21:座談会	B09:その他	エレクトロクロミズム、バナジウム酸化プロングス、溶融塩電解、塩基性度
5645	めっき技術の新しい潮流 - 電気めっき及び無電解めっきの新たな可能性を求めて	國松敬二	47	3	213	1996	3:解説	C07:その他	常温核融合、表面修飾、過剰熱、吸蔵率
5646	溶融塩電解による V 酸化物エレクトロクロミック材料の開発	古藤田哲哉, 藪本周邦, 佐藤守夫, 石田 章, 武井 厚, 宮崎修一, 桑野二郎, 伊藤芳典, 大友勇人, 広住俊次, 村田省三	47	2	223	1996	9:シリーズ-2	C07:その他	金めっき、金合金めっき
5647	常温核融合研究と陰極表面修飾	藪本周邦, 佐藤守夫, 石田 章, 武井 厚, 宮崎修一, 桑野二郎, 伊藤芳典, 大友勇人, 広住俊次, 村田省三	47	3	227	1996	10:比べてみよう	B02:電気めっき・電鍍	253定量分析、295pH、215水質チタン ニッケル、形状記憶、スパッタリング、マイクロマシン、薄
5648	金及び金合金めっきの管理(2)	小野浩司, 川月喜弘	47	3	229	1996	5:原著論文	A10:その他	WC-12%Cr硬質皮膜、減圧プラズマ射、耐摩耗性
5649	日本の温泉	平藤哲司, 寺島知道, 渡辺英一郎, 栗阿部真二, 西脇泰二, 渡辺秀人, 本間和気亮介, 吉原良一, 兼田善弘	47	3	235	1996	5:原著論文	C07:その他	高分子液晶、モルフォロジー、表面張力
5650	Ti - 50at.% 及び 52at.% Ni 合金薄膜の形状記憶特性に及ぼす熱サイクルの影響	小野浩司, 川月喜弘	47	3	240	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	クロムめっき、電析、2個クロムイオン、ギ酸、硫酸クロム
5651	減圧プラズマ溶射による WC - Co 硬質皮膜の形成条件	平藤哲司, 寺島知道, 渡辺英一郎, 栗阿部真二, 西脇泰二, 渡辺秀人, 本間和気亮介, 吉原良一, 兼田善弘	47	3	245	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	無電解めっき、ノンアン浴、金ワイヤーボンディング性
5652	高分子・液晶複合体のモルフォロジーの観察及び制御技術	小野浩司, 川月喜弘	47	3	250	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	溶接缶、電解スズめっき、電解クロムめっき、電析、溶接性
5653	ギ酸を含む2個クロム電解浴からのクロム電析	小野浩司, 川月喜弘	47	3	256	1996	5:原著論文	B08:化成処理	マグネシウムダイカスト、化成処理、透過電子顕微鏡、皮膜構造
5654	亜硫酸金錯体からの無電解金めっきのワイヤーボンディング性	小野浩司, 川月喜弘	47	3	263	1996	5:原著論文	B07:アノード酸化	マグネシウムダイカスト、陽極処理、透過電子顕微鏡、皮膜構造
5655	粒状スズを下地にした缶用薄クロムめっき鋼板の開発	小野浩司, 川月喜弘	47	3	268	1996	5:原著論文	A:05塗布・塗装	耐候性鋼、さび安定化表面処理、消光さび層、流出さび
5656	マグネシウムダイカスト AZ91D の化成処理により成長した表面皮膜の構造と生成機構	小野浩司, 川月喜弘	47	3	273	1996	5:原著論文	A:05塗布・塗装	はっ水性表面への水の付着に関する熱力学からの一考察
5657	マグネシウムダイカスト AZ91D の陽極酸化により生成した皮膜の構造と成長機構	小野浩司, 川月喜弘	47	3	279	1996	7:速報論文	B09:その他	環境保全と表面処理
5658	リン酸 - 酸化鉄 - PVB 処理を施した耐候性鋼のさび安定化作用	小野浩司, 川月喜弘	47	4	285	1996	1:巻頭言	A10:その他	表面分析の重要性 - 現状と将来
5659	はっ水性表面への水の付着に関する熱力学からの一考察	小野浩司, 川月喜弘	47	4	286	1996	2:総説	B09:その他	地方公設研究機関における表面分析
5660	環境保全と表面処理	小野浩司, 川月喜弘	47	4	292	1996	3:解説	C07:その他	自動車産業における表面分析
5661	表面分析の重要性 - 現状と将来	小野浩司, 川月喜弘	47	4	297	1996	3:解説	B09:その他	金属産業における表面分析
5662	地方公設研究機関における表面分析	小野浩司, 川月喜弘	47	4	301	1996	3:解説	C07:その他	エレクトロニクス産業における表面分析
5663	自動車産業における表面分析	小野浩司, 川月喜弘	47	4	305	1996	3:解説	C07:その他	半導体成長表面の表面分析
5664	金属産業における表面分析	小野浩司, 川月喜弘	47	4	309	1996	3:解説	A:05塗布・塗装	塗料・塗装産業における表面局所分析
5665	エレクトロニクス産業における表面分析	小野浩司, 川月喜弘	47	4	313	1996	3:解説	B02:電気めっき・電鍍	C1:めっきのシミの原因と対策
5666	半導体成長表面の表面分析	小野浩司, 川月喜弘	47	4	320	1996	9:シリーズ-2	C07:その他	炭素鋼とステンレス鋼
5667	塗料・塗装産業における表面局所分析	小野浩司, 川月喜弘	47	4	324	1996	10:比べてみよう	C02:化学研磨・電解研磨	SUS304 鋼焼鈍材の脱スケール過程における溶解挙動
5668	C1:めっきのシミの原因と対策	小野浩司, 川月喜弘	47	4	325	1996	6:技術論文	A10:その他	反応性イオンプレーティング法による Fe 窒化鉄薄膜の作製とその耐食性評価
5669	炭素鋼とステンレス鋼	小野浩司, 川月喜弘	47	4	330	1996	5:原著論文	A10:その他	In2O3 - Sn 系白色導電粉の調製
5670	SUS304 鋼焼鈍材の脱スケール過程における溶解挙動	小野浩司, 川月喜弘	47	4	338	1996	5:原著論文	A08:イオン注入	窒素イオン注入した Ti 合金のトライボロジー特性
5671	反応性イオンプレーティング法による Fe 窒化鉄薄膜の作製とその耐食性評価	小野浩司, 川月喜弘	47	4	345	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	無電解 Ni - P めっき膜のノジュールの発生要因
5672	In2O3 - Sn 系白色導電粉の調製	小野浩司, 川月喜弘	47	4	349	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	トリメチルアミンボランを還元剤とする無電解パラジウムめっき皮膜の結晶構造
5673	窒素イオン注入した Ti 合金のトライボロジー特性	小野浩司, 川月喜弘	47	4	356	1996	5:原著論文	A05:塗布・塗装	リン酸 - 酸化鉄 - PVB 系さび安定化処理法のさび非晶質化に及ぼす P, Cu の影響
5674	無電解 Ni - P めっき膜のノジュールの発生要因	小野浩司, 川月喜弘	47	4	360	1996	5:原著論文	A05:塗布・塗装	リン酸 - 酸化鉄 - PVB 系さび安定化処理膜のイオン選択透過性と安定さび生成機構
5675	トリメチルアミンボランを還元剤とする無電解パラジウムめっき皮膜の結晶構造	小野浩司, 川月喜弘	47	4	366	1996	5:原著論文	A05:塗布・塗装	
5676	リン酸 - 酸化鉄 - PVB 系さび安定化処理法のさび非晶質化に及ぼす P, Cu の影響	小野浩司, 川月喜弘	47	4	366	1996	5:原著論文	A05:塗布・塗装	
5677	リン酸 - 酸化鉄 - PVB 系さび安定化処理膜のイオン選択透過性と安定さび生成機構	小野浩司, 川月喜弘	47	4	366	1996	5:原著論文	A05:塗布・塗装	

5678	マイクロ波プラズマMOCVDによる酸化シリコン薄膜の低温堆積	築田博行・伊藤 滋・明石和夫	47	4	372	1996	13:研究ノート	B01:化学蒸着	マイクロ波プラズマCVD、ヘキサメチルジシロキサン、シリコン酸陽極酸化皮膜、クラック、硬度、曲げ応力、応力繰返し数曲線、回転曲げ疲労
5679	アルミニウム陽極酸化皮膜の回転曲げ疲労	平田昌範・前嶋正受・猿渡光一・重野博・高谷松文	47	4	376	1996	13:研究ノート	B07:アノード酸化	等方性ドライエッチング、シリコン、六フッ化イオウ、高速、表面ダイレクトプレーティング、PPE樹脂、表面改質、銅イオン吸着、導電性膜
5680	SF6プラズマを用いた平坦な表面の得られるシリコンの高速等方性ドライエッチ	峯田 貴・菅沼栄一	47	4	378	1996	8:Letters	C04:気相エッチング	亜鉛、ニッケル 鉄合金めっき、電析、分極曲線、ニッケルイオン/亜鉛イオンモル比
5681	熱硬化片PPE樹脂の表面改質を利用するダイレクトプレーティング	縄舟秀美・金井敏信・久後行平・水本省三・清田 優・新居マリ・M.I - ナン・沖 猛雄	47	4	380	1996	8:Letters	B03:無電解めっき	鉄共析、亜鉛、ニッケル 鉄電析、結晶背向、格子間隙
5682	Zn - Ni - Fe合金析出の分極挙動	沖 猛雄・マリ - M.I - ナン	47	4	382	1996	8:Letters	B02:電気めっき・電鍍	協会、活性化
5683	Zn - Ni - Fe合金の結晶構造に及ぼす鉄共析の効果	沖 猛雄・マリ - M.I - ナン	47	4	384	1996	8:Letters	B02:電気めっき・電鍍	ダイヤモンド薄膜、ヘテロエピタキシイ、シリコン、白金、マイクロ波プラズマCVD
5684	会員と協会	竹内 学	47	5	395	1996	1:巻頭言		燃焼法、高品質ダイヤモンド、自由励起子、カソードミネッセ窒化炭素、超硬材料、CVD、PVD、薄膜
5685	ダイヤモンド薄膜のヘテロエピタキシャル成長	橋 武史・横田嘉宏・宮田浩一・小橋宏司	47	5	396	1996	3:解説	B01:化学蒸着	ドライホロゾー、金属蒸着テープ、ダイヤモンド類似カーボン、保護層、家庭用デジタルVCR
5686	天然ダイヤモンドを上回る高品質ダイヤモンドの合成	竹内貞雄・川原田洋・村川正夫	47	5	402	1996	3:解説	B09:その他	フラレン薄膜、摩擦、超伝導性その場、電子計数、光子放出
5687	新超硬材料としての炭化窒素薄膜合成 - ダイヤモンドより硬い材料は可能か	瀧 優介・高井 治	47	5	407	1996	3:解説	A01:物理蒸着	固体表面、亀裂伝播
5688	家庭用デジタルVTR(DVC)用DLC膜形成蒸着 - プラズマプロセス	植田英之・高橋喜代司・村居幹夫・小田 桐優	47	5	414	1996	3:解説	B01:化学蒸着	治具
5689	フラレンC60薄膜の合成と応用	広中清一郎	47	5	419	1996	3:解説	A01:物理蒸着	言語
5690	オープンカウンターで観察できる固体表面の電子状態	宇田応之・長島 聡	47	5	422	1996	9:シリーズ-2	C07:その他	酸化インジウム系導電粉、導電性、カップリング剤、劣化防止
5691	治具の現場の改善事例(1)	青江徹博	47	5	427	1996	9:シリーズ-2	B02:電気めっき・電鍍	ダイヤモンド、鉄、リン、ニッケルリン、CVD、マイクロ波プラズマ
5692	英語と西語(スペイン語)	長井順子	47	5	431	1996	10:比べてみよう		数値解析、二次電流分布、通電ロール、めっき付着現象、連続ストリップ電気めっき
5693	In2O3 - Sn系白色導電粉のカップリング剤処理	長岡 茂・好本昭洋・岡崎直美・原田 孝・真嶋 宏	47	5	433	1996	6:技術論文	A10:その他	フッ化グラファイトの分散、ニッケルグラファイト複合皮膜、制御因子、電気めっき
5694	Fe - P,Ni - Pめっき基板上へのダイヤモンド合成	瀬川剛央・高谷松文・坂本幸弘	47	5	438	1996	5:原著論文	B01:化学蒸着	共析機構、ニッケル 二酸化チタン、電析
5695	通電ロールへのめっき付着現象の電気化学的シミュレーション	矢川敦久・木本雅之・津田哲明・渋谷敦義・増子 昇	47	5	443	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	即発ガンマ線、放射化分析法、バリアー型アルミナ皮膜、ホウ素濃度
5696	フッ化グラファイトの分散とニッケルとの電解共析	山口文雄・小浦延幸	47	5	448	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	鉄、ニッケル電析、構造、相形態図
5697	Ni - TiO2共析とその共析機構	山口文雄・小浦延幸	47	5	453	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	166環境、123応用
5698	バリアー形アルミニウム陽極酸化皮膜中のBの濃度と分布	森崎重喜・小川吉寛・前野智和・米沢仲四郎・伊藤康雄・澤幡浩之	47	5	456	1996	5:原著論文	B07:アノード酸化	自動車塗装、水性塗料、粉体塗料、揮発性有機化合物、鉛フリー
5699	Fe - Ni合金電析膜の結晶構造と表面形態	福室直樹・近沢正敏・渡辺 徹	47	5	461	1996	7:速報論文	B02:電気めっき・電鍍	屋根材の動向と屋根用塗装覆装鋼板の開発
5700	科学技術創造立国への幕開け	和田健二	47	6	469	1996	1:巻頭言		屋根材の動向と屋根用塗装覆装鋼板の開発
5701	環境に優しい自動車塗装の最近の動向	上田彬之	47	6	470	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	腐食表面微小部の視覚化
5702	屋根材の動向と屋根用塗装覆装鋼板の開発	神田勝美	47	6	475	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	不活性溶融金属を移送媒体とした拡散被覆法
5703	腐食表面微小部の視覚化	William - H.SMYRL・瀬尾真浩	47	6	482	1996	3:解説	C07:その他	フッ素系ガスによる薄膜堆積装置のクリーニング
5704	不活性溶融金属を移送媒体とした拡散被覆法	若松良徳	47	6	488	1996	3:解説	A09:拡散皮膜	電気二重層コンデンサ - の高性能化
5705	フッ素系ガスによる薄膜堆積装置のクリーニング	毛利 勇・藤井 正・小林義幸・早川誠而	47	6	493	1996	3:解説	C06:洗浄	ひずみゲ - ジ法によるめっき膜内部応力の評価
5706	電気二重層コンデンサ - の高性能化	石川正司・松田好晴	47	6	498	1996	3:解説	B01:化学蒸着	治具の現場の改善事例(2)
5707	ひずみゲ - ジ法によるめっき膜内部応力の評価	津留 豊	47	6	503	1996	9:シリーズ-2	B02:電気めっき・電鍍	銅精錬と亜鉛精錬
5708	治具の現場の改善事例(2)	青江徹博	47	6	508	1996	9:シリーズ-2	B02:電気めっき・電鍍	水晶振動子マイクロバランス法による亜鉛電析の研究
5709	銅精錬と亜鉛精錬	土橋 誠	47	6	512	1996	10:比べてみよう	B07:アノード酸化	イオン窒化とスパッタリングを組合せたプラズマ浸硫窒化
5710	水晶振動子マイクロバランス法による亜鉛電析の研究	土橋 誠・吉原佐知雄・白樫高史・高橋直樹・横田俊子	47	6	513	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	硫酸浴からのZn - Coめっきの腐食挙動
5711	イオン窒化とスパッタリングを組合せたプラズマ浸硫窒化	洪 晟弾・寺門一佳・横田仁志・浦尾亮一・日野 実・西田典秀・平松 実・秋山光一・川崎仁士	47	6	518	1996	5:原著論文	A10:その他	亜鉛合金の2回ジンケート前処理における電位と質量変化の追跡
5712	硫酸浴からのZn - Coめっきの腐食挙動	安住和久・瀬尾真浩・Leonard - NANIS	47	6	524	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	VCで被覆した合金工具(SKD11)及び析出硬化系ステンレス鋼(SUS630)の食塩水中での腐食磨耗について
5713	亜鉛合金の2回ジンケート前処理における電位と質量変化の追跡	安住和久・瀬尾真浩・Leonard - NANIS	47	6	529	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	分散めっきにおける電析Cu - ZrB2複合層中のZrB2含有量の制御
5714	VCで被覆した合金工具(SKD11)及び析出硬化系ステンレス鋼(SUS630)の食塩水中での腐食磨耗について	榎木敏幸・湯浅 真・関根 功	47	6	536	1996	5:原著論文	A03:溶融めっき	バルスマイクロ波プラズマCVDによる微細ダイヤモンド膜の合成
5715	分散めっきにおける電析Cu - ZrB2複合層中のZrB2含有量の制御	伊勢武一・目黒真作	47	6	543	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	Ni - Cr合金溶射皮膜の皮膜構造と熱伝導特性
5716	バルスマイクロ波プラズマCVDによる微細ダイヤモンド膜の合成	坂本幸弘・牛久保浩司・高谷松文	47	6	548	1996	7:速報論文	B01:化学蒸着	アゾベンゼン修飾界面活性剤を用いた金属粒子への顔料の無電解めっき
5717	Ni - Cr合金溶射皮膜の皮膜構造と熱伝導特性	森本純司・山口昭雄・鈴木茂之	47	6	550	1996	7:速報論文	A02:溶射	表面処理と地球環境の調和
5718	アゾベンゼン修飾界面活性剤を用いた金属粒子への顔料の無電解めっき	佐治哲夫・中根 章・劉 順林	47	6	552	1996	8:Letters	B02:電気めっき・電鍍	溶剤型塗料による表面へのはっ水性付与
5719	表面処理と地球環境の調和	榎橋純一	47	7	557	1996	1:巻頭言		電着塗装法によるはっ水皮膜の作製
5720	溶剤型塗料による表面へのはっ水性付与	齋藤博之・高沢寿佳	47	7	558	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	低温プラズマ処理による表面の疎水化
5721	電着塗装法によるはっ水皮膜の作製	室井克美	47	7	562	1996	3:解説	B02:電気めっき・電鍍	金属酸化物表面の疎水化技術
5722	低温プラズマ処理による表面の疎水化	小駒益弘	47	7	566	1996	3:解説	B01:化学蒸着	
5723	金属酸化物表面の疎水化技術	多賀康訓・大脇健史	47	7	571	1996	3:解説	A08:イオン注入	

5724	透明高はっ水性皮膜の低温形成 - 透明プラスチック基板への応用	穂積 篤,高井 治	47	7	575	1996	3:解説	B01:化学蒸着	透明プラスチック、はっ水性、デ イップコーティング、高周波プラ スチック
5725	化学吸着法による超はっ水表面の実現	高田祐助	47	7	580	1996	3:解説	C07:その他	超はっ水、プラズマエッチング、 単分子層、化学吸着、透明性
5726	はっ水性粉末を用いた複合めっき	千葉 格,前田俊之	47	7	584	1996	3:解説	B02:電気めっき・電鍍	複合めっき、フッ素樹脂、フッ化
5727	家電製品用塗覆鋼板の動向	神田勝美	47	7	589	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	家電製品、塗覆鋼板、動向、 走査電子顕微鏡、二次電子、反 射電子、試料作成
5728	表面状態の解析(4)1 - 走査電子顕微鏡 (SEM)のテクニック	小倉一道	47	7	594	1996	9:シリーズ-2		
5729	生産現場におけるろ過のポイント	柳下芳輝,東橋鴻太郎,能津十三郎	47	7	599	1996	9:シリーズ-2	C06:洗浄	ろ材、ろ過、めっき
5730	表面処理分野のシーズとニ - ズ	菅谷好倫	47	7	605	1996	10:比べてみよう		商品開発
5731	エチレングリコール溶液中におけるシリコン陽極酸化膜のX線光電子分光法による解析	柚賀正光,吉岡学,洋,竹内 舞,高橋三男,大山昌憲,田中大之,田中壽晃,相馬英明,吉田真人,酒井 彰,青藤英之,三澤俊平,安永龍哉,河田和久,杉崎康昭,池田貢基,上窪文生,松永守央,三角紳博,細川邦典	47	7	607	1996	5:原著論文	B07:アノード酸化	陽極酸化膜、エチレングリコール 溶液、X線電子分光法
5732	マイクロ波プラズマCVD法による種々の表面処理を施した炭素鋼基板でのダイヤモンド膜合成	田中大之,田中壽晃,相馬英明,吉田真人,酒井 彰,青藤英之,三澤俊平,安永龍哉,河田和久,杉崎康昭,池田貢基,上窪文生,松永守央,三角紳博,細川邦典	47	7	611	1996	5:原著論文	B01:化学蒸着	ダイヤモンド、CVD、マイクロ波プラ ズマ、炭素鋼、窒化チタン
5733	ダイナミックイオンミキシングによる炭素鋼の低温ホウ化処理	安永龍哉,河田和久,杉崎康昭,池田貢基,上窪文生,松永守央,三角紳博,細川邦典	47	7	616	1996	5:原著論文	A08:イオン注入	ホウ素イオン注入、チタン析出、 ダイナミックイオンミキシング、硼 化処理、軟鋼
5734	ダブルパルス法によるCu / Co多層膜の電析	伊勢武一,目黒真作	47	7	623	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	多層膜、銅 コバルト合金、ダブル パルス電流、薄膜
5735	分散めっきによる電析Ag - ZrB2複合層のZr B2含有量	村上和美,国枝義彦,兼松秀行,沖 猛雄	47	7	628	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	分散めっき、臭化ジルコニウム、 銀マトリックス、電流密度、回転 炭素繊維強化炭素複合材料、 PAN系繊維、黒鉛化、熱処理温 度、サイクリックボルタモグラム
5736	熱処理温度を変えたPAN系C / Cコンポジット表面のX線回折及びサイクリックボルタモグラム特性	沖口圭子,杉村博之,坂本幸弘,高谷逢坂哲彌	47	7	633	1996	5:原著論文	B06:熱処理	ダイヤモンド、CVD、マイクロ波プラ ズマ、原子間力顕微鏡
5737	マイクロ波CVDにより作製したダイヤモンド膜のAFM観察	沖口圭子,杉村博之,坂本幸弘,高谷逢坂哲彌	47	7	638	1996	7:速報論文	B01:化学蒸着	国際交流
5738	国際交流についての一考	西岡良二	47	8	645	1996	1:巻頭言		国際交流
5739	塗装材料の塗膜 - プレコート材料の塗膜 - (1)新機能プレコート塗膜	山下正明	47	8	646	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	プレコート鋼板、加工性、耐汚染 制、硬度、耐熱性
5740	塗装材料の塗膜 - プレコート材料の塗膜 - (2)潤滑防錆鋼板	永田順一郎	47	8	651	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	プレス加工性、潤滑、オイルレス 潤滑材、脱脂、耐食性
5741	耐火塗料の現状と将来	畑中昭良	47	8	656	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	耐火塗料
5742	抗菌・防カビ塗料の新展開	中家俊和	47	8	662	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	抗菌、防カビ、塗料
5743	低汚形塗料の新展開	尾野真史	47	8	667	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	低汚染型塗料、表面エネルギー ギー、ローリングアップ、汚染物 スズ無添加防汚塗料、防汚 剤、低表面エネルギー、導電性 缶被覆、ラミネート、環境保護、 製缶のシステム
5744	低汚形塗料の現状と将来	宮澤哲夫,今津勝宏	47	8	672	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	めっきテスト法
5745	容器用塗膜の新展開 - ラミネート	中村 元	47	8	677	1996	3:解説	A05:塗布・塗装	めっきテスト法
5746	めっき管理ポイント - ベントカソードテスト	茅根道生	47	8	682	1996	9:シリーズ-2	B02:電気めっき・電鍍	344溶融めっき、341溶射、271塗 アークイオンプレーティング、チタ ン・ハフニウム合金、反応確率、 セラミックス膜
5747	溶融亜鉛めっき・亜鉛溶射・ジンクリッチ塗	姜 求賢,内田裕久,黄 燕清	47	8	686	1996	10:比べてみよう	A03:溶融めっき	めっきテスト法
5748	AlP法によるTi - 60at% Ni合金の窒化物薄膜作製と反応性に関する研究	藤原俊明,山田正人,田本仁一,金丸小池一幸,篠原信幸,藤本準一,林 芳夫,神田勝美	47	8	689	1996	5:原著論文	A10:その他	低汚染型塗料、表面エネル ギー、ローリングアップ、汚染物 スズ無添加防汚塗料、防汚 剤、低表面エネルギー、導電性 缶被覆、ラミネート、環境保護、 製缶のシステム
5749	ハーフアロイ化溶融亜鉛めっき鋼板のプレス成形性	李 鐘榮,増田正孝,林 安德	47	8	696	1996	5:原著論文	A03:溶融めっき	344溶融めっき、341溶射、271塗 アークイオンプレーティング、チタ ン・ハフニウム合金、反応確率、 セラミックス膜
5750	電気亜鉛めっき鋼板のはんだ付け特性に及ぼす前めっきの影響	浦川秀美,杉本芳春,秋山徹也,福島	47	8	701	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	電気亜鉛めっき鋼板、はんだ特 性、前めっき、メニスコグラフ
5751	金属層挿入酸化被覆ステンレス鋼の腐食挙動	李 鐘榮,増田正孝,林 安德	47	8	707	1996	5:原著論文	A10:その他	皮膜欠陥、不動態保持電流密 度、RFマグネトロンスパッタリ ング電析、亜鉛・マンガン合金、ホウ フ化物物溶
5752	ホウフ化物からの亜鉛 - マンガン合金電析挙動	村田 究,亀山秀雄	47	8	714	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	プレート状触媒、触媒有効係数、 陽極酸化、白金/アルミナ触媒、 細孔構造
5753	陽極酸化アルミナ層を担体とした白金 / アルミナプレート状触媒の触媒有効係数	縄舟秀美,上浦有紀,水本省三,芳賀正記,内田 衛,津留壽昭,小林繁夫,山崎澄男,沢田松木健三	47	8	720	1996	5:原著論文	B07:アノード酸化	無電解めっき、鉛・ホウ素合金、 トリメチルアミンボラン、物質収 支、析出機構
5754	トリメチルアミンボランを還元剤とする無電解パラジウムめっきの物質収支及び析出機構	津留壽昭,小林繁夫,山崎澄男,沢田松木健三	47	8	725	1996	13:研究ノート	B03:無電解めっき	白金 モリブデン ニッケル合金 皮膜、電析、X線回折、構造
5755	電析法によるPt - Mo - Ni合金めっき	中 稔晴	47	8	729	1996	7:速報論文	B02:電気めっき・電鍍	めっき設備、ランダム制御、生産 品制御
5756	表面と技術	吉川一紀	47	9	735	1996	1:巻頭言		液管理、補給機構、自動ドレン機
5757	めっき設備の現状と将来	斎藤光雄	47	9	736	1996	3:解説	B02:電気めっき・電鍍	めっき設備、ランダム制御、生産 品制御
5758	めっき浴の自動液管理装置	小原勝彦,畑瀬 博,櫻井達美	47	9	740	1996	3:解説	B03:無電解めっき	排水、処理技術、リサイクル
5759	排水処理の現状と環境管理を考慮したこれらの処理技術	小原勝彦,畑瀬 博,櫻井達美	47	9	745	1996	3:解説	B03:無電解めっき	排水、処理技術、リサイクル
5760	表面処理における電流分布解析の応用	佐藤一也	47	9	751	1996	3:解説	B02:電気めっき・電鍍	電気めっき、表面処理、電流分 布、有限要素法、電気化学セル プラスチック上へのめっき、ABS 樹脂、エッチング
5761	プラスチック素材上へのめっきのポイント	黒沢 進	47	9	758	1996	9:シリーズ-2	B03:無電解めっき	3アルミニウム、49鉄、347リサイ 電子シャワー、インジウム スズ 酸化物、ホウ素、二酸化窒素 ガスセンサー、気相 液相 固相 エレクトロクロミク、酸化タンク ステン、スパッタリング、光学的 無電解ニッケル リン、高比抵 抗、錯化剤
5762	鉄とアルミニウム	小野住重和,井上琢海,湯本久美	47	9	765	1996	10:比べてみよう	C07:その他	減圧プラズマ溶射、コバルト ニッ ケル クロム アルミナ イットリウ ム、タンタル、時効処理、ガンマ 相、ベータ相
5763	電子シャワー - 法によるITO薄膜の作製とN O2検知特性の評価	長 秀雄,小川真吾,二木 崇,竹本幹男	47	9	767	1996	5:原著論文	A10:その他	電析銀、レーザー弾性表面波、 ウェーブレット変換、群速度分 布、密着性
5764	スパッタリングによるWO3膜の形成条件とE C特性	牧野英司,柴田隆行,野村慶一,安住和久,藤重祐介,瀬尾真浩,Leonard-NANIS,中尾英弘,田代雄彦	47	9	773	1996	5:原著論文	A10:その他	組成制御、りん酸、フォトエッチ ング、ファインセラミックス
5765	無電解析出法による高比抵抗NiP皮膜の作製とその特性	野口邦広,西田 稔,千葉 昂,原田良夫	47	9	779	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	アルミニウム、めっき、二回ジン ケート、添加効果
5766	減圧プラズマ溶射したCoNiCrAlYTa皮膜の微細構造に及ぼす熱処理の影響	長 秀雄,小川真吾,二木 崇,竹本幹男	47	9	784	1996	5:原著論文	A02:溶射	
5767	レーザー弾性表面波の速度分散解析によるめっき層特性の非接触評価	牧野英司,柴田隆行,野村慶一,安住和久,藤重祐介,瀬尾真浩,Leonard-NANIS,中尾英弘,田代雄彦	47	9	790	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	
5768	ファインセラミックスのフォトエッチングのための高温リン酸エッチングの組成制御	長 秀雄,小川真吾,二木 崇,竹本幹男	47	9	796	1996	5:原著論文	C07:その他	
5769	アルミニウムの2回ジンケート前処理に及ぼす溶液組成の影響	長 秀雄,小川真吾,二木 崇,竹本幹男	47	9	802	1996	5:原著論文	B09:その他	

5770	レーザーによる工業用純チタンの表面硬化処理	重松一典, 中村 守	47	9	808	1996	13:研究ノート	C07:その他	チタニウム、表面処理、レーザー、窒化チタン、硬度
5771	電析法によるPt-Mo-C合金めっき	津留壽昭, 小林繁夫, 山崎澄男, 沢田榎本英彦	47	9	810	1996	7:速報論文	B02:電気めっき・電鍍	白金 モリブデン コバルト合金、電析、X線回折、構造
5772	魅力ある学会にするためには	和氣亮吉, 吉原良一, 兼田善弘, 溝口良平, 岩本芳昭	47	10	817	1996	1:巻頭言		学会、技術
5773	溶接性と潤滑性に優れた薄クロムめっき鋼板の開発		47	10	818	1996	3:解説	B02:電気めっき・電鍍	溶接製缶、電解スズ板、クロムめっき、溶接性、潤滑性
5774	分子コート膜の開発と実用化	小川一文	47	10	823	1996	3:解説	A04:吸着	化学吸着、単分子膜、はっ水・はっ油性
5775	亜鉛合金めっきの稼動状況	小谷 勇, 野口裕臣	47	10	829	1996	3:解説	B02:電気めっき・電鍍	亜鉛 ニッケルめっき、亜鉛 鉄めっき、スズ 亜鉛めっき、浴量、クロメート処理
5776	In-Situ-XRD	仁科辰夫	47	10	834	1996	9:シリーズ-2	C07:その他	電気化学、その場X線回折、表面科学
5777	X線光電子回折(XPED)	石井秀司	47	10	839	1996	9:シリーズ-2	C07:その他	X線光電子回折、表面、中間面、薄膜、前方散乱ピーク
5778	めっき前処理技術のポイント(その1 前処理洗浄から)	矢部 賢	47	10	845	1996	9:シリーズ-2	C06:洗浄	前処理、表面調製、エッチング、めっき
5779	電池のエネルギー密度	釜崎清治	47	10	850	1996	10:比べてみよう		100一次電池、276二次電池、エネルギー密度
5780	イオン照射及び有機モノマーガス吸着の併用による石英ガラスへのはっ水性付与	伊藤由彦, 東 博純, 野田正治	47	10	853	1996	5:原著論文	A02:溶射	はっ水性、イオン照射、吸着、有機モノマーガス、石英ガラス
5781	低出力Arイオン照射前処理によるTi薄膜/Si基板間の密着性の改善	近藤市治, 近藤憲司, 竹中 修, 永田雅彦, 草野英二, 金原	47	10	858	1996	5:原著論文	A10:その他	アルゴンイオン照射、密着、薄膜、チタン、シリコン
5782	鉄系多孔質繊維焼結材料(炭素鋼)の硬さ評価	福田勝己	47	10	863	1996	5:原著論文	C07:その他	硬度、炭素鋼、多孔質繊維材料、空孔率
5783	硫酸塩浴からのZn-Cr合金の電析過程	Ye-LIN, 大貝 猛, 秋山徹也, 福島久哲, 山内祐樹	47	10	868	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	電析、亜鉛 クロム合金、ポリエチレングリコール、加水分解
5784	フェロキシル試験によるステンレス鋼の耐錆性評価	水谷 滋	47	10	873	1996	5:原著論文	C07:その他	ステンレス鋼、耐錆性、フェロキシルテスト、大気暴露試験、孔食
5785	気/液界面上に展開したステアリルアミン単分子膜上への鉛薄膜の無電解析出	益田秀樹, 大森 隆, 張 甲丹, 津留壽夫, 小林繁夫, 大貝 猛, 秋山徹也, 福島久哲	47	10	880	1996	13:研究ノート	B03:無電解めっき	単分子膜、鉛薄膜、無電解析出、ステアリルアミン
5786	ホウフッ化浴からのレニウム電析	樋口和人, 山田 浩, 宮城武史, 齊藤雅之, R. F誘導結合型プラズマを用いたスパッタリングによる窒化ホウ素薄膜の作製	47	10	887	1996	8:Letters	A10:その他	フッ素処理、ホウプロピレン、ニッケルめっき、フッ素、表面処理
5787	噴流式めっき装置によるめっき膜に対する膜厚分布のCVS解析	橋本嗣夫, 菊山裕久	47	10	889	1996	8:Letters	B02:電気めっき・電鍍	情報
5788	R.F誘導結合型プラズマを用いたスパッタリングによる窒化ホウ素薄膜の作製	平山良夫, 竹下淳一	47	11	895	1996	1:巻頭言	B03:無電解めっき	無電解めっき、導電性微粒子
5789	ポリプロピレンのフッ素ガス処理による低温ニッケルめっき	竹下淳一, 竹島鋭機, 児島 薫, 城倉貴史	47	11	896	1996	3:解説	A01:物理蒸着	スパッタリング、複合粉末
5790	情報基地として表協	渡辺信淳	47	11	905	1996	3:解説	C07:その他	濡れ現象、接触面、表面エネルギー、フッ化黒鉛、陽極効果
5791	無電解めっきによる微粒子の表面処理		47	11	910	1996	3:解説	A10:その他	ガス蒸発法、分散した超微粒子、マイクロディスプレイ描画装置
5792	スパッタリングによる微粒子の表面処理		47	11	911	1996	3:解説	C07:その他	超微粒子、ダイヤモンド、コロイド、精製
5793	超はっ水性粉末の開発		47	11	912	1996	3:解説	C07:その他	前処理、酸化膜の除去、エッチング、活性化
5794	超微粒子による基金属薄膜形成	小田正明	47	11	910	1996	3:解説	A10:その他	色彩、波長、可視光
5795	超微粒ダイヤモンド	牧田 寛	47	11	914	1996	3:解説	C07:その他	接着、フッ素ゴム、アルミニウム、プラズマ処理、X線光電子分光法
5796	めっき前処理のポイント(その2 めっき素材と活性化)	矢部 賢	47	11	919	1996	9:シリーズ-2	C06:洗浄	電析、コバルト ニッケル 鉄皮膜、磁気特性
5797	北の国と南の国の色彩感覚	茅根道生	47	11	925	1996	10:比べてみよう		色彩、波長、可視光
5798	プラズマを利用したフッ素ゴムのアルミニウムとの接着	百瀬義広, 室橋徹晶, 竹内基勝, 佐久間隆昭, 本橋嘉信	47	11	927	1996	5:原著論文	C07:その他	接着、フッ素ゴム、アルミニウム、プラズマ処理、X線光電子分光法
5799	電析法によるCoNiFe薄膜の作製とその磁気特性	中村明義, 高井まどか, 林 勝義, 達坂 慧	47	11	934	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	電析、コバルト ニッケル 鉄皮膜、磁気特性
5800	シランカップリング処理を施したシリカ粒子と亜鉛との分散めっき	田里伊佐雄, 陳 慧, 江林 秀考	47	11	939	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	亜鉛 シリカ分散めっき、シランカップリング剤、電位差滴定
5801	ワット浴からのシランカップリング処理を施したシリカとニッケルとの分散めっき	田里伊佐雄, 陳 慧, 江林 秀考	47	11	944	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	ワット浴、シリカ粒子、溶液pH、分散めっき、電位差滴定
5802	ボ-ラスSiの発光特性及び微細構造に及ぼす電解エッチング電流密度の影響	執行和浩, 瀧尾真浩, 安住和久, 高橋	47	11	949	1996	5:原著論文	C03:化学エッチング・電解エッチング	多孔性シリコン、電気化学エッチング、電流密度、微細構造、発光
5803	高温酸化により作製したTiO2皮膜の光アノード分極特性に及ぼす作製時における酸素分圧の効果	原 基, 夢沼賢太郎, 佐藤芳幸, 中川時子	47	11	957	1996	5:原著論文	C07:その他	光電気化学、酸化チタン、酸化物皮膜、高温酸化、イオン欠陥
5804	パルス電位法による溶融塩中のTa膜の電析とその耐食性	原 基, 磯部光則, 佐藤芳幸, 中川時子	47	11	963	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	電析、溶融塩、タンタル膜、パルス電位
5805	Ti-C-N被覆鋼の転がり-すべり接触解析	田村元紀, 戸田正弘	47	11	969	1996	5:原著論文	C07:その他	弾性 塑性解析、チタン 炭素 窒素皮膜の転がり接触、鋼、イオンブレーティング
5806	接触角の自動測定に関する研究	平野健次, 後藤健一	47	11	974	1996	5:原著論文	C07:その他	接触角、密着性濡れ、濡れ性、画像処理
5807	マイクロ波プラズマCVD法による高温酸化クロム基板上的ダイヤモンド膜の合成	斉藤英之, 八木澄子, 吉田真人, 酒井彰, 三澤俊平, 田中壽晃, 相馬英明, 田佐藤芳幸, 原 基, 川嶋 旭, 橋本功二	47	11	979	1996	7:速報論文	B01:化学蒸着	マイクロ波プラズマCVD、ダイヤモンド膜、クロム、酸化膜
5808	Ni-Y合金層を被覆したNiの高温酸化に及ぼすレーザー表面処理の効果	上野武司, 齋藤いほ, 吉田裕道, 田村和男, 松本誠臣	47	11	981	1996	7:速報論文	B02:電気めっき・電鍍	溶融塩、レーザー、表面改質、高温酸化、希土類
5809	りん酸による銅の電解研磨における銅イオンの影響	吉野隆子, 佐藤昌宏, 大森 隆, 益田秀樹, 馬場宣良, 山川宏二	47	11	983	1996	7:速報論文	C02:化学研磨・電解研磨	電析、銅、りん酸、銅イオン
5810	電解合成法によって作製されたイリジウム水和酸化物薄膜とそのエレクトロクロミック特性	高井 治	47	11	985	1996	8:Letters	B02:電気めっき・電鍍	イリジウム酸化物膜、エレクトロクロミズム、電析、コロイド状電解質
5811	表面の機能		47	12	991	1996	1:巻頭言		機能
5812	エレクトロクロミック膜の構造と性能		47	12	992	1996	3:解説	B01:化学蒸着	エレクトロクロミック膜、構造、性能、析出法
5813	酸化物超伝導薄膜の積層構造制御	池川純夫, 元井雄一	47	12	997	1996	3:解説	A10:その他	高温超伝導体、積層構造、ジョセフソン接合、逐次析出、自己構成
5814	自己集合膜の構造と金属の腐食防止	荒牧國次	47	12	1002	1996	3:解説	B09:その他	自己集合単分子膜、アルカンチオール、化学修飾、保護膜、銅

5815	水素吸蔵合金薄膜の構造と特性	釜崎清治	47	12	1008	1996	3:解説	A10:その他	水素吸蔵合金、薄膜、アモルファス、ニッケル 水素電池
5816	ダイヤモンド薄膜の新しい機能とその可能性 - 冷陰極を中心に	齋藤光以・澤辺厚仁	47	12	1014	1996	3:解説	A10:その他	ダイヤモンド、負の電子親和力、冷陰極
5817	不動態皮膜の構造制御と耐環境性	藤本慎司・柴田俊夫	47	12	1019	1996	3:解説	C07:その他	不動態、表面構造、腐食、耐環境性、ステンレス鋼
5818	電析金属多層膜の構造と特性	常光幸美・柏原 智・林 安德	47	12	1025	1996	3:解説	B02:電気めっき・電鍍	電析、金属多層膜、巨大磁気抵抗効果
5819	形状記憶合金薄膜	石田 章・宮崎修一	47	12	1029	1996	3:解説	A10:その他	スパッタリング、形状記憶合金、チタン ニッケル、マイクロマシン
5820	水溶液電解法による酸化Zn膜の作製	伊崎昌伸	47	12	1031	1996	3:解説	B09:その他	酸化亜鉛、カソード析出、水溶液、光透過性、ウルツァイト構造
5821	アルミニウム陽極酸化皮膜を利用した干渉色発色と皮膜構造制御	塚本由美子・海老原健	47	12	1232	1996	3:解説	B07:アノード酸化	干渉色発色、陽極酸化皮膜、アルミニウム、構造
5822	PTFEのプラズマスパッタリングを利用した黒鉛表面のフッ素化	百瀬義広・桑島正樹・井上和浩・西田伊藤秀章・杉山和義	47	12	1034	1996	5:原著論文	A10:その他	黒鉛フッ素化、プラズマスパッタリング、テフロン、接触角、表面
5823	CVDダイヤモンド膜 - 窒化ケイ素基板の密着性に及ぼすDLC中間層の効果	義岩原弘育・李 星洙・高井 治	47	12	1037	1996	5:原著論文	B01:化学蒸着	ダイヤモンド膜、ダイヤモンド状炭素中間層、密着性、切削工具
5824	Al - N膜の電気及び光学特性の制御方法及び傾斜機能膜の形成	王道元・永畑幸雄・林 安德	47	12	1048	1996	5:原著論文	A10:その他	電気特性、光特性、アルミニウム窒化物膜、アルミニウム窒化物 / アルミニウム / アルミニウム窒化物膜、アルミニウム アルミニウム二層磁気材料、無電解めっき
5825	Fe基液体急冷非晶質合金薄膜上への無電解CoP合金めっき膜の形成	丸山耕一・沼田博雄・大野 潔・佐藤駿	47	12	1054	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	分極曲線、急冷非晶質基体、コバルト リン合金皮膜
5826	次亜リン酸塩を還元剤とする無電解パラジウム - リン合金めっき皮膜の特性に及ぼすリン共析の影響	縄野秀美・松村智美・水本省三・芳賀正記・内田 衛	47	12	1060	1996	5:原著論文	B03:無電解めっき	無電解めっき、パラジウム リン合金、リン共析、内部応力、吸蔵
5827	酸性水溶液からのCuInSe2の電析と光電気化学応答	市野良一・森 淳志・興戸正純	47	12	1065	1996	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	銅 インジウム セレン、化合物半導体、電析、光電気化学応答、光起電力材料
5828	バリアー型アルミニウム陽極酸化皮膜へのEuイオン注入とエレクトロロミネッセンス	前野智和・岩崎良之・森崎重喜	47	12	1070	1996	5:原著論文	B07:アノード酸化	アルミナバリアー皮膜、エレクトロロミネッセンス、ユロビウム、イオン注入
5829	有機液体中で機械的に研磨された銅表面の光電子放出特性	昭沼百合子・本間正和・高橋健一郎・百瀬義広	47	12	1075	1996	5:原著論文	C01:機械研磨・研削	光電子放出、摩擦、有機液体、酸 塩基相互作用、陽子親和力
5830	Tb2+及びTm2+イオン注入したバリアー型アルミニウム陽極酸化皮膜からのエレクトロロミネッセンス	前野智和・伊藤 寿・岩崎良之・森崎重喜・水木一成	47	12	1082	1996	7:速報論文	A08:イオン注入	アルミナバリアー皮膜、エレクトロロミネッセンス、テルビウム、ツリウム、イオン注入
5831	シアン化物からの黄銅規則合金の電析	藤原 裕・榎本英彦	47	12	1084	1996	8:Letters	B02:電気めっき・電鍍	電析、シアン化物浴、黄銅、超格子
5832	石炭と石油 - 一次エネルギー源の現状	森田昌行	47	12	1086	1996	10:比べてみよう		石炭、石油、エネルギー源
5833	新年にあたり	松本誠臣	48	1	1	1997	1:巻頭言	C07:その他(新技術を含む)	
5834	歯科材料の表面処理と新顕微鏡観察	巨理文夫	48	1	2	1997	3:解説	C07:その他(新技術を含む)	生体材料、原子間力顕微鏡 (AFM)、共焦点レーザー走査型電子顕微鏡(CLSM)、レーザー顕微鏡、低真空SEM、その場観察、顕微鏡、歯、表面処理
5835	高配向ダイヤモンド膜の合成とその表面形態制御	前田英明・齊藤文晴・草壁克己・諸岡	48	1	8	1997	3:解説	B01:化学蒸着(CVD)	ダイヤモンド薄膜、CVD、配向、合成、制御、表面形態、優先成
5836	不均化反応の表面処理への応用	沖 猛雄	48	1	14	1997	12:武井記念シリーズ	A07:ライニング	不均下反応、表面処理、ライニング、表面硬化、
5837	Al処理工程改善のポイント1. エッチング、アルマイト	川合 慧	48	1	19	1997	9:シリーズ-2	B07:アノード酸化	Al、エッチング、アルマイト処理、カラー、表面処理、管理、封孔処理・(題名が違う)
5838	全面腐食と局部腐食	馬飼野信一	48	1	23	1997	10:比べてみよう	C03:化学エッチング・電解エッチング	腐食、粒界腐食、応力腐食、すきま腐食、接触腐食、
5839	バレル研磨面の知的認識法	五百井俊宏・松永正久・加藤和彦・小林史明・富田好之	48	1	25	1997	6:技術論文	C01:機会研磨・研削	バレル研磨、検査、表面粗さ、光沢生、テクスチャリング
5840	アーキオンブレーティング法によるポリカーボネート基板へのTiNの低温成膜	武田利彦・茂呂義明・伊藤 滋・湯本久美・明石和夫	48	1	31	1997	5:原著論文	A01:物理蒸着(CVD)	イオンブレーティング、ポリカーボネイト、TiN、内部応力、金色、耐
5841	反応性イオンブレーティング法による金・窒化アルミニウム複合薄膜の形成	上條幹人・有泉直子・日原政彦・児嶋	48	1	36	1997	5:原著論文	A01:物理蒸着(CVD)	イオンブレーティング、AIN、複合皮膜、黒色、構造
5842	スパッタ法でAl - Mg合金基板上に成膜したAIN薄膜の防食特性及び皮膜構造に与える成膜時のArガス圧の影響	山本兼司・中山武典・佐藤廣士	48	1	42	1997	5:原著論文	A01:物理蒸着(CVD)	スパッタリング、Al-Mg、Al、Mg、AIN、耐食、構造、成膜、残留応力、
5843	超硬合金上へのCVDダイヤモンドの被覆とその切削特性	小池一幸・丹花通文・林田貴裕・篠原信幸	48	1	49	1997	5:原著論文	B01:化学蒸着(CVD)	超硬合金、CVD、ダイヤモンド、薄膜、物性、レーザ、表面硬化処理、耐摩耗、構造、切削、
5844	ダイナミックイオンミキシングによる炭素鋼表面に低温成膜した浸炭層、窒化層の構造	安永龍哉・河田和久・池田貢基・上窪	48	1	54	1997	5:原著論文	A01:物理蒸着(CVD)	イオンミキシング、浸炭、窒化、構造、Ti、C、N、イオン注入、表
5845	次亜リン酸及びジメチルポランを還元剤とする鉄 - ニッケル合金の無電解析出	矢島弘之・沼田博雄・大野 潔	48	1	62	1997	5:原著論文	B03:無電解めっき	無電解めっき、Fe、Ni、次亜リン酸、DMAB、Fe-Ni、パーマロイ、Co、電析、酸性浴、配向、垂直磁
5846	酸性浴からの電析コバルトの優先配向	丸山完允・沼田博雄・大野 潔・春山志	48	1	68	1997	5:原著論文	B02:電気めっき・電鍍	メモリー、分極曲線、
5847	有機酸塩添加有機アルカリ性浴(1 - アミノ - 2 - プロパノール - フッ化物基液)中でのAlの陽極酸化	野口駿雄・下村教史・吉村長蔵	48	1	76	1997	5:原著論文	B07:アノード酸化	Al、アノード酸化、有機添加剤、添加剤、構造、
5848	アルミナ複合植物研磨材によるバレル研磨(第1報) - 金属材料の研磨	竹内茂夫	48	1	82	1997	5:原著論文	C01:機会研磨・研削	アルミナ、バレル研磨、研磨剤、表面粗さ、光沢
5849	SnO2 - Sb系白色電導性微粉末の調整	長岡 茂・好本昭洋・岡崎直美・原田 孝・真嶋 宏	48	1	87	1997	5:原著論文	A10:その他(新技術を含む)	粉体、導電性、Sn2O3-Sn、In2O3-Sn、白色、ITO、ATO、
5850	SnO2 - Sb系白色電導性微粉末の色調と分散性	長岡 茂・好本昭洋・岡崎直美・原田 孝・真嶋宏	48	1	93	1997	5:原著論文	A10:その他(新技術を含む)	粉体、導電性、Sn2O3-Sn、In2O3-Sn、白色、ITO、ATO、分散性、
5851	無電解NiBめっきによるマイクロパターンニング	高井まどか・武房さなえ・横島時彦・塚坂哲彌	48	1	98	1997	7:速報論文	B03:無電解めっき	無電解めっき、マイクロパターンニング、Ni-B、Ni、B、次亜リン酸、DMAB、レジスト、チオジグリコール、添加剤、異常析出
5852	活性炭のマイクロ波低温プラズマ処理とその表面特性	蔵野理一・山田比路史・藤田繁則・矢島龍彦・杉山和夫	48	1	100	1997	7:速報論文	A10:その他(新技術を含む)	活性炭、プラズマ、マイクロ波、比表面積、吸着

5853	大気中紫外線光電子計数法によるめっき前処理プロセスの評価	神月 靖, 朽木純子, 手塚良磨, 中野 正, 角田光雄, 斉藤明夫, 右田泰治, 山口昭浩, 津留青柿良一	48	1	102	1997	8:Letters	B02.電気めっき・電鍍	めっき, 前処理, 光電子, 評価, 紫外線
5854	水溶液中における銀 - シアン錯体の研究	青藤明夫, 右田泰治, 山口昭浩, 津留青柿良一	48	1	104	1997	8:Letters	B02.電気めっき・電鍍	Ag, CN, シアン, 錯体
5855	創立50周年記念への準備について	青柿良一	48	2	131	1997	1:巻頭言		
5856	鉄鋼のリサイクルと不純物元素	伊藤秀夫	48	2	132	1997	3:解説	リサイクル	Fe, 鉄鋼, リサイクル, 不純物, 鋼, 製鋼, スクラップ
5857	表面処理金属材料の母材再生技術 (1)真空焼成による防錆鋼板再利用技術の開発	岡田裕二	48	2	138	1997	3:解説	リサイクル	鋼, 防錆, リサイクル, 鋼板, スクラップ
5858	表面処理金属材料の母材再生技術 (2)アルミニウム箔複合材の再生技術	小森章夫	48	2	143	1997	3:解説	リサイクル	Al, リサイクル, 複合材, 箔, スクラップ
5859	表面処理金属材料の母材再生技術 (3)鉄鋼の回生・利用技術	武内美継	48	2	147	1997	3:解説	リサイクル	鉄鋼, 鋼, リサイクル, 製鋼, 不純物, スクラップ
5860	表面処理非金属材料の母材再生 (1)自動車バンパーのリサイクル技術	熊田正隆	48	2	154	1997	3:解説	リサイクル	自動車, バンパー, リサイクル,
5861	表面処理浴の再生・リサイクル技術 1.電気めっき浴の再生技術	星野芳明	48	2	159	1997	3:解説	リサイクル	リサイクル, 浴, めっき, 再生, 環境, 不純物,
5862	表面処理浴の再生・リサイクル技術 2.無電解めっき浴の長寿命化技術	久保井義夫	48	2	165	1997	3:解説	B03.無電解めっき	無電解めっき, 浴, 長寿命, Ni, P, 透析, イオン交換, 廃液, 潤滑, トライボロジー, 流体, 粘度, ベアリング, 潤滑剤
5863	潤滑の常識と"非"常識(1)	森 誠之	48	2	171	1997	3:解説	潤滑	Al, 水洗, カラーリング, 封孔, アルマイト, エッチング, カーレース, F-1, 自動車, 電解重合, 電池, Pb, 蓄電池, C, 電析
5864	A1処理工程改善のポイント 2.水洗.カラーリング封孔	川合 慧	48	2	176	1997	9:シリーズ-2	B07.アノード酸化	Al, 水洗, カラーリング, 封孔, アルマイト, エッチング, カーレース, F-1, 自動車, 電解重合, 電池, Pb, 蓄電池, C, 電析
5865	F-1レースとINDYレース	佐藤 登	48	2	181	1997	10:比べてみよう	C07.その他(新技術を含む)	カーレース, F-1, 自動車, 電解重合, 電池, Pb, 蓄電池, C, 電析
5866	鉛蓄電池用負極活物質の電解合成	坂上貴彦, 小浦延幸, 兼本隆二	48	2	185	1997	5:原著論文	電解重合	電解重合, 電池, Pb, 蓄電池, C, 電析
5867	アンモニアアルカリ性水溶液からのCdTeの電析	平藤哲司, 中谷純也, 栗倉泰弘	48	2	190	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	アンモニア, Cd, Te, 半導体, 電析, 化合物, 構造, 物性,
5868	Ni表面調整処理によるカラー鋼板の塗膜密着性向上メカニズム	水野賢輔, 川口 純, 荻野陸雄	48	2	195	1997	5:原著論文	A05.塗布・塗装	Ni, 鋼板, 密着, 塗膜, カラー, Ni, 機構, 溶融塩めっき, クロメー
5869	光沢Ni-Crめっき鋼板のCASS試験による腐食特性についての解析	藤田実, 横山真一郎, 松本誠臣	48	2	201	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	光沢, Ni, Cr, 電析, めっき, 鋼板, CASS, ピット, 腐食, 塗装, Zn, Ni, 鋼板, 電析, 腐食, XPS, 耐食, 塗装,
5870	亜鉛・ニッケル合金めっき鋼板の腐食過程	羽木秀樹, 世継博幸	48	2	206	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	ダイヤモンド, Al, 磨耗, 摩擦, DLC, CVD, 高周波プラズマ, 摺セラミクス, 磨耗, 摩擦, 金属, 摺動, 耐摩耗, 潤滑, 軸受,
5871	アルミニウム合金上に生成したDLC膜の摩擦・磨耗特性	出水 敬, 曾根 匠, 足立和俊, 横山雄二	48	2	213	1997	5:原著論文	B01.化学蒸着(CVD)	ダイヤモンド, Al, 磨耗, 摩擦, DLC, CVD, 高周波プラズマ, 摺セラミクス, 磨耗, 摩擦, 金属, 摺動, 耐摩耗, 潤滑, 軸受,
5872	シリコン系セラミクスと純金属との乾燥摩擦 - 摩擦特性に対する温度の影響と金属	川本 信	48	2	219	1997	5:原著論文	磨耗	ダイヤモンド, Al, 磨耗, 摩擦, DLC, CVD, 高周波プラズマ, 摺セラミクス, 磨耗, 摩擦, 金属, 摺動, 耐摩耗, 潤滑, 軸受,
5873	減圧プラズマ溶射によるプレス用金型の表面改質	桑野三郎, 伊藤芳典, 大友勇人, 広住俊次, 村田省三	48	2	225	1997	5:原著論文	A02.溶射	プラズマ, 溶射, 金型, 表面改質, 耐摩耗,
5874	圧縮試験におけるアルミニウム陽極酸化皮膜の埋没	前嶋正受, 猿渡光一, 石本和夫, 高谷	48	2	230	1997	5:原著論文	B07.アノード酸化	Al, アルミナライジング, 硬さ, クラック, 圧縮試験, 加工硬化
5875	熱処理に伴う無電解ニッケル・リン合金めっき皮膜の変色防止	園田 司, 林 行信	48	2	233	1997	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき, 膜, Ni, P, 変色,
5876	はっ水性表面への湿雪の付着に関する一検討	斎藤博之, 高井健一, 高沢寿佳	48	2	237	1997	5:原著論文	A05.塗布・塗装	はっ水性, 塗膜, 湿雪, フッ化ビニリデン,
5877	高利率化と技術へ	山崎龍一	48	3	241	1997	1:巻頭言		
5878	めっき廃水の処理	小坂幸夫	48	3	242	1997	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	めっき, 廃水, リサイクル, シアン, 管理, 無電解めっき, Cr, 酸, アルカリ, 錯化剤, 水洗, 廃液, フッ素, ホウフッ化イオン, イオン交換, 廃水,
5879	フッ素化合物の廃液処理	和田洋六	48	3	246	1997	5:原著論文	C06.洗浄	廃水, Pb, キレート樹脂, ろ過, 排水,
5880	表面処理工場の鉛含有系排水処理対策	斉藤光雄	48	3	251	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	排水, 廃水, N, P, Zn, 塩素酸化法, 吸着法, 触媒法, ストリッピング法, 凝集沈澱法, MAP法
5881	脱窒・脱リンについての排水処理	渡辺 敦	48	3	257	1997	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	めっき液, フェントン法, 廃液, 廃水, 錯体, EDTA, 酸化分解法, めっき, 廃水, 排水, 凝集分離, 凝集沈澱, 造粒,
5882	錯体を含むめっき液のフェントン法による廃液処理	横幕豊一	48	3	261	1997	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	めっき液, フェントン法, 廃液, 廃水, 錯体, EDTA, 酸化分解法, めっき, 廃水, 排水, 凝集分離, 凝集沈澱, 造粒,
5883	高効率凝集分離装置によるめっき排水処理	松島豊彦, 八町尚史, 福永和久	48	3	266	1997	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	めっき液, フェントン法, 廃液, 廃水, 錯体, EDTA, 酸化分解法, めっき, 廃水, 排水, 凝集分離, 凝集沈澱, 造粒,
5884	生体材料のトライボロジー	笹田 直	48	3	271	1997	3:解説	磨耗	生体材料, トライボロジー, 磨耗, 摩擦, 疲労強度, 金属, 磨耗毒性, 表面保護, 金属酸化物
5885	ダイヤモンド薄膜の合成・評価及びこれからの課題	広瀬洋一	48	3	277	1997	3:解説	B01.化学蒸着(CVD)	ダイヤモンド, 合成, 歴史, CVD, 評価,
5886	粉体への遷移金属の湿式コーティング	南橋啓司	48	3	282	1997	3:解説	B08.化成処理	粉体, 被服, 表面改質, 湿式法, 有機溶媒, コーティング,
5887	走査トンネル顕微鏡によるAuめっき過程の表面構造解析	澤口隆博, 沖中 裕, 板谷謹悟	48	3	286	1997	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	STM, Au, 電析, 表面, 解析, 表面, 反応
5888	潤滑の常識と"非常識"(2)ゾル・ゲル法による機能性コーティング薄膜の作製	森 誠之	48	3	291	1997	10:比べてみよう	潤滑	潤滑, トライボロジー, 摩擦, ソル・ゲル法, コーティング, 機能, 薄膜, 耐食, はっ水, 防水,
5889	化学研磨のチェックポイント	南 努, 志永清治	48	3	298	1997	12:武井記念シリーズ	B05.熱分解・ゾル・ゲル法	化学研磨, 評価, 光沢, ピット
5890	光電極と光触媒	山口靖英	48	3	304	1997	9:シリーズ-2	C02.化学研磨・電解研磨	化学研磨, 評価, 光沢, ピット
5891	光電極と光触媒	山口靖英	48	3	310	1997	10:比べてみよう	光触媒	光触媒, 光電極, 酸化チタン, 太陽電池, 白金電極, 光, Ti, イオン注入, 炭素, XPS, ラマン分光, 薄膜, 構造, TIC, X線,
5892	Ti:イオン注入による炭素薄膜の構造変化	畑田瑠理子, 馬場恒明	48	3	313	1997	5:原著論文	A08.イオン注入	プラズマ窒化, 窒化, 表面改質, Fe, ICP, 高周波, X線
5893	直流バイアス電圧印可加高周波プラズマ窒化による純鉄の表面改質	佐藤貴康, 野内勇雄, 佐原正人, 伊藤滋, 明石和夫	48	3	317	1997	5:原著論文	A01.物理蒸着(CVD)	プラズマ窒化, 窒化, 表面改質, Fe, ICP, 高周波, X線
5894	プリント回路基板表面のマイグレーションに対する検討	鶴田加一, 吉原佐知雄, 白樺高史	48	3	324	1997	5:原著論文	マイグレーション	プリント回路, 基板, マイグレーション, Ag, Cu, IC, LSI, 反応, オージェ,
5895	亜鉛電析皮膜の質量変化に及ぼす添加剤の影響 - 水晶共振子マイクロバランス測定による研究	土橋誠, 吉原佐知雄, 白樺高史, 横田俊子	48	3	330	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Zn, 電析, 添加剤, 光沢剤, 水晶振動子, マイクロバランス, 質量変化, ゼラチン, 表面モーフオスバタリング, 密着, プラズマ, 熱酸化, Si, Ti, N, LSI, AES, EPMA, ERDA, TEM, X線, マイグレーション, ダマシヨ, 配線, アークイオンプレーティング,
5896	カソード分極に伴う50.9at% Ni - Ti合金への水素化物の形成	羽木秀樹, 水野 誠, 伊部壽夫	48	3	337	1997	5:原著論文	A01.物理蒸着(CVD)	AIP, Cr, N, Cr-N, 耐溶融, Al, 製膜, ヒートサイクル, 結晶構造, TEM, Ti, 断面TEM
5897	流動層によるオーステナイト系ステンレス(SUS304)鋼のホウ化処理	上田順弘, 佐藤幸弘, 浦谷文博, 曾根匠, 池永 明, 川本信	48	3	343	1997	5:原著論文	A01.物理蒸着(CVD)	AIP, Cr, N, Cr-N, 耐溶融, Al, 製膜, ヒートサイクル, 結晶構造, TEM, Ti, 断面TEM

5898	マグネシウムダイカストAZ91Dの化成処理及び陽極酸化により生成した皮膜の組成と形態	志田あづさ,小野幸子,齋藤 誠,鈴木正教,堀口 誠,寺島慶一,松坂菊生,増子大賀智也,大八木八七,野口雅敏	48	3	349	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Nb, Sn, パルス、電析、溶融塩、常温、超伝導、BPC、
5899	酸性果実缶での硝酸イオンによる脱スズ現象に及ぼす硫化化合物の影響	大賀智也,大八木八七,野口雅敏	48	3	355	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Sn, 銅板、密着、塗膜、クロメート処理、皮膜、Cr
5900	シールド型アーケイオンプレATINGによる硬質窒化炭素薄膜の作製	瀧 優介,北河敏久,高井 治	48	3	362	1997	5:原著論文	B06.熱処理(窒化)	シールド、窒化、炭素薄膜
5901	陽極酸化により作製された酸化亜鉛皮膜の殺菌特性	山口靖英,山崎正敏,吉原佐知雄,白樫高史	48	3	364	1997	7:速報論文	B07.アノード酸化	Zn, 陽極酸化、酸化亜鉛、殺菌、皮膜、半導体、紫外線、黄色ブドウ球菌、光触媒、
5902	モリブデン硫化物を含浸したアルミニウム陽極酸化皮膜の断面観察	前嶋正受,猿渡光一,中川三紀夫,石禾和夫,高谷松文	48	3	366	1997	8:Letters	B07.アノード酸化	陽極酸化、モリブデン硫化物、断面構造、Mo, Al, EPMA
5903	表面技術誌の在り方	山下嗣人	48	4	373	1997	1:巻頭言		
5904	'特集 / 無電解めっき'の企画に当たって	海老名延郎	48	4	374	1997			
5905	最近の無電解めっき技術	齋藤 困	48	4	375	1997	3:解説	B03.無電解めっき	無電解めっき、分類、置換めっき、還元めっき、自己触媒、還元無電解めっき、Ni、浴、機能、分類、反応、
5906	無電解ニッケルめっき浴の機能分類と応用	中岸 豊	48	4	380	1997	3:解説	B03.無電解めっき	Cu、無電解めっき、ホルマリン、反応、表面形態、応用、電磁波シールド、スルーホールめっき、プリント配線、組成、
5907	ノーホルマリン無電解銅めっきの多機能化	藤波知之	48	4	387	1997	3:解説	B03.無電解めっき	Au、無電解めっき、浴、反応、分類、シアン、置換めっき、自己触媒、高速、ボンディング、Pd、無電解めっき、応用、還元めっき、特性、密着、反応、物性
5908	無電解金めっき浴の種類と応用	西山浩二,渡辺秀人	48	4	393	1997	3:解説	B03.無電解めっき	Pb, Sn、無電解めっき、還元めっき、はんだ、応用、物性、濡れ性、浴、接合、密着、
5909	無電解パラジウムめっきと応用	内田 衛	48	4	400	1997	3:解説	B03.無電解めっき	Al, Sn、無電解めっき、置換めっき、反応、物性、機能、
5910	無電解はんだめっき技術の開発と実用化	久保元伸,堀田輝幸	48	4	405	1997	3:解説	B03.無電解めっき	無電解めっき、還元めっき、Mg, Ni、クロメート処理、防錆、反応、Ni、黒、無電解鍍金、フォスブラック、耐摩耗性、耐熱性、光吸収、鍍金、前処理、難めっき、密着、
5911	アルミニウム上への置換スズめっき - アルスタン60プロセスの特性と応用	堀切靖晃	48	4	409	1997	3:解説	B03.無電解めっき	構造、水素、吸蔵、状態、水素エネルギー、製造、輸送、貯蔵、利用、
5912	マグネシウム合金へのダイレクト無電解ニッケルめっきプロセス	柴田光男	48	4	413	1997	3:解説	B03.無電解めっき	Ni、無電解めっき、異方性、伝導、微粒子、粒子、作製、X線、スピアホール、無電解めっき、Cu、均一、プリント配線、エポキシ樹脂、グリオキシル酸、つきまわり性、ストライク無電解めっき、
5913	濃黒色無電解ニッケルめっき - フォスブラック -	新田昌弘,足立洋史	48	4	417	1997	3:解説	B03.無電解めっき	Cu, TiN, Ti, N、密着、プラズマ、LSI、ダマシシ、マイグレーション、バリヤ、マグネトロン、スパッタリング、X線、水素、構造、TEM、断イオンプレATING、アーケイオンプレATING、Ti, Al, Cr, N、ヒートサイクル、硬さ、TEM、断面TEM、X線、クラック
5914	難めっき金属の前処理 (1)概論	矢部 賢	48	4	420	1997	9:シリーズ-2	前処理	Nb, Sn, パルス、電析、異常、溶融塩、合金、常温、分極曲線、Sn、クロメート処理、銅板、密着、塗膜、XPS、
5915	水素 - その状態と密度 -	釜崎清治	48	4	426	1997	10:比べてみよう	水素	Ni, P, Ni-P、レーザ、無電解めっき、トライボロジー、摩耗、摩擦、耐摩耗、銅板、硬さ、
5916	無電解ニッケルめっきによる異方性導電微粒子の作製	望月 勇,伊澤和彦,渡辺城司,本間英夫	48	4	429	1997	5:原著論文	B03.無電解めっき	Ni, Cu, P, Ni-Cu-P、合金、無電解めっき、機構、反応、
5917	微小ビアホールへの無電解銅めっきの均一析出性	阿部真二,藤波知之,青野隆之,本間英夫	48	4	433	1997	5:原著論文	B03.無電解めっき	Pt, アルミナ、複合めっき、無電解めっき、多孔質、水素透過、メンブレン、分離膜、耐硫黄
5918	Cu / TiN 薄膜間の付着力に対するTi膜の効果	則武千景,石原康生,近藤市治,近藤憲司,竹中 修,金原察	48	4	439	1997	5:原著論文	B03.無電解めっき	Zn, 電析、添加剤、光沢、TEM、断面TEM、ゼラチン、構造、ポリエチレングリコール
5919	AlP法によりTi - 6Al - 4V基板上に形成したCr - N膜の構造および耐溶融Al性を与える成膜時の窒素圧の影響	山本兼司,湯瀬文雄,中山武典,上窪文夫	48	4	446	1997	5:原著論文	A01.物理蒸着(CVD)	無電解めっき、還元めっき、エチレンジアミン、Pd、干酸、X線、浴、
5920	パルス電析法による常温型溶融塩浴からのNb - Sn合金の電析	凌 国平,小浦延幸	48	4	454	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni, P, Ni-P、レーザ、無電解めっき、トライボロジー、摩耗、摩擦、耐摩耗、銅板、硬さ、
5921	低スズめっき鋼板の塗料密着性に及ぼすクロメート皮膜の影響	大賀智也,前田重義,浅井恒敏	48	4	460	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni, P, Ni-P、レーザ、無電解めっき、トライボロジー、摩耗、摩擦、耐摩耗、銅板、硬さ、
5922	レーザ照射した無電解Ni - Pめっき皮膜のトライボロジー特性	日野 実,西田典秀,平松 実,辻川正人,川本 信	48	4	466	1997	5:原著論文	B03.無電解めっき	Ni, Cu, P, Ni-Cu-P、合金、無電解めっき、機構、反応、
5923	無電解ニッケル - 銅 - リン合金めっきの析出機構	縄舟秀美,上垣隆,水本省三,石川正巳,中村 恒	48	4	468	1997	7:速報論文	B03.無電解めっき	Pt, アルミナ、複合めっき、無電解めっき、多孔質、水素透過、メンブレン、分離膜、耐硫黄
5924	無電解めっき法による白金 / 多孔質アルミナ複合膜の調整	上宮成之,島山紀子,梶原昌高,小島紀徳,水元和成,土橋 誠,吉原佐知雄,白樫高史,横田俊子	48	4	470	1997	7:速報論文	B03.無電解めっき	Zn, 電析、添加剤、光沢、TEM、断面TEM、ゼラチン、構造、ポリエチレングリコール
5925	亜鉛電析皮膜の構造におよぼす各種添加剤の影響 - 透過型電子顕微鏡観察による検討	縄舟秀美,中尾誠一郎,水本省三,内田衛,岡田 隆	48	4	472	1997	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	無電解めっき、還元めっき、エチレンジアミン、Pd、干酸、X線、浴、
5926	干酸を還元剤とするエチレンジアミン錯体浴からの無電解パラジウムめっき	縄舟秀美,中尾誠一郎,水本省三,内田衛,岡田 隆	48	4	474	1997	8:Letters	B03.無電解めっき	Ni, P, Ni-P、レーザ、無電解めっき、トライボロジー、摩耗、摩擦、耐摩耗、銅板、硬さ、
5927	高比抵抗無電解Ni - P薄膜の熱安定性	逢坂哲彌,高井まどか,東川太一,飯塚光田章一	48	4	476	1997	8:Letters	B03.無電解めっき	Ni, P, Ni-P、レーザ、無電解めっき、トライボロジー、摩耗、摩擦、耐摩耗、銅板、硬さ、
5928	表協らしさ	奥野和義	48	5	487	1997	1:巻頭言		
5929	'小特集 / めっき・塗装材のはく離技術'の企画によせて	奥野和義	48	5	488	1997			
5930	最近のはく離技術	榎本英彦	48	5	489	1997	3:解説	はく離技術	はく離、陽極酸化、めっき、塗膜、電解はく離、
5931	環境問題に対処した最近のペイントのはく離方式の動向	間宮富士雄	48	5	496	1997	3:解説	はく離	はく離、塗膜、ペイント、環境、代替塗装、レーザ、プラスト、廃棄物、高圧水
5932	一般めっき皮膜のはく離	青江徹博	48	5	501	1997	3:解説	はく離技術	はく離、めっき、電解はく離、化学はく離、リサイクル、機械はく離
5933	機能めっき皮膜のはく離剤	岩沢裕之	48	5	507	1997	3:解説	はく離技術	はく離、めっき、皮膜、機能、プリント配線、プラスチック
5934	亜鉛ダイカスト及び銅系合金素材上へのめっきはく離法と金属回収法	西浜幸男	48	5	513	1997	3:解説	はく離技術	Ni, Cu、はく離、リサイクル、Cu、ニッケル、めっき、電解はく離、プリント配線、
5935	チタン系イオンプレATING皮膜のはく離	前田光秀	48	5	518	1997	3:解説	A01.物理蒸着(CVD)	はく離、イオンプレATING、Ti, TiN, TiC、過酸化水素、めっき、前処理、Zn、合金、脱脂、洗浄、ストライトめっき、
5936	難めっき金属の前処理法 (2)亜鉛合金、アルミニウム合金	矢部 賢	48	5	522	1997	9:シリーズ-2	前処理	血液、表面
5937	血液型と表面技術	黒沢 進	48	5	530	1997	10:比べてみよう	A10.その他(新技術を含む)	血液、表面

5938	高純度銅原料を用いた蒸着膜のエッチング及び特性	御田 護	48	5	533	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	エッチング、蒸着、めっき、Cu、薄膜、プリント基板、プリント配線、X線、蒸着、薄膜、エッチング、プリント配線、プリンと基板、微細パターン、電析、めっき、ポリイミド、Cu、異常析出、
5939	高純度銅原料用いた銅蒸着膜のめっき特性	御田 護	48	5	539	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Co、Fe、P、Co-Fe-P、多層膜、アモルファス、結晶、磁性、パルス、磁気ヘッド、パーマロイ、磁気記録、磁歪、表面、TEM、電析、めっき、耐摩耗、Fe、W、Fe-W、合金、熱処理、アモルファス、硬さ、応用、刃物、Zn、Ni、Zn-Ni、合金、皮膜、引っぱり強度、アコースティックエミッション、物性、電析、表面、耐食、鋼板、Cu、Ni、塑性変形、割れ、Ag、光沢、シアン、非シアン、浴、電気接点、分極曲線、こはく酸、フッ化水素、水素、吸蔵、表面改質、水素化、La、Ni、Al、水素吸蔵合金、合金、フッ化処理、HF、XPS、SEM、PCT
5940	直流重畳パルスめっき法による結晶 / 非結晶 Co - Fe - P 軟磁性多層膜の作製	湯本久美 今元 徹 木名瀬良紀 李 松 姫 石原正統 押木 満雅	48	5	544	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	偏光ラマン分光、ラマン、ダイヤモンド、Si、エピタキシャル、CVD、平板ダイヤ、配向、
5941	電析 Fe - W 合金めっき膜の切削刃物への応用	渡辺 徹 渡辺将志	48	5	549	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	自動車、環境、表面技術、エネルギー、リサイクル、防食、触媒、排ガス、酸性雨、電池、自動車、エミッション、触媒、排気ガス、環境、Pd、貴金属、自動車、触媒、排気ガス、表面技術、環境、チーゼル、NOX、貴金属触媒、
5942	A E 検出による Zn - Ni 合金めっき皮膜の引張破断強度評価	羽木秀樹	48	5	554	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	自動車、リサイクル、タイヤ、プラスチック、シュレッターダスト、金自動車、塗膜、酸性雨、紫外線、表面技術、環境、防食、腐食、エッチング、コーティング
5943	非シアン浴からの光沢 Ag めっき	正木征史 井上博之 山川宏二 伊藤 学 青野文昭	48	5	559	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	環境、自動車、表面技術、燃費、ピストリング、ピストン、シリンドラ、洗浄、
5944	高純度フッ化水素による水素吸蔵合金 La N:4.7A10.3 の表面改質と水素化特性	小菅明良 平山良司 菊山裕久 釜崎清治	48	5	565	1997	5:原著論文	吸着	インターネット、表面技術、パソコン、情報、ホームページ、電子メール、WWW、インターネット、表面技術、ホームページ、WWW、E-メール、検索、表面分析、データベース、画像処理、電子顕微鏡、写真、EMILIA、インターネット、WWW、イメージングプレート、えみりあ
5945	偏光ラマン分光分析法による平板状ダイヤモンドの評価	大島龍司 飯塚完司 鈴木敏正 平林敬二 広瀬洋一	48	5	567	1997	5:原著論文	B01.化学蒸着(CVD)	インターネット、ネットワーク、コンピュータ、WWW、金属材料技術研究所
5946	会員増強運動の推進と課題	山崎五郎	48	6	575	1997	1:巻頭言		インターネット、文献検索、WWW、用語、
5947	自動車と環境 - 表面技術の役割	佐藤 登	48	6	576	1997	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	インターネット、イントラネット、WWW、情報、ネットワーク、LAN、前処理、電析、難めっき、脱脂、洗浄、Mg、アルカリ脱脂、酸浸漬、活性化、表面調質、無電解めっき、後処理、クロメート処理
5948	ガソリン車とエミッション盛業と触媒技術	松澤繁光	48	6	583	1997	3:解説	触媒	Ag、シアン、非シアン、光沢、電鍍、皮膜、特性、コハク酸、電気接点、均一電着、つきまわり、硬さ、はんだ着け、接触抵抗、表面
5949	ディ - ゼル車の排気浄化触媒と表面技術	御園生誠	48	6	588	1997	3:解説	触媒	電析、クエン酸、臨界電流密度、浴、Zn、銅鋅、反応、
5950	自動車材料のリサイクル	草川紀久	48	6	592	1997	3:解説	リサイクル	密着、ダイヤモンド、工具、切削、プラズマ、CVD、皮膜、WC-Co、Ni、電極、オキシ水酸化、硝酸ニッケル、電池、電解含浸、多孔PR電解、ピアホール、電析、プリンと配線、Cu、エポキシ樹脂、無電解、ハルズ、
5951	自動車用塗膜の酸性雨及び紫外線劣化対策における表面技術	田海俊弥	48	6	598	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	耐食、炭化ケイ素、酸化皮膜、Si、含浸、SiC、曲げ強度、
5952	自動車用エンジン部品の表面技術と環境技術	小野田元伸	48	6	604	1997	3:解説	環境	フォトクロミック、白、顔料、合成、
5953	インターネットで表面技術情報を活用するための手法	神長京子	48	6	610	1997	3:解説	インターネット	密着、付着、超硬質膜、ダイヤモンド、c-BN、CLC、CVD、工具、耐熱性、スクラッチ試験、界面自由エネルギー
5954	表面技術関連のホームページの紹介	井手本康 小浦延幸	48	6	615	1997	3:解説	インターネット	密着性、付着、スパッタリング、磁性膜、ハードディスク、磁気ディスク、シミュレーション、微細構造、硬さ、摩擦、
5955	電顕画像データベースえみりあ(EMILIA)の紹介	谷山 明 進藤大輔	48	6	618	1997	3:解説	データベース	密着性、付着力、高分子、蒸着、放電処理、エッチング、プラズマ、
5956	金材技研におけるネットワークの構築と運用	山崎政義 山内 泰	48	6	623	1997	3:解説	インターネット	
5957	インターネットを利用した文献検索	井上泰志 高井 治	48	6	629	1997	3:解説	インターネット	
5958	インターネットとイントラネット	杉本則彦	48	6	635	1997	10:比べてみよう	インターネット	
5959	難めっき金属の前処理 (3)マグネシウム合金	矢部 賢	48	6	637	1997	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	
5960	非シアン浴から得られた光沢銀電析物の皮膜特性	正木征史 井上博之 山川宏二	48	6	643	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	
5961	クエン酸を含有する硫酸塩浴からの亜鉛電析の臨界電流密度	Win-MAW-SOE 大貝 猛 秋山徹也 福島久哲	48	6	649	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	
5962	密着性に優れたダイヤモンド被覆工具による Al-18Mmass% Si 合金の切削特性	木山信道 坂本幸弘 高谷松文	48	6	653	1997	5:原著論文	B01.化学蒸着(CVD)	
5963	硝酸ニッケル水溶液から析出されたオキシ水酸化ニッケルの電極特性	佐々木康 山下嗣人	48	6	658	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	
5964	PR 電解法によるピアフィリングの形成	藤波知之 小林 健 眞庭朝夫 本間英夫	48	6	660	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	
5965	シリコン含浸 SiC に形成された酸化皮膜の沸騰濃硫酸環境下における耐食性	二川正敏 小貫 薫 R.W.Steinbrech 好永俊宏 森下正育 長岡 茂	48	6	662	1997	5:原著論文	耐食	
5966	フォトクロミック白色顔料の調整	今井 八郎	48	6	664	1997	8:Letters	A05.塗布・塗装	
5967	インキュベ - タとしての大学の役割	今井 八郎	48	7	671	1997	1:巻頭言		
5968	超硬質膜の付着力・密着性	村川正夫 竹内貞雄	48	7	672	1997	3:解説	密着性	
5969	スパッタ法による磁性膜の付着力・密着性	星 陽一	48	7	678	1997	3:解説	密着性・	
5970	高分子薄膜及び高分子への蒸着における付着力・密着性	鈴木一博	48	7	682	1997	3:解説	密着性	

5971	湿式成膜における密着性確保の指針と実際	平松 実, 日野 実, 小見 崇	48	7	687	1997	3:解説	密着性	密着性、付着、湿式製膜、めっき、評価、前処理、銅鍍、セラミックス、後処理、スクラッチ試験、プラスチック、セラミックス、
5972	半導体超伝導薄膜の付着力、密着性 - 基板の重要性 -	鈴木敏正, 櫻井 伸, 飯塚完司	48	7	692	1997	3:解説	密着性	密着性、付着、半導体、超伝導体、MBE、GaAs、YBCo、素地、エピタキシャル、顕微ラマン、
5973	ガラスへのコーティングの密着性	鈴木すすむ	48	7	698	1997	3:解説	密着性	密着性、ガラス、コーティング、付着、引っぱり試験、CVD、スパッタリング、イオン注入、イオンビーム照射、前処理、
5974	光学薄膜の密着性	栗山桂司	48	7	703	1997	3:解説	密着性	密着、薄膜、光学、テープテスト、ガラス、Si、PMMA、プラスチック、前処理、洗浄
5975	LEEDとRHEED	日比野浩樹	48	7	710	1997	10:比べてみよう	表面分析	LEED、RHEED、表面分析、反射電子線回折、反射高速電線線回折前処理、めっき、電析、難めっき、ステンレス、酸浸析、脱脂、無電解めっき、
5976	難めっき金属の前処理 (4) ステンレス鋼	矢部 賢	48	7	713	1997	9:シリーズ-2	前処理	電析、電鍍、アルカリ性、浴、Pt、硬さ、耐摩耗性、装飾、ガラス工業、X線、光沢
5977	ヘキサヒドロオクソ白金酸塩を用いたアルカリ白金電鍍浴	鎗田聡明, 来田勝継	48	7	719	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	スパッタリング、Ti、C、N、TiC-TiN、トライボロジー耐摩耗、複合、MRスパッタリング、組成、硬電析、浴、水溶液、Cd、Te、CdTe、太陽電池、半導体、めっき、X線、結晶
5978	RFスパッタリングによるTiC - TiN複合皮膜の作製とそのトライボロジー特性	今田康夫, 百武秀治, 本多文洋, 中島耕一	48	7	723	1997	5:原著論文	A01.物理蒸着(CVD)	防臭、自動車、表面処理、臭、クロマト処理、酸洗浄、塗布、塗装、エアコン、親水性、臭気、アルミナ、研磨、パレル、複合、植物、セラミックス、耐摩耗、耐熱、粉体、研磨剤、パレル研磨、
5979	アンモニア-アルカリ性水溶液からのCdTe電析に及ぼす電解液組成の影響	平藤哲司, 稲嶺正一, 二井一志, 栗倉泰弘	48	7	728	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	防臭、自動車、表面処理、臭、クロマト処理、酸洗浄、塗布、塗装、エアコン、親水性、臭気、アルミナ、研磨、パレル、複合、植物、セラミックス、耐摩耗、耐熱、粉体、研磨剤、パレル研磨、
5980	自動車用エアコンの臭気抑制 - 表面処理皮膜臭とその抑制	金子秀昭, 竹中 修, 水野博好	48	7	733	1997	5:原著論文	防臭	防臭、自動車、表面処理、臭、クロマト処理、酸洗浄、塗布、塗装、エアコン、親水性、臭気、アルミナ、研磨、パレル、複合、植物、セラミックス、耐摩耗、耐熱、粉体、研磨剤、パレル研磨、
5981	アルミナ複合植物研磨材によるパレル研磨(第2報) - アルミナ系複合セラミックスの研磨	竹内茂夫	48	7	740	1997	5:原著論文	C01.機会研磨・研削	防臭、自動車、表面処理、臭、クロマト処理、酸洗浄、塗布、塗装、エアコン、親水性、臭気、アルミナ、研磨、パレル、複合、植物、セラミックス、耐摩耗、耐熱、粉体、研磨剤、パレル研磨、
5982	表面技術における志向性	大野 涼	48	8	751	1997	1:巻頭言	環境	環境、塗料、業界、対策、VOC
5983	環境問題への塗料業界の取り組み	増田 平	48	8	752	1997	3:解説	環境	環境、塗料、業界、対策、VOC
5984	<塗料メーカーへの対応> 防食塗料の無溶剤化とその応用	飯田真司	48	8	755	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	塗料、環境、防食、溶剤、VOC、作業、水性、粉体塗料、静電塗装、テープ、フィルム
5985	<塗料メーカーへの対応> 環境対応における水性塗料の進歩	朝倉光彦	48	8	760	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	塗料、水性塗料、環境、VOC、防食
5986	<塗料メーカーへの対応> 粉体塗料の開発とその応用	倉内健生	48	8	765	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	粉体、塗料、開発、応用、コーティング、VOC、環境、ポリエステル、静電塗装、流動浸漬法、溶剤、塗料、塗装、回収、装置、蒸留法、環境、有機溶剤、蒸留
5987	<機器メーカーへの対応> 普及型溶剤回収装置	杉本 久	48	8	771	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	塗装、静電塗装、装置、屋外、塗料ミスト、評価、構造物、ポリエステル、
5988	<機器メーカーへの対応> 屋外塗装に適する静電塗装機の開発	杉本 久	48	8	776	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	スプレー、塗装、環境、装置、VOC、エアースプレー、静電スブ
5989	<機器メーカーへの対応> スプレー塗装機の低圧化	森田信義	48	8	781	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	塗装、耐食、長寿命、再塗装、橋梁、防食、省行程、品質管理、
5990	<ユーザーサイドへの対応> JHにおける省工程塗装への取り組み - 鉄道路橋を対象として -	藤原 博	48	8	789	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	塗料、塗装、無機、環境、環境
5991	無機塗料の適用	田中 一	48	8	795	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	アルゼンチン、韓国、
5992	アルゼンチンと韓国	高井 治	48	8	801	1997	10:比べてみよう	A05.塗布・塗装	アルゼンチン、韓国、
5993	亜鉛系合金めっきの管理のポイント	青江徹博	48	8	803	1997	9:シリーズ-2	B02.電気めっき・電鍍	Zn、合金、めっき、電析、管理、Ni、Zn-Ni、Fe、Zn-Fe、Sn、Zn-Sn、Co、Zn-Co、浴、耐食、
5994	フッ素樹脂塗装鋼板の加工法に及ぼすポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)の結晶構造の影響	川西勝次	48	8	811	1997	5:原著論文	A05.塗布・塗装	フッ素樹脂、鋼板、ポリフッ化ビニリデン樹脂、結晶構造、加工性、PVDF、塗装、
5995	塗装アルミニウムイ板のシリコン系シーリング材による汚染状態の解析	宇野清文, 伊藤研策, 北野博巳, 吉岡中田毅, 和田一郎, 今井八郎, 池島賢司, 井上晃一郎, 渡	48	8	815	1997	5:原著論文	A05.塗布・塗装	塗装、Al、シリコン、汚染、板、暴露試験
5996	Al単結晶表面上へのジンケート処理と無電解Ni-Pめっき	今井八郎, 池島賢司, 井上晃一郎, 渡	48	8	820	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Al、単結晶、ジンケート処理、無電解めっき、Ni、P、Ni-P、構造、ハードディスク、結晶面、カソード分極、水素脆化、合金、Ni-Ti、Ti、Ni、めっき、電析、水素、機械的性質、
5997	カソード分極に伴う50.9at% Ni-P合金の水素脆性化	羽木秀樹, 水野 誠, 伊部壽夫	48	8	826	1997	5:原著論文	水性脆化	アーク、溶射、電解アーク、合金、皮膜、特性、鋼、Fe、フレーム溶射、腐食、試験、構造、
5998	電解アーク加熱処理した自溶合金溶射皮膜の特性	森本純司, 山口昭雄, 富江通雄, 楠原孝良	48	8	732	1997	7:速報論文	A02.溶射	アーク、溶射、電解アーク、合金、皮膜、特性、鋼、Fe、フレーム溶射、腐食、試験、構造、
5999	逆さに見れば	高井 治	48	9	839	1997	1:巻頭言		
6000	「小特集 / 金属建材における表面処理」の企画に当たって	渡辺豊文	48	9	840	1997			
6001	住宅建材の耐久性と必要性能	石本徳三郎	48	9	841	1997	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	建材、耐久性、外装、防水、強度、断熱、斜音、防火、耐候、外屋外、建材、塗装、防錆、塗料、電着塗料、粉体塗料、
6002	屋外建材の塗装	佐藤忠明	48	9	847	1997	3:解説	A05.塗布・塗装	住宅、建材、鋼板、塩水噴霧、環境、溶融めっき、ステンレス、暴露
6003	住宅用建材	増原憲一	48	9	853	1997	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	暴露
6004	スチールハウス用形鋼の耐久性	竹本好文	48	9	859	1997	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	スチールハウス、鋼板、耐久性、
6005	住宅内部の腐食環境と亜鉛系めっき鋼板の耐食性	藤田 栄	48	9	865	1997	3:解説	めっき	建材、耐食、加速試験、形鋼、腐食、環境、建材、ない層、鋼板、耐食、Zn、防錆、ACM型腐食
6006	電気めっきにおける膜厚シミュレーション	小林和幸, 川向博史	48	9	873	1997	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	電析、メッキ、膜厚、シミュレーション、理論、ハルセル試験、スパッタリング、膜厚、シミュレーション、モンテカルロシミュレーション、
6007	薄膜プロセスにおけるスパッタ成膜シミュレーション	多賀康訓	48	9	879	1997	3:解説	A01.物理蒸着(CVD)	溶射、HVOF、プラズマ溶射、皮膜、残留応力、機構、シミュレーション、ガス炎溶射
6008	溶射のシミュレーション	黒田聖治	48	9	885	1997	3:解説	A02.溶射	溶射、HVOF、プラズマ溶射、皮膜、残留応力、機構、シミュレーション、ガス炎溶射
6009	光学薄膜の分光特性シミュレーション	栗山桂司	48	9	890	1997	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	工学、分光、薄膜、シミュレーション、計算、反射、フィルター、干

6010	有限要素法による表面密着性解析	神谷豊晴,重松浩一,近藤市治,金原	48	9	895	1997	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	有限要素法, 薄膜, 表面, 密着, 解析, 応力, 剥離, 破壊, 界面応
6011	境界要素法による腐食・防食のシミュレーション	宮坂松甫,青木 繁	48	9	900	1997	3:解説	腐食,防食,	境界要素法, 腐食, 防食, シミュレーション,
6012	半導体の表面研磨(MCPとCMP)	江口和弘	48	9	906	1997	10:比べてみよう	C01.機会研磨・研削	半導体, 研磨, LSI, 機械研磨, 化学研磨, 微細加工, イオンエッチング, 光沢, 基板
6013	スルホ - ルめっきのポイント	内藤 薫	48	9	908	1997	9:シリーズ-2	B03.無電解めっき	スルーホールめっき, 無電解めっき, サブストラクティブ, 脱マスト, ソフトエッチング, 活性化処理, 触媒, プレディッピング, 前処理, イオンミキシング, インピーダンス, Ti, Al, N, ダイナミックイオンミキシング, AFM, 電気化学特
6014	ダイナミックイオンミキシング法によるTi-Al ₂ O ₃ 膜の電気化学インビタンス特性	神谷 誠,中村 勲,鷹野一朗,沢田芳夫	48	9	913	1997	5:原著論文	A01.物理蒸着(CVD)	Cr, めっき, 腐食, 機構, 酸素処理, 電析, 腐食試験, 耐食性, 封孔処理, クラック, 割れ, デンドリマー, センサー, 表面修飾, コバルトポリフィリン, 電極, 酸素, Co, O,
6015	酸素処理水中におけるクロムめっきの腐食機構	岡田亮二,沢口啓二	48	9	919	1997	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	溶解塩めっき, 鋼板, 組織, 構造, Zn, Al, Zn-Al, 合金, 銅, めっき
6016	デンドリマー側鎖を有するコバルトポリフィリンを表面装飾した電極系の酸素センサーとしての検討	湯浅 真,星 周,関根 功	48	9	924	1997	5:原著論文	C07.その他(新技術を含む)	Si, レーザ, レーザアロイング, Ti, 表面改質, 表面硬化, ケイ化物, 耐摩耗
6017	二段階溶解Zn-Alめっき鋼のめっき層組織とその形成挙動	田中順一,益田雄策,武市知明,阪口寛,成田敏夫,重松一典,中村 守,	48	9	929	1997	5:原著論文	溶解塩めっき	
6018	シリコンを用いたレーザアロイングによる工業用純チタンの表面改質	山田康雄,斉藤尚文,馬淵 守,中西勝,下島康嗣,清川 肇,池田隆一,	48	9	937	1997	13:研究ノート	レーザアロイング	
6019	はっ水性Ni-P合金複合めっき皮膜の電析	鄭容宝,米沢 晋,高島正之	48	9	939	1997	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	はっ水性, 複合めっき, 電析, 皮膜, Ni-P, Ni, P, PTFE, 分散めっき, 微粒子,
6020	ごみ焼却炉環境における溶射皮膜の耐高温腐食性	森本純司,山口昭雄,山田勝弘,清水重雄	48	9	941	1997	7:速報論文	A02.溶射	焼却炉, 環境, 溶射, 皮膜, 耐食, 高温腐食, 爆発溶射, Ni-Cr, Ni, Cr, 合金, ボイラー,
6021	公設試における表面技術研究開発強化のために	久米道之	48	10	947	1997	1:巻頭言		
6022	素材合金と表面処理	海老原健	48	10	948	1997	3:解説	合金	合金, Al, 表面改質, 調質, 組成, 強度, 陽極酸化
6023	Al建材の表面処理の現状と課題	川端 清	48	10	956	1997	3:解説	B07.アノード酸化	建材, 陽極酸化, Al, カラー, 構造, 耐候性, 塗装, 封孔, 化成皮膜, 着色, 環境
6024	自動車車体用Al合金の表面処理技術	石井 均	48	10	961	1997	3:解説	B08.化成処理	自動車, 表面処理, 合金, Al, リン酸処理, 化成処理, P, Zn, フッ素, F, 塗装, 密着, クリオライト, 缶, 表面処理, Al, 化成処理, ADI缶, 脱脂, エッチング, クロメート処理, リン酸クロメート処理, 塗装, 密着
6025	アルミニウム飲料缶の表面処理	堀口 誠	48	10	966	1997	3:解説	B08.化成処理	PS版, 表面処理, Al, 光感光性, リソグラフ, 陽極酸化, 印刷, Al, コンデンサ, 箔, 表面処理, 電解コンデンサ, エッチング, 陽極酸化, 皮膜, ハードディスク, Al, 基板, 表面処理, Ni-P, 無電解めっき, ジンケート処理, 硬さ, アノード酸化, Al, 細孔, 長距離秩序, アルミナ, 陽極酸化, 誘電体, 固体電解質, ポリビニール, アルミナ, コンデンサ, 周波数特性, 陽極酸化, Al, アルマイト, 触媒, 細孔, 排ガス, XANES, EXAFS, 表面分析, 装置, 原理, IC, LSI, リードフレーム, はんだ, めっき, Pb, Sn, Pb-Sn,
6026	PS版の表面処理	高田輝雄	48	10	971	1997	3:解説	PS版	
6027	アルミニウム電解コンデンサの表面処理の現状と課題	神崎信義	48	10	976	1997	3:解説	C03.化学エッチング・電解エッチング	電解コンデンサ, エッチング, 陽極酸化, 皮膜
6028	ハードディスク(HD)基板の表面処理の現状と課題	斉藤昌弘,山中郁雄	48	10	982	1997	3:解説	B03.無電解めっき	ハードディスク, Al, 基板, 表面処理, Ni-P, 無電解めっき, ジンケート処理, 硬さ,
6029	陽極酸化アルミナ細孔配列の長距離秩序化	益田秀樹	48	10	986	1997	3:解説	B07.アノード酸化	アノード酸化, Al, 細孔, 長距離秩序, アルミナ,
6030	誘電体と固体電解質層の電解同時形成処理	直井勝彦,武田政幸	48	10	990	1997	3:解説	B07.アノード酸化	陽極酸化, 誘電体, 固体電解質, ポリビニール, アルミナ, コンデンサ, 周波数特性, 陽極酸化, Al, アルマイト, 触媒, 細孔, 排ガス,
6031	アルマイト触媒体	亀山秀雄	48	10	994	1997	3:解説	B07.アノード酸化	陽極酸化, Al, アルマイト, 触媒, 細孔, 排ガス,
6032	XANSとEXAFS	佐藤 登	48	10	998	1997	10:比べてみよう	表面分析	XANES, EXAFS, 表面分析, 装置, 原理,
6033	ICリードフレーム外装はんだめっき	大平武征	48	10	1000	1997	9:シリーズ-2	B02.電気めっき・電鍍	IC, LSI, リードフレーム, はんだ, めっき, Pb, Sn, Pb-Sn,
6034	スルホコハク酸錯体からのスズ - 亜鉛合金めっき	縄舟秀美,池田一輝,水本省三,竹内孝夫,青木和博,田中順一,益田雄策,樹本亮治,大笹憲一,成田敏夫,安住和久,藤重祐介,瀬尾真浩,佐伯功,Leonard,NANIS,中尾英弘,田代雄彦	48	10	1007	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Sn, Zn, Sn-Zn, 合金, めっき, 電析, スルホコハク酸, 浴,
6035	Fe-Zn合金層とZn-Al融液との反応	田中順一,益田雄策,樹本亮治,大笹憲一,成田敏夫,安住和久,藤重祐介,瀬尾真浩,佐伯功,Leonard,NANIS,中尾英弘,田代雄彦	48	10	1012	1997	5:原著論文	A03.熔融めっき	溶誘めっき, Fe, Zn, Al, Fe-Zn, Zn-Al, 合金, 反応, 構造,
6036	Al合金のジンケート前処理におよぼす表面調整の効果	瀬尾真浩,佐伯功,Leonard,NANIS,中尾英弘,田代雄彦	48	10	1019	1997	5:原著論文	B03.無電解めっき	Al, 合金, シンケート処理, 前処理, XPS, 構造, Al-Mg, 反応
6037	室温近傍における再生Pbの酸化挙動に及ぼす不純物の影響	山口正美,平沢今吉	48	10	1025	1997	5:原著論文	酸化	Pb, 再生, 不純物, 酸化, 挙動, 環境, 回収,
6038	アルカリ白金電鍍浴の白金めっきチタン電極への応用	鎗田聡明,澤田松範	48	10	1032	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Pt, Ti, 電鍍, アルカリ, 電極, めっき, 電析,
6039	AIP法で形成したTiAlN膜による耐熱チタン合金の耐酸化性の改善	山本兼司,佐藤俊樹,大山英人	48	10	1035	1997	7:速報論文	A01.物理蒸着(CVD)	アーケイオンプレーティング, AIP, TiAlN, Ti, 合金, 耐酸化, 酸化皮膜, 耐摩耗, 耐熱,
6040	超ローカルなはなし「特集/マルチメディア時代における真空装置と薄膜応用」の企画に当たって	桜井武広	48	11	1042	1997			
6041	1.半導体の最新動向と真空装置 - 半導体と真空装置	前田和夫	48	11	1043	1997	3:解説	A01.物理蒸着(CVD)	半導体, 真空, 装置, LSI, 微細加工
6042	1.半導体の最新動向と真空装置 - ULSI配線技術の動向	上野和良	48	11	1050	1997	3:解説	微細加工	微細加工, 配線, LSI, ULSI, ダマシシ, 多層, めっき, スパッタリング, CVD, PVD, Ti, TiN, Cu, デュアルダマシシ, マイグレーション, アスペクト,
6043	1.半導体の最新動向と真空装置 - 高誘電率薄膜成膜技術	川原孝昭	48	11	1054	1997	3:解説	B01.化学蒸着(CVD)	誘電, 薄膜, 比誘電率, SiO ₂ , Si ₃ N ₄ , キャパシタ, リソグラフィ, CVD, BST, 半導体

6045	II. ディスク・ヘッド技術の最新動向と真空技術 - 磁気ディスク・ヘッド技術の動向	田上勝通	48	11	1059	1997	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	磁気ディスク、ヘッド、メモリー、MRヘッド、長手記録、SN比、
6046	II. ディスク・ヘッド技術の最新動向と真空技術 - 光ディスク・DVD量産装置	太田 淳.五十嵐日出明.吉瀬寿彦.長沢昭治	48	11	1065	1997	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	光ディスク、磁気ディスク、スバツタリング、装置、製膜
6047	II. ディスク・ヘッド技術の最新動向と真空技術 - 超高密度薄膜磁気記録媒体 - 次世代ハードディスクと真空成膜装置	高橋 研	48	11	1070	1997	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	磁気メモリー、記録密度、ハードディスク、真空装置、構造、スバツタリング、磁気、薄膜、GMR、薄膜、成膜、装置、磁気ヘッド、磁気抵抗効果、比抵抗、磁場中成膜、ハードディスクCVD、薄膜、半導体、表面改質、アモルファスシリコン、シリコン、SiN、Si、CVD、cat-CVD、GaAs半導体、真空技術、ULSI、誘電率、磁気ディスク、ヘッド、光ディスク、記録密度、記録媒体、DVD、装置、薄膜、GMR、成膜、CVD、表面改質、cat-CVD
6048	II. ディスク・ヘッド技術の最新動向と真空技術 - GMRと成膜装置	恒川孝二	48	11	1076	1997	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	ページ1091、和田和六は和田洋六・表面処理、排水、環境、水、シアン、沈殿分離、浮上分離、酸、アルカリ、固液分離、スラック摩擦、摩擦、潤滑、Ni-B、Ni、B、無電解めっき、めっき、錯化剤、構造、耐摩耗性、DMAB、X線、アモルファス、電析、めっき、浴、膜、構造、アルカリ、Pt、Sn、構造、硬さ、X線、合金、Pt-Sn、耐熱性、耐食性電析、めっき、Cu、機械的性質、不純物、表面形態、結晶構造、X線、配向、結晶粒径、Ni、電析、めっき、残留応力、Zn、表面形態、反応、結晶構造、浴、電流電位
6049	III. マルチメディアデバイス最前線 - cat-CVD法を用いた薄膜堆積と半導体表面改質	和泉 亮.松村英樹	48	11	1082	1997	3:解説	B01.化学蒸着(CVD)	分散めっき、複合めっき、電析、めっき、分散粒子、粉体、ゼータ電位、共析、疎水性、CF、親水性、界面活性剤、Zn、Fe、Ni、Co、浴、電析、めっき、合金、チオシアン酸、硫酸塩浴、Zn-Fe、Zn-Ni、Zn-Co、赤外線半導体レーザー、分子線、超音波分子線、ビーム、エビタキシャル、Fe、カルボニル錯体、回EQCM、QCM、Au、Pd、析出、サイクリックポルタンメトリー、反酸化、構造、皮膜、内部酸化、Fe-Al、合金、Fe、H2-H2O-Ar、
6050	用語解説	桜井武広	48	11	1088	1997	18:用語	A10.その他(新技術を含む)	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6051	表面処理排水の環境対策	和田和六	48	11	1091	1997	3:解説	排水	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6052	摩擦と摩耗	森 誠之.七尾英孝	48	11	1097	1997	10:比べてみよう	摩擦、摩耗	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6053	無電解NiBめっきにおける錯化剤の影響	金 満.東川太一.飯塚 淳.逢坂哲彌	48	11	1099	1997	5:原著論文	B03.無電解めっき	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6054	アルカリ性白金 - スズ合金浴からの析出物の特性	鎗田聡明.来田勝継	48	11	1105	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6055	銅電析皮膜の表面形態と機械的性質におよぼす不純物の影響	横田俊子	48	11	1109	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6056	Niめっき膜の残留りに及ぼす亜鉛イオンの影響	津留 豊.徳田朋稔	48	11	1115	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6057	分散粒子ゼータ電位と共析	山口文雄.小浦延幸.根岸秀之	48	11	1119	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6058	硫酸塩浴からの亜鉛 - 鉄属金属合金電析に及ぼすチオシアン酸イオンの影響	矢野正明.Win-MAIW-SOE.大貝 猛.秋山徹也.福島	48	11	1124	1997	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6059	赤外線半導体レーザーを用いた超音速分子線中のFeカルボニル錯体の回転・並進状態の評価	本田数博	48	11	1131	1997	13:研究ノート	A10.その他(新技術を含む)	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6060	EQCM法による金電極上のパラジウムの析出状態の評価	有泉直子.柴田正美.古屋長一	48	11	1134	1997	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6061	H2-H2O-Ar混合ガス中で酸化したFe-1.26および2.12mass%Al合金の組成変化	田中成徳.渡辺 徹.寺島慶一.山崎桓友	48	11	1136	1997	8:Letters	酸化	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6062	東北地域における表面技術	松永利昭	48	12	1141	1997	1:巻頭言		水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6063	特集「エネルギー分野を支える表面技術」の企画に当たって	釜崎清治	48	12	1142	1997			水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6064	水素エネルギーの活用 - 水素吸蔵合金の役割と表面技術 -	天野宗幸	48	12	1143	1997	3:解説	水素	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6065	高性能リチウムイオン電池の電池自動車およびハイブリット型電気自動車への適用研究	堀江英明	48	12	1148	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6066	燃料電池搭載電気自動車	木村良雄	48	12	1153	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6067	太陽電池を支える表面技術	中野昭一.酒井総一	48	12	1158	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6068	電気二重層キャパシタを支える表面技術	吉田昭彦	48	12	1163	1997	3:解説	キャパシタ	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6069	ニッケル・水素電池と表面技術	神田 基	48	12	1169	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6070	リチウム電池と表面技術 - 負極と表面改質 -	森田昌行	48	12	1176	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6071	リチウム電池と表面技術 - ポリマー(有機イオウ系)正極の表面改質 -	直井勝彦.森 満博	48	12	1183	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6072	電気自動車用電池と表面技術	佐藤 登	48	12	1189	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6073	高分子電解質燃料電池(PEFC)と表面技術	松沢繁光	48	12	1196	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6074	溶融炭酸塩型燃料電池と表面技術	小浦延幸	48	12	1201	1997	3:解説	電池	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6075	無水フッ化水素で表面改質したLaNi _{4.7} Al _{0.3} の水素吸蔵特性に及ぼす大気保存の影響	伊藤 学.青野文昭.小菅明良.平山良司.菊山裕久.釜崎 青野文昭.伊藤 学.中澤 亨.小菅明良.内田裕久.平山良司.菊山裕久.釜崎 湯淺 真.鳥居広康.糸内友一.五喜田将紀.関根 功	48	12	1207	1997	5:原著論文	水素吸蔵	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6076	無水フッ化水素で表面改質したLaNi _{5-x} Al _x (x=0.0,0.3)の水素化・脱水素化特性に及ぼすCOの影響	伊藤 学.青野文昭.小菅明良.平山良司.菊山裕久.釜崎 湯淺 真.鳥居広康.糸内友一.五喜田将紀.関根 功	48	12	1212	1997	5:原著論文	水素吸蔵	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ
6077	多量化コバルトポルフィリン / 高分子配位子系を表面修飾した電極による酸素還元:分子構造と酸素還元電位電極触媒活	伊藤 学.青野文昭.小菅明良.平山良司.菊山裕久.釜崎 湯淺 真.鳥居広康.糸内友一.五喜田将紀.関根 功	48	12	1218	1997	5:原著論文	電極	水素、H、水素吸蔵、エネルギー、合金、表面技術、水素化、ラーベース合金、ミッシュメタル、水素圧力、水素電池、水素自動車、貯蔵、輸送、ヒートポンプ

6078	電解法によりアルマイト上に固定したTiO ₂ の光触媒活性	松本泰道 中西千夕起,石川善恵,鯉沼陸央,八代伸光	48	12	1225	1997	5:原著論文	触媒	電解,アルマイト,光触媒,TiO ₂ ,Ti,XPS,チタニルアンモニウム
6079	メソフェーズ系カーボン薄膜電極の作成とリチウム脱挿入挙動	李 栖宗,内田 勇	48	12	1227	1997	5:原著論文	電極	電極,カーボン薄膜,Li,メンフェーズ,サイクリックボルタモグ
6080	ペロブスカイト型酸化物のNOx検知特性	杉山和夫,栗原香暁,田中伸一,七海昌昭,浅野洋一,大山下嗣人,阿部 聡,宮川博司	48	12	1229	1997	5:原著論文	センサー	センサー,ペロブスカイト,酸化物,NOx,希土類,酸化物半導体,
6081	カーボンプラスチック上における臭素の電極反応	山下嗣人,阿部 聡,宮川博司	48	12	1231	1997	5:原著論文	電極	電極,カーボンブラック,電極反応,Br,平衡論
6082	臭化物イオンを含む臭化亜鉛水溶液中における亜鉛の腐食に及ぼす非イオン界面活性剤の影響	山下嗣人,杉森庸一郎	48	12	1233	1997	8:Letters	腐食	腐食,界面活性剤,Br,Zn,水溶液,
6083	Al ₂ O ₃ 粉末とのボールミルによる水素吸蔵合金LaNi ₅ の表面改質	釜崎清治,金山琢也,見崎吉成,山田釜崎清治,木原 勝,見崎吉成,山田正昭	48	12	1235	1997	8:Letters	水素吸蔵	Al,Co,水素吸蔵,合金,表面改質,ボールミル,LaNi ₅ ,La,Ni,
6084	アルカリ前処理したAB5型水素吸蔵合金のNi-MH電池負極特性	釜崎清治,木原 勝,見崎吉成,山田正昭	48	12	1237	1997	8:Letters	水素吸蔵	水素吸蔵,前処理,アルカリ,電池,AB5型,Ni-MH,Ni
6085	第95回講演大会報告	千葉和茂	48	12	1239	1997			
6086	年頭所感	本間英夫	49	1	1	1998	1:巻頭言	経済	
6087	[小特集・湿式法による化合物薄膜の作製・構造と物性]の企画に当たって	佐藤祐一	49	1	2	1998	23:小特集	B04.アノード析出	アノード酸化
6088	ソフト溶液電気化学プロセス(SSEP)による機能性酸化物膜の作製	松本泰道	49	1	3	1998	3:解説	B04.アノード析出	ソフト溶液,電気化学のプロセス,機能性酸化物
6089	電着法による化合物半導体薄膜の作製	高橋 誠,魚崎浩平	49	1	7	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	電着,半導体,薄膜
6090	電解法による二次電池用Ni(OH) ₂ 電極の作製	桑島三郎,中村敏昭,鶴田慎司	49	1	15	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	電気化学的注入,Ni,二次電池,水素
6091	電解法によるECD用イリジウム酸化物薄膜の作製	吉野隆子	49	1	20	1998	3:解説	B04.アノード析出	Ir,エレクトロクロミズム,電析,酸化還元
6092	電解法による高温超伝導酸化物薄膜の作製	根岸秀之,井手本康,小浦延幸	49	1	25	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	電解,電析,薄膜,高温Tc,超電導体
6093	液相析出法(LPD法:Liquid Phase Deposition)による機能性薄膜材料の合成	出来成人,青井芳史	49	1	30	1998	3:解説	B08.化成処理	LPD,薄膜,機能材料,水溶液
6094	液相析出法(LPD法:Liquid Phase Deposition)による電子材料の作製	阪井康人	49	1	35	1998	3:解説	B08.化成処理	LPD,Si,LCD
6095	チタンのアノード酸化物薄膜の構造と物性	安住和久	49	1	39	1998	3:解説	B07.アノード酸化	Ti,陽極酸化皮膜,腐食,応用
6096	表面処理排水のリサイクル	和田洋六	49	1	44	1998	9:シリーズ-2	C06.洗浄	イオン交換,オゾン,UV,活性炭
6097	工学系学協会		49	1	51	1998	10:比べてみよう		
6098	新シリーズ掲載開始にあたって	鈴木峰晴	49	1	53	1998	9:シリーズ-2		
6099	自動車用塗膜の劣化とESRによる解析	辻田隆広,岡本信吾	49	1	54	1998	9:シリーズ-2	A05.塗布・塗装	塗膜,劣化,ESR,ラジカル
6100	分析受託機関の紹介	鈴木峰晴	49	1	59	1998	9:シリーズ-2		
6101	多孔質シリコン層中の化学結合に及ぼす室温エージングの影響	福田芳雄,古屋一夫	49	1	63	1998	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	ポーラス,Si,化学結合,PL
6102	イリジウムめっきチタン電極の電気化学的挙動	佐藤祐一,本田 智,女部田千穂,小早川統一,橋本一朗,牛久栄作	49	1	68	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ir,電析,過電圧
6103	Pbフリーはんだ用Sn-Ag合金めっき・ピロリン酸浴からのPd-Sn合金めっきにおけるジェチレントリアミン五酢酸の影響	新井 進,渡辺 徹,野呂美智雄,藤原裕,榎本英彦,小見正木,征史,吉本雅一,井上博之,本間	49	1	73	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	鉛フリー,電析,Sn,Ag,ハンダ付け
6104	ヨウ化カリウム浴からの銀めっきの電流効率に及ぼすI ² の影響	野呂美智雄,藤原裕,榎本英彦,小見正木,征史,吉本雅一,井上博之,本間	49	1	78	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Pb,Sn,合金,ピロリン酸塩
6105	アルカリ性白金-亜鉛合金浴からの析出物の特性	正木征史,吉本雅一,井上博之,本間	49	1	84	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ag,ヨウ化カリウム,電流効率
6106	窒化ケイ素微粒子上への窒化ケイ素超微粒子コーティング	鎗田聡明,来田勝継,英 敬信,上宮成之,小島紀徳	49	1	88	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Pt,Zn,合金,アルカリ
6107	陰極にダイヤモンドを用いた直流プラズマCVD法によるダイヤモンド薄膜の合成	廣澤さくら,阿部匡朗,山中 博,広瀬洋	49	1	92	1998	7:速報論文	A01.物理蒸着(PVD)	コーティング,Si,Ni,CVD
6108	Hotはお好き? -1997年北海道夏期セミナー報告-	遠藤一彦	49	1	94	1998	7:速報論文	A01.物理蒸着(PVD)	ダイヤモンド,薄膜,プラズマ,カソード
6109	第97回講演大会	小林賢三	49	1	96	1998	編集委員会から		
6110	航空宇宙工業における表面技術の企画に当たって	野口裕臣	49	2	119	1998	1:巻頭言		
6111	航空宇宙工業における表面技術の特異性	高田幸路	49	2	120	1998	23:小特集		
6112	航空宇宙産業がリードする表面技術-電鍍,ケミカルミリング,洗浄-	田尻桂介,神島尚文,梶間一広	49	2	121	1998	2:総説	B07.アノード酸化	高力アルミ合金,疲労破壊,超高力鋼,水素脆性
6113	航空機製造における陽極酸化処理	宮崎洋輔	49	2	127	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	電鍍,ケミカルミリング,洗浄コントロール
6114	航空機における接着前処理技術	菅原恵輔	49	2	133	1998	3:解説	B07.アノード酸化	航空機,陽極処理
6115	航空機の新機体外装塗装システム	首原恵輔	49	2	138	1998	3:解説	C03.化学エッチング・電解エッチング	表面調整,接着,航空機,信頼性
6116	ジェットエンジンにおける表面処理	徳永俊二	49	2	143	1998	3:解説	A05.塗布・塗装	航空機,外装,塗装
6117	航空機降着装置の表面処理	吉川英規	49	2	149	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	ジェットエンジン,修理,熱溶射
6118	ヘリコプターブレードプロテクターのニッケル電鍍	松尾和広	49	2	154	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	超高張力鋼,水素脆性,チキンワイヤークラック
6119	硫酸酸洗と塩酸酸洗	吉野一彦	49	2	161	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	硬質ニッケルめっき,内部応力,金型
6120	ワイヤボンディング界面の分析事例	渡辺豊文	49	2	164	1998	10:比べてみよう	C03.化学エッチング・電解エッチング	硫酸,塩酸
6121	亜硫酸金アンモニウム浴からの電析物	土師 宏	49	2	166	1998	9:シリーズ-2	B02.電気めっき・電鍍	ワイヤボンディング,TEM,AES,亜硫酸金,アンモニウム,パンプ,シアンフリー,硬さ,光沢
6122	プラズマソースイオン注入による3次元立体物へのイオン注入	鎗田聡明	49	2	173	1998	6:技術論文	B02.電気めっき・電鍍	PSII,イオン注入,プラズマ,3D
6123	スパッタリングによるZnS:TbS ₃ 薄膜の形成条件とEL特性	馬場恒明,畑田留理子	49	2	176	1998	5:原著論文	A08.イオン注入	スパッタリング,EL,薄膜,発光
6124	アルカリ脱脂液での脱脂過程の解析	桑野三郎,伊藤芳典	49	2	180	1998	5:原著論文	A01.物理蒸着(PVD)	脱脂速度,油滴径,分散
6125	酸化物薄膜表面の水に対するぬれ性と摩擦係数	須山 聡	49	2	185	1998	5:原著論文	C06.洗浄	酸化物薄膜,濡れ性,親水性,摩擦係数
6126	液体急冷非晶質薄膜上に析出した無電解CoFe系合金めっき膜の析出挙動と性状	大脇健史,多賀康訓	49	2	191	1998	5:原著論文	A04.吸着	無電解めっき,Co,Fe,非晶質,析出挙動,磁気特性
6127	非シアン銀めっきの密着性に及ぼす電極近傍pH変化の影響	丸山耕一,沼田博雄,大野 涼,佐藤正木,征史,吉本雅一,田中恵美子,井上博之,本間英夫,森崎重喜,前野智和,山室正明	49	2	195	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	陽極酸化皮膜,水素含有量,即発線分析,Al
6128	アルミニウム陽極酸化皮膜中の水素の濃度と分析	寺島慶一	49	3	201	1998	5:原著論文	B07.アノード酸化	表面
6129	[表面]の語史	小林道雄	49	3	213	1998	1:巻頭言		
6130	[小特集1.環境規制と代替技術]の企画に当たって	松浦大規	49	3	214	1998	23:小特集		
6131	3価の装飾クロムめっき	青江徹博	49	3	215	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	環境
6132	クロメート代替処理法の動向		49	3	221	1998	3:解説	B08.化成処理	Cr,装飾めっき,代替技術,非クロメート,クロム酸塩,代替,

6134	非シアン浴からのスズ-銀合金めっき	新井 進	49	3	230	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	鉛フリー、はんだ、Sn、Ag、合金、非シアン、状態図、パンブ
6135	Pbフリーはんだめっきの現状	小谷野英勝	49	3	235	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	鉛フリー、Sn、合金、Ag、Bi、Zn
6136	シリコンウエーハのウェット洗浄技術	泉妻宏治	49	3	242	1998	3:解説	C06.洗浄	Si、湿式洗浄、微粒子、汚染、オゾン
6137	シリコン基板表面状態とゲート酸化膜の信頼性	小澤良夫、福元正人、水津康正	49	3	248	1998	3:解説	B07.アノード酸化	Si、予備酸化、ゲート、絶縁破壊、キャリアー
6138	半導体製造におけるシリコンウエーハ乾燥化学増幅レジストへの基板表面状態、雰囲気の影響	伴 功二、佐藤一直	49	3	253	1998	3:解説	C06.洗浄	乾燥、半導体、製造技術
6139	Al-Si-Cu/Ti/TiN/Ti積層配線の結晶配向性と信頼性に及ぼす下地絶縁膜吸湿の影響 [小特集2 / 表面技術と半導体プロセス]の企画に当たって	遠藤政孝	49	3	260	1998	3:解説	A05.塗布・塗装	化学増幅、レジスト、基板、雰囲気、アンモニア
6140	Al-Si-Cu/Ti/TiN/Ti積層配線の結晶配向性と信頼性に及ぼす下地絶縁膜吸湿の影響 [小特集2 / 表面技術と半導体プロセス]の企画に当たって	吉田友幸、大脇健史	49	3	266	1998	3:解説	A04.吸着	Al配線、エレクトロマイグレーション、吸着、テキスター
6141	用語解説	有門経敏	49	3	272	1998	23:小特集		
6142	めっき設備の腐食損傷事例とその対策 (1)	有門経敏	49	3	273	1998	18:用語		
6143	めっき設備の腐食損傷事例とその対策 (1)	中村太一、松井富士夫、中山郁雄	49	3	274	1998	9:シリーズ-2		腐食、防食、設備
6144	試料加熱法による触媒のSEM観察における帯電防止	吉田公一	49	3	280	1998	9:シリーズ-2	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	SEM、触媒、帯電、加熱
6145	某分析屋の午後-SIMS(シムス)分析、AES(オージェ)分析そしてEPMA(イーピーエムエー)分析-	MS	49	3	285	1998	10:比べてみよう		SIMS, AES, EPMA
6146	モード変換型マイクロ波プラズマMOCVD法による(111)配向ZrO2膜の低温堆積	小松洋介、伊藤 滋、明石和夫	49	3	287	1998	5:原著論文	A01.物理蒸着(PVD)	モード変換、マイクロ波プラズマ、MOCVD、Zr、配向膜
6147	電析法による高比抵抗Ni-Fe系軟磁性薄膜の作製	高井まどか、近藤祥、日羅史明、加世田学、達坂哲彌	49	3	292	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	電析、Ni、Fe、比抵抗、軟磁性、有機添加剤
6148	亜硫酸金塩を用いた自触媒型無電解金めっき浴	鎗田聡明	49	3	297	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき、亜硫酸塩、チオシアン酸塩、ヨウ化物
6149	シリカの濃度傾斜をもつ酸素発生用電極触媒皮膜 - 酸化イリジウム-コロイド状シリカ/チタン基体系 -	虫明克彦、松坂菊生	49	3	302	1998	5:原著論文	B05.熱分解・ソルゲル法	Ir、シリカ、傾斜材料、電極触媒、寿命
6150	鉄-タンクステン系合金めっき膜の非晶質化に及ぼすコバルトおよびニッケルの影響	李明、森満正嗣、松永守央	49	3	305	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Fe、W、合金、電析膜、非晶質
6151	紫外線遮へい用アナーゼ型TiO2微粒子の調整	好永俊宏、森下正育、好本昭洋、真嶋三尾、惇、内田聡、仁平宣弘、山田 仁、狩野 茂、岩木正哉	49	3	311	1998	5:原著論文	B05.熱分解・ソルゲル法	Ti、メタチタン酸、UVA、UV遮断
6152	Alイオン注入したTiN膜の高温酸化	正木征史、近藤哲也、井上博之、本間	49	3	316	1998	5:原著論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	Al、イオン注入、TiN、高温酸化
6153	非シアン浴中における銀陽極の溶解挙動	伊藤靖彦、野平俊之	49	3	320	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	非シアン浴、Ag、アノード溶解
6154	Dual Bath法により作製したCu/Ni多層膜の機械的特性	三宅猛司、久米道之	49	3	323	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	機械的性質、Cu、Ni、多層膜、ジュアル浴
6155	卒業生諸君、そして職場の上司の方々へ	佐藤祐一	49	4	329	1998	1:巻頭言		
6156	溶融塩の精製法と取り扱い技術	佐藤 讓	49	4	331	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	溶融塩、ハロゲン化合物、精製、取り扱い法
6157	溶融塩電気化学プロセスによる表面改質	伊藤靖彦、野平俊之	49	4	336	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	表面改質、溶融塩、電気化学のプロセス、注入、薄膜
6158	耐火金属の溶融塩からの電析	沼田博雄	49	4	341	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	電析、溶融塩、耐火金属
6159	アルミニウムスクラップの再生を目指した溶融塩電解	石川達雄、上田幹人	49	4	347	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	スクラップ、Al、溶融塩、電解精製、ハイポラー
6160	塩化物溶融塩浴からの非晶質Al-Mn合金めっき	内田淳一、平山克郎	49	4	352	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	溶融塩、電析、非晶質、合金めっき
6161	原子炉の使用済み核燃料の乾式再処理技術 - 溶融塩電解精製法を用いた核分裂生成物の分離 -	藤田玲子	49	4	356	1998	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	燃料再利用、熱化学プロセス、溶融塩、超ウラン元素、核分裂生成物
6162	常温溶融塩からの電析 - とくにAlコーティングを中心として -	高橋節子	49	4	361	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	溶融塩、Al、電析
6163	常温型溶融塩からの合金電析	小浦延幸、井手本康、松本 哲	49	4	366	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	電析、合金、常温型溶融塩
6164	めっき設備の腐食損傷例とその対策 (2)	仲村太一、松井富士夫、中山郁雄	49	4	371	1998	9:シリーズ-2	A10.その他(新技術を含む)	腐食、環境、事例
6165	亜鉛系めっき鋼板上に生成する腐食生成物の構造解析	橋本 哲	49	4	378	1998	9:シリーズ-2	B02.電気めっき・電鍍	Zn、鋼板、腐食生成物、表面分析
6166	GaAsとSi	吉田直人	49	4	383	1998	10:比べてみよう		Ga, As, Si
6167	表面制御された超はっ水性皮膜のマイクロ波プラズマCVD法による作製	穂積 篤、高井 治	49	4	385	1998	5:原著論文	B01.化学蒸着(CVD)	超撥水性、マイクロ波、CVD、AFM
6168	自動車用エアコンの臭気抑制 - 微生物に起因する腐敗臭とその抑制 -	水野博好、竹中修、内山一寿、金子高谷泰之、富田友樹、谷 和美、稲葉光晴、原田良夫	49	4	391	1998	5:原著論文	A04.吸着	エアコン、臭気、親水性
6169	WC系サーメット溶射皮膜の分極特性に及ぼすクロムの効果	細倉 匡、丸山耕一、大野 涼、入戸日野 実、西田典秀、平松 実、久我久徳、金谷照人	49	4	396	1998	5:原著論文	A02.溶射	W、Co、Cr、Ni、分極、溶射
6170	多孔質シリコン細孔中に析出した無電解Co系めっき合金の形状および磁気特性	野浪 亨、園田勉、長沼勝義、神谷晶、龜山哲也、許	49	4	401	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	ポーラスシリコン、無電解めっき、垂直磁化
6171	硫酸浴からのZn-Co-シリカ複合めっきに及ぼす界面活性剤の影響	野浪 亨、園田勉、長沼勝義、神谷晶、龜山哲也、許	49	4	407	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	電析、Zn、Co、Si、コンポジット、界面活性剤
6172	純チタンを被覆したTi-4.5Al-3V-2Fe-2Mo基板へのハイドロキシアパタイト粒子の圧入	野浪 亨、園田勉、長沼勝義、神谷晶、龜山哲也、許	49	4	412	1998	7:速報論文	A10.その他(新技術を含む)	超塑性、Ti、水酸アパタイト
6173	第96回講演大会報告	沼田博雄	49	4	414	1998	講演会便り		
6174	「...で、なんなんだい」...「へっ!？」 [小特集1: 抗菌性表面処理技術の最新動向]の企画に当たって	伊藤 滋	49	5	425	1998	1:巻頭言		
6175	家電製品および生活関連資材における抗菌処理の現状	小林道雄	49	5	426	1998	3:解説	A05.塗布・塗装	抗菌材料、家電製品、表面処理、抗菌処理
6176	抗菌性金属表面処理	岡岡敏一	49	5	427	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	抗菌材料、コンポジット、Ni
6177	低温溶射法による光触媒殺菌	小林道雄	49	5	433	1998	3:解説	A02.溶射	バイオケミストリー、光半導体、殺菌
6178	環境マネジメントに関する国際規格 - ISO14000シリーズについて -	桜田 司	49	5	439	1998	3:解説		地球サミット、環境マネージメント
6179	電機・電子業界における認証取得の現状と動向	桑山広司	49	5	445	1998	3:解説		環境マネージメント、認証取得、効果的導入、サポート
6180	ISO 14001自動車業界における認証取得の現状と動向	水野 繕	49	5	452	1998	3:解説		ISO14001、自動車、環境マネージメント
6181	ISO 14001自動車業界における認証取得の現状と動向	保科和宏	49	5	457	1998	3:解説		ISO14001、自動車、環境マネージメント
6182	テ・マノISO 14000シリーズ認証取得	上谷正明、川西秀明、清川卓二、桑山広司、保科和宏、水野 繕、山崎龍一	49	5	464	1998	21:座談会		ISO1400、認証

6183	無電解ニッケルめっきの長寿命化	久保井義夫	49	5	475	1998	9:シリーズ-2	B03.無電解めっき	無電解めっき,イオン交換膜,電解透析,Ni,P
6184	高分解能SEMによる薄膜表面構造の最適な撮影法	多持隆一郎	49	5	482	1998	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	SEM,冷放射,低加速電圧
6185	アルミニウムとチタン	海老原健	49	5	487	1998	10:比べてみよう		Al,Ti
6186	マイクロ波プラズマCVD法による傾斜機能皮膜の作製 - 酸化シリコン皮膜の表面	穂積 篤, 梶田 厳, 高井治	49	5	489	1998	5:原著論文	B01.化学蒸着(CVD)	傾斜機能皮膜,Si,撥水性,プラズマCVD
6187	SUS304鋼材のめっき層及ぼす形成に溶融Al-Siめっき浴中のSi濃度の影響	田中順一, 大笹憲一, 成田敏夫	49	5	496	1998	5:原著論文	A03.溶融めっき	Al,Si,合金,ステンレス鋼,ホットディップ
6188	亜鉛めっきのホイスカ - 発生と浴中化学種との関係	大河原薫, 室井良一	49	5	502	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Zn,ホイスカ,シアン浴,化学種,C
6189	溶融塩電析によるNiシリサイド膜の作製とその高温耐食性	原 基, 本間 明, 佐藤芳幸	49	5	507	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	電析,溶融塩,Ni,Si
6190	水晶振動子マイクロバランス(QCM)法を用いたAgおよびCuのマイグレーション過程の検討	鶴田加一, 野中重嗣, 手塚秀夫, 吉原佐知雄, 白樫高史, 横田俊子, 金児絃征, 半沢規子, 土橋誠, 青木善平, 山口文雄, 小浦延幸, 根岸秀之, 井手本健	49	5	514	1998	5:原著論文	C07.その他(新技術を含む)	マイグレーション,Si,Cu,QCM
6191	Sn不純物を含む銅電析皮膜のTEMならびにESCA観察	丸山耕一, 増田美枝子, 沼田博雄, 佐藤 駿, 大野 涼, 小野幸子, 達坂哲彌, 内藤和久, 中岸豊	49	5	519	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	TEM,ESCA,Cu,Sn,不純物
6192	分散TiO2粒子の粒径とその共析	菅 泰雄	49	5	525	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	共析,粒子径,Ti, 電位
6193	機能と見映えと	澤田 献	49	6	535	1998	1:巻頭言		
6194	小特集1.「ガスと表面処理 - ドライブプロセスを中心として」の企画に当たって	大工原茂樹	49	6	536	1998	23:小特集		
6195	表面処理に利用するガス	松本 功	49	6	537	1998	3:解説	A01.物理蒸着(PVD)	安全性,データ,ガス,取り扱い法
6196	スパッタリングプロセスとガス	清田哲司	49	6	542	1998	3:解説	A01.物理蒸着(PVD)	スパッタリング,不純物,薄膜,Al
6197	CVDとガス	牛川治憲	49	6	547	1998	3:解説	B01.化学蒸着(CVD)	CVD,DRAM,薄膜,理論回路
6198	ドライエッチングとガス	塚田 勉	49	6	552	1998	3:解説	C04.気相エッチング	反応ガス,ドライエッチング,イオンエッチング,フルオロカーボン
6199	ガス利用装置の保守管理と適正処理	柳田一志	49	6	559	1998	3:解説	B01.化学蒸着(CVD)	半導体,環境リスク,メンテナンス,
6200	小特集2.「溶射技術」の企画に当たって	岡田亮二	49	6	564	1998	23:小特集		
6201	溶射技術の最新動向	原田良夫	49	6	565	1998	2:総説	A02.溶射	溶射,プラズマ,HVOF,機能皮膜
6202	高速フレーム溶射法の最新技術	清水保雄, 榊 和彦	49	6	572	1998	3:解説	A02.溶射	HVOF,最新技術,ガンデザイン,応
6203	プラズマ溶射法の最新技術	清水保雄, 榊 幸男	49	6	578	1998	3:解説	A02.溶射	プラズマ溶射,表面改質
6204	ブラステック溶射技術	佐々木光正	49	6	586	1998	3:解説	A02.溶射	低融点プラスチック,溶射,耐食性,耐水性,複合皮膜
6205	溶射皮膜の評価技術	菅 泰雄	49	6	592	1998	3:解説	A02.溶射	溶射,評価,密着性,機械的性質,非破壊試験法
6206	バフ研磨のポイント	片鎌利男	49	6	597	1998	9:シリーズ-2	C01.機械研磨・研削	バフ,コンパウンド
6207	ニッケル金属水素化合物電池材料の表面と構造解析	佐藤 登	49	6	603	1998	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	Ni,H,二次電池,表面分析,構造解析,表面改質
6208	オリンピックとワールドカップ	小林道雄	49	6	609	1998	10:比べてみよう		
6209	無電解ニッケル - リン合金めっき皮膜の耐食性に及ぼす上層スズめっきの影響	園田 司, 林 行信	49	6	613	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	熱処理,耐食性,無電解めっき,Ni,Sn
6210	非晶質薄膜上への無電解Co - Fe合金析出の電気化学的特性	丸山耕一, 増田美枝子, 沼田博雄, 佐藤 駿, 大野 涼, 小野幸子, 達坂哲彌, 内藤和久, 中岸豊	49	6	618	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	Co,Fe,合金,非晶質,リボン,分極,電極触媒,DMAB
6211	Pb / Sn混合触媒を利用した銅のダイレクトプレ - ティング導体化過程の解析	藤田 実, 横山真一郎, 松本誠臣, 牧野英司, 柴田隆行, 山田礼彦	49	6	625	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	ダイレクト銅めっき,Pd,Sn,触媒,ABS,TEM
6212	光沢Ni - Crめっき鋼板の屋外暴露試験による腐食特性についての統計的評価	藤田 実, 横山真一郎, 松本誠臣, 牧野英司, 柴田隆行, 山田礼彦	49	6	632	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	光沢めっき,Ni,Cr,屋外暴露試験,統計的評価
6213	高温リン酸によるファインセラミックスのフォトレジングのためのポリイミドレジスト	菅沼栄一, 丹野裕司, 中野正博, 梅津勇	49	6	637	1998	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	フォトレジング,ファインセラミックス,ポリイミド,リン酸
6214	塩酸 / 硫酸混合溶液中におけるアルミニウムの交流エッチング	菅沼栄一, 丹野裕司, 中野正博, 梅津勇	49	6	643	1998	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	Al,交流,エッチング,硫酸,キャパシタ
6215	アルミニウムの有機アルカリ性浴陽極酸化皮膜に及ぼす浴温度および浴電圧の影響	野口駿雄, 佐野明寿	49	6	649	1998	5:原著論文	B07.アノード酸化	Al,陽極酸化,アルカリ浴,アミン
6216	ダイヤモンド陰極を低温にした直流放電プラズマCVD法によるダイヤモンド薄膜の合成	阿部匡朗, 廣澤さくら, 山中 博, 広瀬洋一	49	6	655	1998	7:速報論文	B01.化学蒸着(CVD)	ダイヤモンド,薄膜,プラズマ,低温カソード
6217	YAGレーザーによるアルミニウム合金上の無電解Ni - Pめっき皮膜の硬化処理	日野 実, 西田典秀, 平松 実, 辻川正人, 川本 信風, 戸 健, 山下嗣人, 中山佳則, 数馬安男, 滝沢貴久男, 小竹英次, 山下嗣人	49	6	657	1998	7:速報論文	C07.その他(新技術を含む)	レーザー,表面改質,YAG,Al,Ni,P
6218	粉体塗装膜の内部応力に及ぼす顔料の影響	安男, 滝沢貴久男, 小竹英次, 山下嗣人	49	6	659	1998	7:速報論文	A05.塗布・塗装	粉体コーティング,内部応力,顔料,加速試験,ウエザリング
6219	高速電析による耐食性ニッケル - リン合金薄膜の作製	福島 誠, 滝沢貴久男	49	6	661	1998	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni,P,耐食性,高速電着
6220	飲料環境中におけるニッケルめっきステンレス鋼製スプリングの腐食挙動	清水健一	49	6	663	1998	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	腐食,スプリング,ステンレス鋼,Ni,S
6221	第97回講演大会報告	清水健一	49	6	665	1998	22:技術資料		
6222	公設試験研究機関の役割	榎木敏幸	49	7	671	1998	1:巻頭言		
6223	「小特集 / 生体材料と細胞・組織の界面」の企画に当たって	遠藤一彦	49	7	672	1998	23:小特集		
6224	生体材料と細胞・組織に関する基礎知識(用語集)	遠藤一彦, 安彦善裕	49	7	673	1998	18:用語		
6225	生体材料の表面処理	遠藤一彦, 大野弘井上 孝, 吉成正雄, 鮎川保則, 田中輝男, 下野正基	49	7	676	1998	2:総説		生体材料,表面修飾,生体適合性
6226	歯科インプラントと生体骨組織との界面 - 表面構造の影響 -	安彦善裕, 賀来 亨	49	7	682	1998	3:解説		歯科インプラント,骨界面,表面形態
6227	歯科インプラントと生体軟組織(上皮・結合組織)との界面 - 粘膜貫通部の特殊性	高橋和人, 岸 好彰, 松尾雅斗	49	7	690	1998	3:解説		歯科インプラント,界面,軟組織,上皮,結合組織
6228	微小循環と歯科インプラント周囲組織	鈴木一臣, 矢谷博	49	7	696	1998	3:解説		歯科インプラント,血管,SEM
6229	歯質象牙質と接着性レジンの接着界面	大西啓靖	49	7	702	1998	3:解説		歯,接着,歯質
6230	人工関節と骨との界面	伊藤悦子, 岡野光夫	49	7	708	1998	3:解説		界面,人工骨,関節,多孔体,ヒドロキシアパタイト,骨セメント
6231	人工血管血液接触面の構造とその特性	堤井信力, 阿部正紀, 北本仁孝	49	7	715	1998	3:解説	A01.物理蒸着(PVD)	人工血管,生体材料,ブロック重合,ミクロドメイン構造
6232	ドライブプロセスにおけるプラズマの役割とフェライトめっきによる酸化物磁性膜の作製とその応用	篠浦 治, 達坂哲彌	49	7	722	1998	3:解説	B04.アノード析出	フェライト,めっき,酸化膜,磁性膜
6233	薄膜磁気ヘッド用軟磁性めっき膜の動向		49	7	728	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	薄膜磁気ヘッド,電気めっき,軟磁
6234			49	7	734	1998	3:解説		

6235	セラミックス及びプラスチック表面の金属化技術	神戸徳蔵	49	7	740	1998	12:武井記念シリーズ	B03.無電解めっき	マイカ,金属化,アルミナ,ゾルゲル,紙,Cu
6236	クロムめっきにおける大気濃縮装置導入のポイント	柘植良男	49	7	744	1998	9:シリーズ-2	B02.電気めっき・電鍍	Cr,回収,大気エバポレーター
6237	ラマン分光法によるダイヤモンド状炭素膜の構造評価	吉川正信, 岩上景子	49	7	750	1998	9:シリーズ-2	B01.化学蒸着(CVD)	アモルファス,ラマン分光法,C,ダイヤモンド状炭素(DLC)
6238	ダイヤモンドとDLC	広瀬洋一	49	7	757	1998	10:比べてみよう		ダイヤモンド,DLC
6239	L-酒石酸錯体浴からのスズ-銀合金めっき	縄舟秀美, 池田一輝, 北村浩司, 水本省三, 武内孝夫, 青木和博	49	7	759	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	鉛フリーはんだ,Sn,Ag,合金,酒石酸
6240	ポーラログラフィー法によるCo-W合金の誘起共析機構の解析	李明, 盛満正嗣, 松永守央, 藤田直幸	49	7	764	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Co,W,合金,誘起析出,ポーラログラフィー
6241	接触めっき法によるFe-B二次系アモルファス合金薄膜の作製と磁気特性	P.B.LIM, 牧野栄治, 井上光輝, 荒井賢一, 藤井壽崇, 牧野英司, 柴田隆行, 山田礼彦	49	7	769	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	接触めっき,Fe,B,磁気特性,非晶質
6242	セラミックスのフォトエッチングのための環化ポリブタジエンレジスト膜の形成条件	浦尾亮一, 洪 晟弾	49	7	781	1998	5:原著論文	A05.塗布・塗装	フォトエッチング,ファインセラミックス,環状ポリブタジエン,リン酸イオン窒化,ホロカソード
6243	ホロカソード放電を利用したCr-Mo鋼のプラズマ浸炭窒化	山口文雄, 小浦延幸	49	7	788	1998	7:速報論文	A01.物理蒸着(PVD)	光触媒,Co,Ni,Ti,殺菌性
6244	Ni-TiO ₂ 分散めっき表面の光触媒による殺菌性	堤 宏守, 竹岡健治, 鬼村謙二郎, 大石 勉	49	7	790	1998	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	ポリアミド,ジスルフィド,Cu,腐食抑制剤
6245	ジスルフィド結合を有するポリアミドの銅防食剤への応用	重松一典, 齊藤尚文, 馬淵 守, 中西勝, 下島康嗣, 山田康雄, 中村 守	49	7	792	1998	7:速報論文	A09.拡散皮膜	Mg,Al,表面硬化
6246	アルミナライジングによるAZ91Dマグネシウム合金の表面硬化処理	有泉直子, 清水良恵, 柴田正実, 古屋長一	49	7	794	1998	7:速報論文	B03.無電解めっき	Ni,P,無電解めっき,Pd,初期析出,EQCM
6247	無電解Ni-Pめっき初期析出過程に及ぼすパラジウム触媒の分散効果	縄舟秀美, 上垣隆, 水本省三, 石川正巳, 中村 恒	49	7	796	1998	8:Letters	B03.無電解めっき	無電解めっき,Cu,Ni,合金,比抵抗,TCR
6248	無電解銅-ニッケル二元合金めっき及びその電気抵抗特性	堀口 誠	49	8	803	1998	1:巻頭言		
6249	セミナ-活動の活性化	坂内恒雄	49	8	804	1998	3:解説	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	エンジン,電気めっき,化成皮
6250	エンジンに用いられる表面処理技術「小特集/身近な自動車部品への表面処理技術の適用」の企画に当たって	坂内恒雄	49	8	804	1998	23:小特集		
6251	自動車用エアコンの表面処理	菅原博好, 竹中修, 金子秀明	49	8	812	1998	3:解説	B08.化成処理	エアコン,悪臭,親水性,防錆性
6252	塗装の艶出しとタイヤの洗浄艶出し	若生英樹, 西田秀渡, 辺健太郎, 山中雅彦	49	8	817	1998	3:解説	A05.塗布・塗装	自動車ボディー,タイヤ,コヤ出し,
6253	ウインドガラスのはっ水処理	畑田賢造	49	8	823	1998	24:トピックス	B05.熱分解・ゾルゲル法	撥水性,ガラス,ゾルゲル,Si
6254	半導体技術からみた実装技術	畑田賢造	49	8	826	1998	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	アセンブリー,パッケージング
6255	システムサイトから見た実装技術-電子装置の可能性を広げる実装技術-	大塚寛治	49	8	831	1998	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	パッケージング,チップワヤリング
6256	話題商品にみる表面実装技術	青木正光	49	8	837	1998	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	表面実装,電子部品,PWB,パッケージング
6257	立体的なマイクロマシンを作る-高アスペクト比マイクロ構造製法	藤田博之	49	8	844	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	マイクロマシン,3D,半導体,LIGA,HARMS
6258	電析法による軟X線縮小投影ソグラフィ-用反射マスクの作製	村上勝彦	49	8	849	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	Ni,電気めっき,マスク,紫外線,ソグラフィ
6259	アルミニウム合金のアルノ-ド酸化:合金元素の合金/被膜界面への濃縮と皮膜中での移動性	幅崎浩樹, 清水健一, P.Skeldon, E.Thompson, G.C.Wood	49	8	854	1998	3:解説	B07.アルノード酸化	陽極酸化,Al,界面濃縮,イオン移動
6260	めっき用電源管理のポイント	荒井 亨	49	8	860	1998	9:シリーズ-2		電源,効率,省エネルギー
6261	表面増強ラマン分光法による吸着インヒビター-の構造解析	荒牧国次	49	8	866	1998	9:シリーズ-2	A04.吸着	表面増強ラマン分光法,腐食抑制剤,Cu,Ag
6262	液晶ディスプレイとプラズマディスプレイ	堀 浩雄	49	8	872	1998	10:比べてみよう		LCD,PDP
6263	高温濃厚LiBr水溶液中における炭素鋼とロウ材との異種金属間腐食	馬淵勝美, 菊池智子, 高橋英明	49	8	875	1998	6:技術論文		LiBr,炭素鋼,フラックス,高温,腐食
6264	硝酸処理によるベルト研磨ステンレス鋼の耐食性改善	木谷 滋	49	8	881	1998	6:技術論文	B08.化成処理	ステンレス鋼,耐食性,鉍浴,ベルト研磨,硝酸
6265	マイクロアキュエ-タ形成のための形状記憶合金圧延シ-ト材の電解フォトエッチ	牧野英司, 柴田隆行, David M.ALLEN	49	8	887	1998	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	硫酸,メタノール,マイクロアキュエーター
6266	無電解プロセスによるグルコ-スのアンペロメトリックセンサ-の作製	松原 浩, 近藤哲也, 程内和範, 山田板垣昌幸, 渡辺邦洋, 小浦延幸	49	8	894	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	グルコース分析,無電解めっき,Cu,Ni
6267	金属の析出反応での電気化学的インビ-ダンスで観察される誘導体挙動の理論的	ルディオノ, 金子富士男, 竹内 学	49	8	900	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	EIS,電析,誘導性挙動
6268	フタロシアニン粒子分散型太陽電池のNO ₂ ガス吸着効果	山田耕太, 佐藤修彰, 藤野威男, 西澤松彦, 山田 勇	49	8	911	1998	7:速報論文	A04.吸着	太陽電池,銅フタロシアニン,NO ₂ ,吸着
6269	静電噴霧法(ESD)を用いた複合酸化物薄膜の作製とリチウムイオン二次電池用電極材料への応用	小浦延幸, 遠藤巧, 井手本康	49	8	913	1998	7:速報論文	A06.泳動電着	ESD,薄膜,金属酸化物,電池カソード
6270	有機溶媒を添加した常温型溶融塩浴からの非晶質Co-Zn合金の電析	福崎智司, 浦野博水, 平松 実	49	8	915	1998	8:Letters	B02.電気めっき・電鍍	アモルファス,Co,Zn,電析,溶融塩
6271	表面処理によるステンレス鋼の表面電荷の変動:表面水酸基の役割	久保光康	49	9	921	1998	1:巻頭言	A04.吸着	ステンレス鋼,OH基,ポテンシオメトリ-水蒸気吸着
6272	表面処理技術に係わる業界の発展のための研磨技術とトライボロジ	梅原徳次	49	9	922	1998	2:総説	C01.機械研磨・研削	トライボロジー,機械研磨,CMP
6273	砥粒加工技術の最新動向	谷 泰弘	49	9	928	1998	3:解説	C01.機械研磨・研削	品質,制御性,生産性
6274	最近の砥粒材料と研磨	川田研治	49	9	933	1998	3:解説	C01.機械研磨・研削	軟粉末,超微粒子,化学機械研磨,ラッピングディスク
6275	化学機械研磨	榎村 寿	49	9	938	1998	トピックス	C01.機械研磨・研削	化学機械研磨,シリコンウエファー,平坦性,微小あらさ
6276	小特集2.化学的な表面制御 企画にあ	森 誠之	49	9	943	1998	23:小特集		
6277	超はっ水表面のはっ水性の光制御	佐々木 洋, 庄司三良	49	9	944	1998	3:解説	A04.吸着	撥水性,光制御,超撥水表面
6278	テレビ表面の改質	近藤洋文	49	9	950	1998	3:解説	A05.塗布・塗装	CRT,反射防止膜,防汚層
6279	界面制御による有機-無機機能性複合材料の創製	多賀谷英幸, 堀 卓也, 桑原恒男! 門川淳一, 千葉耕司	49	9	956	1998	3:解説	A05.塗布・塗装	無機層,有機層,複合層
6280	めっき表面の形状測定-ミクロ表面形態を測定する	森河 務, 横井昌幸	49	9	963	1998	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	3D表面トポグラフィ-SEM,SPM,Cu,電析

6283	水性塗料と溶剤塗料	和田英男	49	9	969	1998	10:比べてみよう	A05.塗布・塗装	塗料,溶剤
6284	マグネシウム合金への電気めっき	尾形幹夫	49	9	971	1998	6:技術論文	B02.電気めっき・電鍍	Mg,電析
6285	硬質材料の金属に対する摩擦・摩耗特性 - 硬質特性と焼結材料の比較 -	出水 敬, 曾根 匠, 石垣博行, 川本中出卓男, 佐藤幸弘, 森河 務, 横井 昌幸	49	9	974	1998	5:原著論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	摩擦,磨耗,セラミックス,コーティング
6286	3価クロムめっき浴からのCr-P-C合金めっき		49	9	980	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Cr,P,C,合金,カチオン交換膜,非晶質
6287	大気加熱処理による電析Cr皮膜の耐孔食性向上効果	山崎 修	49	9	985	1998	5:原著論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	ペーキング,耐ビット性,Cr
6288	フレキシブルなバナジウム酸化物/PPTA複合電析膜の作製とそのエレクトロクロミック特性	山崎澄男, 上野正浩, 島田勝晴, 添嶋康廣, 大浦博樹, 津留寿昭	49	9	990	1998	5:原著論文	B04.アノード析出	V,PPTA,エレクトロクロミック,機械的性質
6289	RFスパッタリングによるZnO透明導電薄膜特性へのAr圧力と・基板温度の影響	辻 隆志, 小嶋裕之, 広橋光治	49	9	996	1998	5:原著論文	A01.物理蒸着(PVD)	Zn,RFスパッタリング,抵抗,密着性,スペクトル
6290	ニッケル酸化膜の摩擦によるエキソ電子放出とエタノールの分解反応との関連	橋本顕宣, 井上和浩, 百瀬義広	49	9	1003	1998	5:原著論文	C07.その他(新技術を含む)	Ni,摩擦,XPS,表面電位
6291	パラジウム薄膜パターンのレザ描画における基板材料および酢酸パラジウム塗布膜厚の影響	牧野英司, 柴田隆行, 早川洋平	49	9	1010	1998	5:原著論文	A05.塗布・塗装	レーザパターンニング,Pd,薄膜,ガラス,ポリイミド
6292	硫酸浴中で直流及び交流にてAlをアノード電解し,Snを電析出した2重皮膜の研究 - 皮膜の微細構造,化学的及び光学Ti:Alの高温酸化に及ぼす微量Ni蒸気を含む酸素中での予備酸化の効果	川合 慧, 山室正明, 和田健二	49	9	1016	1998	5:原著論文	B07.アノード酸化	陽極酸化,電解着色,干渉色
6293	関東支部と電鍍・金型の表面処理研究部会共催による講演会および見学会報告	原 基, 北川善朗	49	9	1021	1998	7:速報論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	Ti,Al,金属間化合物,高温酸化,予備酸化,食塩
6294	公設試が生き残る道	中澤洋二	49	9	1023	1998	支部便り		電鍍,金型
6295	[小特集/湿式エッチングとその応用]企画によせて	馬飼野信一	49	10	1029	1998	1:巻頭言		
6296	湿式エッチングの基礎と応用	海老名延郎	49	10	1030	1998	23:小特集		
6297	高密度プリント配線板におけるエッチング技術の動向	加藤凡典	49	10	1031	1998	2:総説	C03.化学エッチング・電解エッチング	フォトエッチング,フォトレジスト,アートワーク,半エッチング
6298	各種プラスチックのエッチング技術	豊永 実	49	10	1038	1998	3:解説	C03.化学エッチング・電解エッチング	エッチング,フォトレジスト,エッチング速度
6299	ネームプレート作製プロセス-湿式エッチングの利用を含めて	佐藤一也	49	10	1044	1998	3:解説	C03.化学エッチング・電解エッチング	エンブラ,プラスチック,エッチング
6300	各種めっき金属皮膜のエッチング	上原洋一	49	10	1052	1998	3:解説	C03.化学エッチング・電解エッチング	ネームプレート,マスキング
6301	走査型プローブ顕微鏡を用いた微細加工	津久井 豊	49	10	1057	1998	3:解説	C03.化学エッチング・電解エッチング	エッチング,剥離,素地金属,めっき,腐食
6302	酸化物巨大磁気抵抗薄膜の作製とその応用	杉村博之	49	10	1061	1998	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	走査プローブ顕微鏡,自己組織化,オルガノシラン,ナノファブリ
6303	透過電子顕微鏡による材料表面の高温高分解能観察	中野耕太郎, 山崎陽太郎	49	10	1067	1998	3:解説	A01.物理蒸着(PVD)	磁気記録,MRヘッド,ペロブスカイト,マグネタイト
6304	スパッタ法による磁性膜作製におけるガス種の検討	上野武夫	49	10	1073	1998	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	TEM,高温,Si,C,結晶
6305	工業用クロムめっきの液管理とその効果	中川茂樹, 直江正彦	49	10	1078	1998	3:解説	A01.物理蒸着(PVD)	ガス,磁性薄膜,ターゲット,反跳粒子,イオンビーム
6306	表面処理鋼板の表面分析	阿部 弘	49	10	1083	1998	9:シリーズ-2	B02.電気めっき・電鍍	Cr,膜電解,不純物
6307	ガラスの表面処理-親水化とは水化-	前田重義	49	10	1087	1998	9:シリーズ-2	A03.溶融めっき	Sn,TFS,めっき鋼板,表面分析,密
6308	電子シャワー法によるFe4N膜の作製および鉄の窒化	奥野和義	49	10	1093	1998	10:比べてみよう	A04.吸着	ガラス,親水化,撥水化
6309	ZrO ₂ -NiCrAlYプラズマ溶射皮膜の熱溶射皮膜の熱応力によるき裂の特性	李 松姫, 高野昌樹, 鈴木木理之, 湯本久美, 石原正統	49	10	1095	1998	5:原著論文	A01.物理蒸着(PVD)	Fe,N,窒化,電子シャワー
6310	溶融Zn-Alボルトめっき材のめっき層の改善	園家啓嗣, 北原 繁, 戸部省吾	49	10	1100	1998	5:原著論文	A02.溶射	Zr,Y,プラズマスプレイ,熱膨張率
6311	交流型酸化チタン硬膜化学センサーへの電極材料効果	田中順一, 阪口 真, 成田敏夫	49	10	1105	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	鋼ボルト,溶融塩,合金層,Zn,Al
6312	水溶液中のMo錯体構造とMo合金めっき機構	モハメッド ラフィク, イスラム, 熊沢紀之, 竹内 学, 篠田弘造, 松原英一郎, 早稲田嘉夫, 植川英治, 邑瀬邦明, 平藤哲司, 栗倉泰弘, 山下智司, 小川功史, 虫明克彦, 増子 孟, 恵民, 盛満正嗣, 松永守央, 石橋純一, 高田祐一, 本間英夫	49	10	1123	1998	5:原著論文	C07.その他(新技術を含む)	Ti,化学センサ
6313	周期的逆電解による酸化イリジウム系アノードの異常劣化	劉 暉, 興戸正純	49	10	1128	1998	13:研究ノート	B02.電気めっき・電鍍	Ir,Ti,寿命,シリカゾル,加速試験
6314	電気銅めっきによる超微細パターンの作製	浅井利彦	49	11	1139	1998	1:巻頭言	B02.電気めっき・電鍍	Ir,アノード,PR電解,異常劣化,逆電解
6317	熱電極上への亜鉛の電析	榎本英彦	49	11	1140	1998	2:総説	B02.電気めっき・電鍍	Zn,電析,熱電極,結晶配向
6318	雑感(産学官連携について)	山本良雄	49	11	1147	1998	3:解説	B08.化成処理	電気めっき,化成皮膜,陽極酸化,
6319	表面処理による黒色化技術	丸田正敏	49	11	1153	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	黒色クロムめっき,原理,応用
6320	黒色クロムめっきの原理と応用	青江徹博	49	11	1158	1998	3:解説	B08.化成処理	黒色合金めっき,Sn,Ni,Co
6321	黒色スズ系合金めっきの原理と応用	西村敏行	49	11	1164	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	黒色クロムめっき,モリブデン酸塩,自動車部品
6322	亜鉛および亜鉛系合金めっきの黒色化処理	石田 章	49	11	1170	1998	23:小特集		Ti,Ni,合金めっき,着色
6323	黒色スズ-ニッケル-銅合金めっき [小特集2.ULS:微細Cu配線技術の新しい展開]の企画に当たって	上野和良	49	11	1171	1998	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	電析,Cu,LSI,配線
6324	微細Cu配線プロセスにおける成膜技術の現状と課題	谷口和広	49	11	1176	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	トータルアプローチシステム
6325	銅微細配線システム	縄舟秀美	49	11	1180	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	ULSI配線,Cu,電気めっき
6326	湿式銅めっき法によるULS:配線技術の課題	高桑一雄	49	11	1185	1998	3:解説	A01.物理蒸着(CVD)	LTS,Cu,配線
6327	低温ロングスロースパッタリングを用いた新Cu成膜プロセスの展開	小林明子	49	11	1192	1998	3:解説	A01.物理蒸着(CVD)	CVD,Cu,析出速度
6328	CVD-Cu膜の高速成膜	吉原佐知雄	49	11	1196	1998	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	イオンマイグレーション,QCM,Ag,Cu,インヒビター
6329	プリント回路上のイオンマイグレーションのQCMによる評価	海老名延郎	49	11	1201	1998	10:比べてみよう		ワイン
6330	ワインの赤と白	齊藤英之, 八木澄子, 酒井 彰, 三沢俊平, 田中壽晃, 相馬 英明, 田中大之	49	11	1203	1998	5:原著論文	C07.その他(新技術を含む)	マイクロ波プラズマ,CVD,ダイヤモンド,Cr,酸化皮膜
6331	マイクロ波プラズマCVD法による表面酸化処理したクロム基板上的ダイヤモンドの合成	中野博昭, 秋山徹也, 福島久哲	49	11	1209	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	アンダーポテンシアル,電析,Fe,Zn
6332	鉄族金属共存下におけるZnのUnderpotential Deposition								

6334	EMIC系常温型溶融塩浴からの非晶質Co-Zn合金の電析	小浦延幸・松本 哲・井手本 康	49	11	1215	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	EMIC、溶融塩浴、非晶質、電析
6335	レーザー照射および局部Niめっきによるアルミニウム表面のパターンニング	坂入正敏・若林 潤・高橋英明・阿部芳彦・片山直樹	49	11	1220	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Al,アノード酸化皮膜,レーザー,Ni,パターンニング
6336	レーザー照射および局部Niめっきによるアルミニウム表面のパターンニング	坂入正敏・若林 潤・高橋英明・阿部芳彦・片山直樹	49	11	1227	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Al,アノード酸化皮膜,レーザー,Ni,パターンニング
6337	レーザー照射部における局部Niめっきと溶融塩電析によるMoシリサイドの生成	岩岸哲也・八重真治・松田 均	49	11	1233	1998	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	電気めっき,溶融塩,Ni,Si,Mo
6338	無電解めっき法による半導体複合めっき膜の作製とその光電気化学特性	原 基・土田知行	49	11	1235	1998	7:速報論文	B03.無電解めっき	無電解めっき,半導体,微粒子,複合皮膜,光電気化学
6339	ステンレス鋼表面に吸着したタンパク質の形態の研究	福岡智司・浦野博	49	11	1237	1998	8:Letters	A04.吸着	ステンレススティール,蛋白質,吸着,ポテンシオメトリー,静電相互
6340	本質の追究	水平松 実	49	12	1243	1998	1:巻頭言	B09.その他(新技術を含む)	
6341	ウェーハーバンプ形成技術	本間 荘一・吉岡潤一郎・蛭田陽一	49	12	1244	1998	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	バンプ,フリップチップ,電気めっき,はんだ付け,レジスト
6342	鉛フリー・はんだ接合に対応するめっき技術	縄舟秀美	49	12	1251	1998	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	鉛フリーはんだ,Sn,地球環境,パッケージング,バンプ,ビルトアップPCB,
6343	半導体実装における新しい表面処理技術	若林信一	49	12	1257	1998	24:トピックス	B09.その他(新技術を含む)	
6344	無電解めっきによる電磁波シールド	中村憲二	49	12	1262	1998	24:トピックス	B03.無電解めっき	EMIシールド,Cu,無電解めっき,Ni
6345	立体配線技術 - MIDのめっき技術	駒木根力夫	49	12	1266	1998	24:トピックス	B03.無電解めっき	3D配線,MID,無電解めっき,インジェクションモールド
6346	電解銅箔技術	高橋直臣	49	12	1272	1998	24:トピックス	B02.電気めっき・電鍍	電気めっき,PCB,Cu,箔
6347	光沢めっき法による複眼レンズ金型製造の検討	川崎 実・浅沼豊人・鈴木哲也	49	12	1277	1998	6:技術論文	B02.電気めっき・電鍍	複眼レンズ金型,光沢めっき
6348	パラジウムめっきリ・ドフレ・ムの曲げ特性に及ぼす下地ニッケルめっきの析出条	珍田 聡・秋野久則・米川琢哉	49	12	1283	1998	6:技術論文	B02.電気めっき・電鍍	Pd,Ni,スルファミン酸浴,リードフレーム,クラック
6349	BGAパッケージ・ジよテ・ブ基板における無電解金めっき厚さとワイヤボンディング性およびはんだボ・ル接合性	珍田 聡・宮本宣明・吉岡 修	49	12	1291	1998	6:技術論文	C07.その他(新技術を含む)	無電解めっき,Au,Ni,BGAテープキャリアー
6350	チオ尿素 - ヒドロキノン2元還元剤系を用いた極めて安定な非シアン無電解金めっき浴	井上隆史・安藤節夫・牛尾二郎・奥平弘明・竹原裕子・太田敏彦・山本 弘・横野 中	49	12	1298	1998	6:技術論文	B03.無電解めっき	無電解めっき,Au,非シアン浴,チオ尿素,ヒドロキノン
6351	ポリイミドフィルム上へのレーザー・照射無電解金めっき	永峰 聡・小早川絃一・佐藤祐一	49	12	1305	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	レーザーめっき,無電解めっき,Au,ポリイミドフィルム,シアンフリー浴
6352	5.5-ジメチルヒダントインを用いたアルカリ系Sn-Ag合金めっき浴の検討	伊勢立彦・湯浅真・関根 巧・新藤藤原 裕・楢原泰栄子・江本英彦・船田清孝・小見 崇	49	12	1310	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	鉛フリーはんだ,Sn,Ag,合金めっき,アルカリ浴
6353	クエン酸アンモニウム・ヨウ化カリウム浴からのSn-Ag合金めっきにおけるアノードの挙動	縄舟秀美・中尾誠一郎・水本省三・内田 衛・岡田 隆	49	12	1316	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	合金めっき,Sn,Ag,アノード材料,ヨウ化物,鉛フリーはんだ
6354	ギ酸を還元剤とするモノアミノジカルボン酸錯体浴からの無電解パラジウムめっき	水口泰一・小林 健・藤波知之・本間 健・川崎淳一・石橋純一・田中健太郎・本間英夫	49	12	1322	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき,ゼロエミッション,硬さ,はんだ付け性,錯化剤
6355	次亜リン酸塩を還元剤とする無電解銅めっきによる導体層・絶縁樹脂層の密着	横島時彦・湯浅真子・金 満・逢坂哲彌	49	12	1327	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	次亜リン酸塩,無電解めっき,Cu,密着性,ビルトアップPCB
6356	電気銅めっきを用いた各種波形制御によるビアフィリング	藤田直幸・バン ボイ・リム・伊藤昌伸・井上光輝・荒井賢一・藤井壽崇	49	12	1332	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	ビアフィリング,電流波形,無電解めっき,電気めっき,プラナリゼーション
6357	無電解Niめっきを用いたマイクロパターンニングにおける錯化剤の影響	常光幸美・柏原智・林 安德	49	12	1336	1998	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき,マイクロパターンニング,DMAB,錯化剤
6358	マイクロ磁気デバイスへの応用を目的としたFe-Bアモルファス電析膜の作製	野中重嗣・中村 誠・鶴田加一・吉原佐知雄・白樺高史・喜多洋介・本間敬之・逢坂哲彌	49	12	1343	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	アモルファス,Fe,B,ESCA
6359	電析磁性ナノ構造の機能性	縄舟秀美・中尾誠一郎・水本省三・村上義樹・橋本 伸	49	12	1351	1998	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	磁性皮膜,ナノ構造,多層膜,巨大磁気抵抗
6360	水晶振動子マイクロバランス法を用いたはんだのイオンマイグレーション過程の検討	野中重嗣・中村 誠・鶴田加一・吉原佐知雄・白樺高史・喜多洋介・本間敬之・逢坂哲彌	49	12	1356	1998	7:速報論文	C07.その他(新技術を含む)	マイグレーション,水晶振動子,Pb,Sn
6361	無電解Co-Ni-P傾斜機能磁性薄膜の断面構造解析	縄舟秀美・中尾誠一郎・水本省三・村上義樹・橋本 伸	49	12	1358	1998	7:速報論文	B03.無電解めっき	傾斜材料,磁気特性,Co,Ni,P
6362	無電解銅めっき法によるULSI配線の形成	白石 振作	49	12	1360	1998	7:速報論文	B03.無電解めっき	ULSI,Cu,ダマシン,無電解めっき
6363	新年にあたって - 50周年記念事業を新しい技術開発につなげるために -	清水 健一・幅崎浩樹・P.Skeldon・G.E.Thompson・G.C.Wood	50	1	1	1999	1:巻頭言		
6364	バルブ金属表面に生成するアノード酸化皮膜の構造と性質	荒井俊明・廣升泰信・飯寄英保	50	1	2	1999	3:解説	B07.アノード酸化	バルブ金属,酸化皮膜,構造
6365	液晶ディスプレイ向けアルミニウム配線のアノード酸化	佐々木克孝・尾関雅彦	50	1	10	1999	3:解説	B07.アノード酸化	液晶,ディスプレイ,アノード酸化
6366	バルブメタルの金属間化合物のアノード酸化とコンデンサへの応用	高橋 恒	50	1	16	1999	3:解説	B07.アノード酸化	バルブメタル,金属間化合物,コンデンサ
6367	アノード酸化皮膜を用いる厚膜EL素子	趙 志宏・草刈真一・坂上吉一・逢坂	50	1	21	1999	3:解説	B07.アノード酸化	アノード酸化,EL,厚膜
6368	めっき膜の抗菌作用とその応用	杉村博之	50	1	25	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	めっき膜,抗菌
6369	原子間力顕微鏡の利用法	庄司典明	50	1	31	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	原子間力顕微鏡
6370	表面アラサ,表面あらさ,表面粗さ	山下昌三・松原秀樹・深海龍夫	50	1	38	1999	10:比べてみよう	C07.その他(新技術を含む)	粗さ
6371	三磁極マグネトロンスパッタリング法によるNi-Cr合金薄膜の作製	石井敏夫・鳥 順彦・植田広志・権田	50	1	41	1999	6:技術論文	A01.物理蒸着(CVD)	スパッタリング,Ni,Cr,薄膜
6372	TiN-Ti(C,N)-結合膜 - Al ₂ O ₃ 膜被覆切削工具のマイクロ組織と切削特性	山本兼司・佐藤俊樹・岩村栄治	50	1	47	1999	5:原著論文	C01.機械研磨・研削	Ti,Ni,アルミナ,切削加工
6373	AIP法により作製したTiN,CrN,Cr ₂ NおよびAlTiN膜の熱膨張率および二軸弾性率の温度依存性	二川正敏・Rof W・Steinbrech・涌井隆・倉部 誠	50	1	52	1999	5:原著論文	A01.物理蒸着(CVD)	TiN,CrN,熱膨張,弾性率
6374	Si-SiCセラミックスに生成した二層構造シリカ皮膜におよぼす熱処理の影響	渡辺秀人・渡辺健治・本間英夫	50	1	58	1999	5:原著論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	Si,熱処理,セラミックス
6375	無電解Pd-Ni合金比率におよぼす浴組織の影響	朝川隆信・鎗田聡明	50	1	63	1999	5:原著論文	B03.無電解めっき	Pd,Ni,合金
6376	ヒダントインおよびヒダントイン誘導体を用いた非シアン系銀めっき浴		50	1	68	1999	5:原著論文	B03.無電解めっき	銀めっき,添加剤

6377	硫酸浴からのZn-Ni合金めっきに及ぼす界面活性剤の影響	日野 実・西田典秀・平松 実・牧野一貴・金谷照人	50	1	72	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Zn,Ni,界面活性剤
6378	界面活性剤によるPTFE粒子表面改質のCu-PTFE分散めっきに及ぼす効果	田里伊佐雄・林 秀孝・浮田茂幸	50	1	78	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	界面活性剤,PTFE,Cu
6379	ビニルトリエトキシシランによる酸化チタンのカップリング処理	佐貴須美子・本吉史武・長岡 茂・真嶋 宏	50	1	84	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	TiO ₂ ,カップリング
6380	酸化チタン膜の光触媒反応に及ぼす酸素イオン注入の影響	井上陽一・池田由紀子・吉村保廣	50	1	90	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	TiO ₂ ,光触媒,イオン注入
6381	超音速分子線を用いたArFエキシマレーザ - 誘起CVD法による金属光沢薄膜のCr ₂ O ₃ 含浸によるZrO ₂ 溶射皮膜の改質と損傷特性	本田数博	50	1	95	1999	13:研究ノート	A01.物理蒸着(CVD)	エキシマレーザ,薄膜
6382	粗化処理無しの平滑銅 - エポキシ絶縁樹脂間の密着性	荻野邦彦・大森明・森本純司	50	1	99	1999	7:速報論文	A02.溶射	Cr ₂ O ₃ ,ZrO ₂
6383	日米 Joint Forumに参加して	小林 健・望月勇・高橋秀臣・本間	50	1	101	1999	8:Letters	A10.その他(新技術を含む)	密着性,Cu,エポキシ樹脂
6384	Asian Finish 98 表協視察団に参加して	奥野和義	50	1	103	1999	19:寄稿		
6385	環境対策にこそ公的資金を	吉原佐知雄	50	1	103	1999	19:寄稿		
6386	「小特集・めっきの基本組成の役割」の企画に当たって	野口裕臣	50	2	127	1999	1:巻頭言		環境
6387	無電解銅めっき	奥野和義	50	2	128	1999	23:小特集	B02.電気めっき・電鍍	
6388	電気銅めっき	藤波知之	50	2	129	1999	3:解説	B03.無電解めっき	Cu
6389	無電解ニッケルめっき	西浜幸彦	50	2	135	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	Cu
6390	電気ニッケルめっき	田代雄彦	50	2	140	1999	3:解説	B03.無電解めっき	Ni
6391	クロムめっき	村上 透	50	2	146	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	Ni
6392	スズ,はんだおよび鉛フリ - 合金めっき	渡邊和夫	50	2	149	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	Cr
6393	ソル - ゲル法のやさしい概要とその用途	辻 清貴	50	2	155	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	Sn,Pb
6394	プラスチック眼鏡のハ - ドコート膜	土岐元幸	50	2	161	1999	2:総説	B09.その他(新技術を含む)	ソルゲル
6395	液晶パネル中の機能性絶縁膜	中島幹人	50	2	167	1999	3:解説	A01.物理蒸着(CVD)	プラスチック,ハードコート
6396	ソル - ゲル法による金属材料への耐食性	吉田宣昭	50	2	171	1999	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	液晶,絶縁膜
6397	準結晶とアモルファス	平井伸治	50	2	175	1999	3:解説	B05.熱分解・ソルゲル法	ソルゲル,金属
6398	AIP法で形成したTiN膜の純アルミ溶湯との反応性	葵 安邦	50	2	182	1999	10:比べてみよう		準結晶,アモルファス
6399	高周波誘導型高密度プラズマを用いた純鉄の窒化	山本兼司・安永龍哉・佐藤樹山	50	2	185	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	TiN,Al
6400	鉛蓄電池における負極の異常成長と充放電特性に及ぼすリグニンの影響	山田仁子・伊藤滋・明石和夫	50	2	191	1999	5:原著論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	プラズマ,Fe
6401	ニッケルめっき膜の引張応力に及ぼすクロム(Ⅱ)イオンの影響	田口正美・渡邊満生	50	2	196	1999	5:原著論文	B09.その他(新技術を含む)	Pb,リグニン,蓄電池
6402	スルファミン酸塩浴からのCu/Ni多層膜の塩酸溶液中の三角波パルス電流エッチングで生ずるアルミニウムのピット形態と複合サイクル腐食試験における有機複合被覆鋼板の耐食性機構	津留 豊・大野倫子	50	2	202	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni,Cr,引張り応力
6403	凍結時に促進されるシアン化物イオンによるヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸イオンの還元反	三宅猛司・久米道智	50	2	208	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Cu,Ni,多層膜
6404	無電解めっき法におけるセンシタイジング液の長寿命化 - 溶存酸素制御と安定化剤添加の効果 -	菅沼栄一・丹野祐司・伊藤 武・中野筋田成子・望月一雄・森戸延行	50	2	212	1999	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	パルス,エッチング,Al,ピット
6405	第38回講演大会報告	筋田成子・望月一雄	50	2	218	1999	5:原著論文	B09.その他(新技術を含む)	有機被膜,腐食試験
6406	1998年北海道夏期セミナー - と北海道支部設立10周年記念式典に参加して	本田数博	50	2	225	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	シアン化物,Fe
6407	表面技術の進歩と協会誌	善我倫明・内野智朗・山岸憲史・八重真治・松田 均	50	2	231	1999	7:速報論文	B03.無電解めっき	溶存酸素,安定化剤
6408	光触媒の固定化法	松永利昭	50	2	233	1999	22:技術資料		
6409	光触媒の超親水性 - 理論と応用	遠藤一彦	50	2	236	1999	22:技術資料		
6410	照明製品の防汚コート	瀬尾真浩	50	3	241	1999	1:巻頭言		
6411	光触媒皮膜による抗菌作用とその効果 - 酸化チタンと酸化亜鉛被膜 -	吉本哲夫	50	3	242	1999	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	光触媒
6412	光触媒膜の酸化チタンと酸化亜鉛被膜	下吹越光秀	50	3	247	1999	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	光触媒,親水性
6413	光触媒膜の酸化チタンと酸化亜鉛被膜	石崎有義	50	3	251	1999	3:解説	A05.塗布・塗装	照明器具,防汚
6414	光触媒膜の酸化チタンと酸化亜鉛被膜	山口靖英	50	3	256	1999	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	光触媒,TiO ₂ ,ZnO ₂ ,抗菌
6415	光学顕微鏡の正しい使い方 - 20の常識 -	竹内浩士	50	3	260	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	光触媒,大気浄化
6416	水素とバ - シヤル	小松 啓	50	3	265	1999	9:シリーズ-2		光学顕微鏡
6417	アルモルファスシリコン薄膜トランジスタのオフ電流特性に及ぼすプラズマ処理の効果	武田宏治	50	3	271	1999	10:比べてみよう		
6418	電流遮断法による単結晶シリコン陽極酸化	鷲塚 謙・藪田哲史・岡本昌也	50	3	273	1999	5:原著論文	A01.物理蒸着(CVD)	アモルファス,プラズマ,シリコントランジスタ
6419	流動層中でのニッケルのホウ化処理	柚賀正光・竹内学・大山昌憲	50	3	278	1999	5:原著論文	B07.アノード酸化	電流遮断劣,単結晶,Si
6420	TiO ₂ 粉末を用いたレ - ザアロイングによるアルミニウムの表面改質	上田順弘・菅根匠・水越朋之・池永明・川本 信	50	3	282	1999	5:原著論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	Ni,ホウ化処理
6421	無電解NiBめっきにおける複合錯化剤の影響	赤沼正信・田中大之・高橋義美・柴田隆行・牧野英司・池金 満・飯塚 淳	50	3	289	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	TiO ₂ ,レーザ,Al
6422	白金上の水素吸着過程に対する磁気効果の検討	久保宮敬幸・逢坂鶴川孝行・大浦公志・森 香代・吉原佐知雄・白樫高史	50	3	301	1999	13:研究ノート	B03.無電解めっき	Ni,B,錯化剤
6423	実績評価のあり方	大坂 敏明	50	4	307	1999	1:巻頭言		
6424	アルミニウム陽極酸化皮膜の黒染め処理	伊藤 英彌	50	4	308	1999	3:解説	B03.無電解めっき	無電解,黒色,めっき
6425	銅および銅合金の黒色化処理	坂口 雅章	50	4	315	1999	3:解説	B07.アノード酸化	Al,陽極酸化,黒染め
6426	新シリーズ掲載開始にあたって	小嶋隆司	50	4	322	1999	3:解説	B08.化成処理	銅,銅合金,黒染め
6427	新電気化学入門	伊藤 輝明	50	4	326	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	
6428	X線回折法による薄膜材料の評価	馬場 宣良	50	4	327	1999	17:講座	C07.その他(新技術を含む)	電気化学
6429	天然歯と歯科インプラント	飛田 一郎	50	4	333	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	X線回折,薄膜
6430	ダイヤモンド膜の耐摩耗性に及ぼす圧縮応力の効果	遠藤 一彦	50	4	338	1999	10:比べてみよう	C07.その他(新技術を含む)	インプラント
6431	ニッケル - リン合金めっき膜の内部ひずみに及ぼす亜鉛イオンの影響	竹内 貞雄・村川正夫	50	4	341	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	ダイヤモンド,耐摩耗性,応力
6432	無電解NiB被膜の結晶構造に及ぼす共析元素の影響	都留 豊・持永 光	50	4	347	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	ニッケル,リン,亜鉛イオン
6433	ソルゲルコーティング - Zr酸化物に覆われたアルミニウムのアノード酸化	金 満・飯塚 淳・久保宮敬幸・逢坂哲彌	50	4	353	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	ニッケル,ホウ素,結晶構造
6434		渡辺 恵司・坂入正敏・高橋 英明・平井 伸治・山口	50	4	359	1999	5:原著論文	B07.アノード酸化	ソルゲル,ジルコニウム,アルミニウム,アノード酸化

6436	アンモニア - アルカリ性水溶液からのCdTe電析におよぼすアンモニア濃度の影響	邑藤 邦明、中谷 巖、平藤 哲司、粟倉 泰弘	50	4	367	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Cd-Te,アンモニア,電析
6437	中性無電解銅めっきによるULSI銅配線の形成	縄舟 秀美、中尾誠一郎、水本 省三、村上 義樹、橋本 山岸 憲史、曾我 倫明、西羅 正芳、八重 真治、松田 斉藤 英之、八木 澄子、酒井 彰、三澤 俊平、田中 壽晃、相馬 英明、田中 大之、田村 元祐、中 宏守、前田 祐一、鬼村謙二郎、大石 勉	50	4	374	1999	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解,銅めっき,配線
6438	無電解めっきの活性化前処理におけるSnおよびPdの吸着量とCo-Pめっき皮膜の表面形態	山岸 憲史、曾我 倫明、西羅 正芳、八重 真治、松田 斉藤 英之、八木 澄子、酒井 彰、三澤 俊平、田中 壽晃、相馬 英明、田中 大之、田村 元祐、中 宏守、前田 祐一、鬼村謙二郎、大石 勉	50	4	378	1999	7:速報論文	B03.無電解めっき	無電解めっき,スズ,パラジウム,表面形態
6439	マイクロ波プラズマCVD法によるクロムめっき鉄鋼基板上でのダイヤモンド薄膜の合成	澄子、酒井 彰、三澤 俊平、田中 壽晃、相馬 英明、田中 大之、田村 元祐、中 宏守、前田 祐一、鬼村謙二郎、大石 勉	50	4	380	1999	7:速報論文	B01.化学蒸着(CVD)	プラズマCVD,ダイヤモンド,クロムめっき
6440	リポ酸誘導体の銅防食剤への応用	古賀 孝昭	50	4	382	1999	7:速報論文	B08.化成処理	防食剤,銅
6441	表面技術の多様性	古賀 孝昭	50	5	393	1999	1:巻頭言		
6442	「小特集 / めっき析出過程の基礎解析」の企画にあたって	本間 敬之	50	5	394	1999	3:解説		
6443	めっき析出過程の基礎解析手法	本間 敬之	50	5	395	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	めっき,解析
6444	透過型電子顕微鏡によるめっき膜中の混入不純物の観察	中原 昌平、沖中 裕	50	5	400	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	TEM,不純物,めっき膜
6445	光音響分光法および水晶振動子マイクロバランス法を用いた解析	吉原佐知雄	50	5	408	1999	24:トピックス	C07.その他(新技術を含む)	水晶振動子,光音響分光法
6446	デンドライト電析における結晶成長過程のシミュレーション	井出本 康	50	5	412	1999	24:トピックス	B02.電気めっき・電鍍	デンドライト,結晶成長
6447	電解槽の電流分布シミュレーション	小原 勝彦	50	5	416	1999	24:トピックス	C07.その他(新技術を含む)	電流分布
6448	磁場・重力場の影響を考慮した析出機構	青柿 良一	50	5	421	1999	24:トピックス	B02.電気めっき・電鍍	磁場,析出機構
6449	新電気化学入門 - 2	馬場 宣良	50	5	425	1999	17:講座	A10.その他(新技術を含む)	電気化学
6450	塗膜表面の状態分析へのFT-IRの活用	加川 邦博	50	5	431	1999	9:シリーズ-2	A05.塗布・塗装	塗膜,FT-IR
6451	自動車のボディーカラー - ソリッドとメタリック&パール -	坂内 恒雄	50	5	437	1999	10:比べてみよう	A05.塗布・塗装	自動車,塗装
6452	Co-Ni合金電析膜の微細構造	福室 直樹、近沢 正敏、渡辺 徹	50	5	441	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Co,Ni,合金,微細構造
6453	Co-Fe合金電析膜の微細構造	福室 直樹、近沢 正敏、渡辺 徹	50	5	448	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Co,Fe,合金,微細構造
6454	フッ化物水溶液中においてSUS304ステンレス鋼に生成した不動態皮膜の耐硫酸腐食性	柴田 俊夫、山崎 修、松浦 修、藤本 慎司	50	5	453	1999	5:原著論文	B08.化成処理	SUS304,不動態皮膜,フッ化物
6455	6-ジアリルアミノ-1,3,5-トリアジン-2,4ジチオールの有機めっきに及ぼすNaNO2の促進作用	森 邦夫、佐々木八重子、平原 英俊、大石 好行、田中 広瀬 洋一、梶が谷 洋史、大島 龍司、飯塚 完司、内田 衛、岡田 隆、縄舟 秀美、中尾誠一郎、水本 省	50	5	460	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	有機めっき,NaNO2
6456	平板状ダイヤモンド結晶における生成条件の検討	大石 好行、梶が谷 洋史、大島 龍司、飯塚 完司、内田 衛、岡田 隆、縄舟 秀美、中尾誠一郎、水本 省	50	5	467	1999	7:速報論文	A01.物理蒸着(CVD)	ダイヤモンド,結晶成長
6457	ギ酸を還元剤とする無電解パラジウムめっきの析出機構	内田 衛、岡田 隆、縄舟 秀美、中尾誠一郎、水本 省	50	5	469	1999	7:速報論文	B03.無電解めっき	ギ酸,パラジウム,無電解めっき
6458	Cr2O3封孔によるAl2O3溶射皮膜の改善と損傷特性	荻野 邦彦、大森 明、森本 純司、山本 渡、今林 亜夫、大川戸照男、安沢 友義、斉藤いほえ、田村 和男	50	5	471	1999	7:速報論文	A02.溶射	クロム,アルミナ,溶射,封孔
6459	高速めっきに対応したハルセルの特性	山本 渡、今林 亜夫、大川戸照男、安沢 友義、斉藤いほえ、田村 和男	50	5	473	1999	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	高速めっき,ハルセル
6460	21世紀の表面技術のために	縄舟秀美	50	6	497	1999	1:巻頭言		
6461	「小特集・気相合成ダイヤモンド薄膜の最近の動向」の企画にあたって	広瀬洋一	50	6	480	1999	23:小特集		
6462	純酸素中でのグラファイトレザ - アプレ - ションによるダイヤモンド薄膜の水素フリー - 気相合成	吉本 護、菱谷佳子	50	6	481	1999	3:解説	B01.化学蒸着(CVD)	レザ,ダイヤモンド,薄膜
6463	ダイヤモンドの電気化学反応への応用	八木 一三、藤嶋 伊藤 利道、八田 章光、平木 昭夫	50	6	486	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	ダイヤモンド,電気化学
6464	ダイヤモンド表面からの電子放出 - ディスプレイへの応用を目指して -	伊藤 利道、八田 章光、平木 昭夫	50	6	494	1999	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	ダイヤモンド,ディスプレイ,電子放出
6465	ダイヤモンド表面弾性波フィルタ	鹿田 真一	50	6	500	1999	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	ダイヤモンド,弾性波,フィルタ
6466	圧力センサー - 半導体ダイヤモンド薄膜の歪み抵抗効果 -	北畠 真、出口 正洋	50	6	505	1999	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	ダイヤモンド,センサー,歪み抵抗
6467	環境を考慮した最近の食品容器の動向	沖 慶雄	50	6	511	1999	2:総説	B09.その他(新技術を含む)	環境,食品
6468	金属容器における表面処理	吉田 昌之	50	6	516	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	容器,表面処理
6469	ガラス容器における表面処理	佐々木光雄	50	6	521	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	ガラス,表面処理
6470	食品包装用プラスチックフィルム・シート・容器に関する最近の表面処理	高橋 亨	50	6	526	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	包装,プラスチック,フィルム
6471	新電気化学入門(No.3)	馬場 宣良	50	6	532	1999	9:シリーズ-2	B09.その他(新技術を含む)	電気化学
6472	GD-OESによる金属表面薄膜の分析	清水 健一	50	6	538	1999	9:シリーズ-2	A10.その他(新技術を含む)	GD,OES,薄膜
6473	クロメート皮膜	伊崎 輝明、岡本 屋敷 貴司、岡本 明夫、木田 貴之、大山 英人	50	6	545	1999	10:比べてみよう	B08.化成処理	クロメート
6474	建材用酸洗仕上げ純チタン板の光沢度に及ぼす焼鈍条件の影響	平野 茂、大八木八七	50	6	547	1999	6:技術論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	酸洗い,チタン,焼鈍
6475	フェノールスルホン酸浴からのSnめっきに及ぼすSnイオン濃度と流速および電流密度の影響	柳 むつみ、軽部 健司、須田 新塚本由美子、海老原 健	50	6	553	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Snめっき,フェノールスルホン酸
6476	自己析出皮膜の析出機構	柳 むつみ、軽部 健司、須田 新塚本由美子、海老原 健	50	6	559	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	析出機構
6477	多層膜干渉を利用したアルミのウム陽極酸化皮膜の発色機構	日野 実、平松 実、出水 敬、辻川 正人、川本 信杉、村 博之、穂積 篤、牛山 和哉、高井 治、興戸 正純	50	6	565	1999	5:原著論文	B07.アノード酸化	多層膜,陽極酸化,アルミニウム
6478	レーザ照射したアルミニウム合金上の無電解Ni-Pめっき皮膜トライボロジー特性	日野 実、平松 実、出水 敬、辻川 正人、川本 信杉、村 博之、穂積 篤、牛山 和哉、高井 治、興戸 正純	50	6	571	1999	8:Letters	B03.無電解めっき	レーザ,アルミニウム,無電解めっき,トライボロジー
6479	親水 / 疎水基板へのメソポーラスシリカ膜の成長	日野 実、平松 実、出水 敬、辻川 正人、川本 信杉、村 博之、穂積 篤、牛山 和哉、高井 治、興戸 正純	50	6	574	1999	7:速報論文	A04.吸着	親水,疎水,ポーラスシリカ
6480	思考停止症	滝沢喜久男	50	7	581	1999	1:巻頭言		
6481	機能性プラズマポリマー膜の合成の試みと応用	稲垣 訓宏	50	7	582	1999	2:総説	B01.化学蒸着(CVD)	プラズマ,ポリマー
6482	プラズマ重合による金属の防食	入山 裕	50	7	589	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	プラズマ,重合,防食

6483	ポリイミド蒸着重合膜	飯島 正行、浮島 禎之、佐藤 昌敏、飯田 敬子、高橋 善和、佐々木重邦、松浦 敏、山本二三	50	7	596	1999	3:解説	A01.物理蒸着(CVD)	ポリイミド蒸着膜
6484	化学センサ用プラズマポリマー膜	杉本 岩雄	50	7	602	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	化学センサ、プラズマ
6485	新電気化学入門(No.4)	馬場 宣良	50	7	608	1999	9:シリーズ-2	A10.その他(新技術を含む)	電気化学
6486	集束イオンビーム(FIB)装置による部位指定TEM用試料作製	富田 雅人、飯塚 俊生	50	7	613	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	FIB,TEM
6487	赤外線イメージング用デバイス - 光電変換素子の違いによる比較	瀬山 倫子	50	7	618	1999	10:比べてみよう	C07.その他(新技術を含む)	光電変換素子、赤外線
6488	反射型カラーLCD用反射板の凹凸形状設計	鷲塚 諫、津田 和彦、枅川 正也、縄舟 秀美、北村 浩司、水本 省三、内田 衛、岡田 隆原 基、北川 善朗、佐藤 芳幸、川嶋 朝日	50	7	621	1999	5:原著論文	C07.その他(新技術を含む)	LCD
6489	ULSI銅配線の形成を目的としたエチレンジアミン錯体浴からの銅電析	内田 隆原 基、北川 善朗、佐藤 芳幸、川嶋 朝日	50	7	625	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	ULSI,エチレンジアミン錯体,Cu
6490	Ti:Al金属間化合物の高温酸化に及ぼすレーザ表面処理の効果	牧野 英司、山下泰二郎、柴田 隆行	50	7	630	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	Ti,Al,高温酸化,レーザ
6491	電解フォトエッチングによる金属基板上の微細パターン形成	大澤 伸夫、福岡 潔	50	7	637	1999	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	フォトエッチング,微細パターン
6492	電解コンデンサ用アルミニウム箔の直流エッチング挙動に及ぼす結晶性酸化物の	重松 一典、中村 守、山田 康雄、斉藤 尚文、馬淵 守、中西 勝、下島 三上 俊秀、石川 豊、山中 博、広瀬 洋一	50	7	643	1999	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	電解コンデンサ,Al,エッチング,酸化物
6493	シリコンを用いたレーザアロイングによるAZ91Dマグネシウム合金の表面処理	藤 尚文、馬淵 守、中西 勝、下島 三上 俊秀、石川 豊、山中 博、広瀬 洋一	50	7	648	1999	7:速報論文	A10.その他(新技術を含む)	レーザ,マグネシウム合金
6494	ダイヤモンドを陰極とした直流プラズマCVD法によるダイヤモンド薄膜の高速合成	穂積 篤、牛山 和哉、杉村 博之、高井 治	50	7	650	1999	7:速報論文	B01.化学蒸着(CVD)	ダイヤモンド,CVD,薄膜
6495	疎水 / 親水マイクロ領域からなる不均一表面の微小水滴	山下 嗣人	50	7	652	1999	7:速報論文	B09.その他(新技術を含む)	疎水,親水,不均一表面
6496	第99回講演大会報告 (社)表面技術協会創立50周年記念 第100回講演大会への誘い	久米 道之	50	7	654	1999	22:技術資料		第99回
6497	表面技術とイオン交換	和田 洋六	50	8	661	1999	1:巻頭言		
6498	イオン交換体の設計と輸送現象	須藤 雅夫	50	8	662	1999	2:総説	B09.その他(新技術を含む)	イオン交換
6500	電気再生式純水装置	原田 克範	50	8	667	1999	3:解説	B09.その他(新技術を含む)	イオン交換
6501	ニッケルめっきの透析膜処理	久保井義夫	50	8	674	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	純水装置
6502	新イオン交換膜による酸回収	寺田 一郎	50	8	678	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	Ni, 透析膜
6503	イオン交換樹脂による酸と金属の分離	阿部 裕士	50	8	683	1999	3:解説	C06.洗浄	イオン交換膜, 酸回収
6504	電解透析方によるめっき液のリサイクル	高橋 昇	50	8	687	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	電解透析, リサイクル
6505	AIアノード酸化とレーザ照射を利用した金属微細構造の作製 - 新LiGAプロセスを目指して -	菊地 竜也、清 松 竹、加藤 善大、坂 正敏、高橋 英	50	8	692	1999	3:解説	C03.化学エッチング・電解エッチング	アノード酸化, LiGA, レーザ
6506	マイクロ電極システムを用いた生体材料の局所機能探索と応用	未永 智一	50	8	697	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	マイクロ電極, 生体材料
6507	HFC系冷媒を用いた冷凍冷蔵庫回路の評価	志水 康彦、滝沢 貴久男	50	8	705	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	HFC, 冷蔵庫
6508	新電気化学入門(No.5)	馬場 宣良	50	8	710	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	電気化学
6509	ミクロ構造解析の再検証 - 主としてウルトラミクロトームによる電顕試料の観察例 -	朝倉健太郎	50	8	716	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	ミクロトーム, 電子顕微鏡
6510	銀塩カメラとデジタルカメラ	大工原茂樹	50	8	722	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	カメラ
6511	活性化反応蒸着法による窒化インジウム薄膜のエレクトロクロミック特性に及ぼす	南 千洋、鈴木 理之、湯本 久美	50	8	729	1999	10:比べてみよう	C07.その他(新技術を含む)	CVD, 窒化インジウム, エレクトロクロミズム, 酸素
6512	高周波イオンプレーティングによる金 - 銅合金薄膜の形成	上条 幹人、勝又 信行、日原 政彦、児嶋 弘直	50	8	733	1999	5:原著論文	B01.化学蒸着(CVD)	イオンプレーティング, 金, 銅, 合金
6513	ニッケルめっき膜の引っ張り応力に及ぼす溶液内アルミニウムイオンの影響	津留 豊、占部 俊二、田淵 誠	50	8	738	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	引っ張り応力, ニッケルめっき, アルミニウムイオン
6514	冷却水系での軟鋼の腐食に対するアクリル酸 / カフェ酸アミド系二元共重合体およびその類縁体の効果	関根 功、小村 亮、湯浅 真、和氣 敏治、村田 浩陸、染谷新太郎、宇田 篠原 稔雄	50	8	745	1999	5:原著論文	A04.吸着	軟鋼, 腐食, アクリル酸, カフェ酸アミド
6515	景観と色彩	北原 洋明	50	9	751	1999	1:巻頭言	C01.機械研磨・研削	
6516	大型・超高精細液晶パネルと透明導電膜プロセスの新しい役割	宋 豊根、重里 有	50	9	763	1999	2:総説	C07.その他(新技術を含む)	液晶, 透明導電膜
6517	透明導電膜の構造制御	高橋誠一郎、久保田高史	50	9	764	1999	3:解説	B01.化学蒸着(CVD)	透明導電膜, 構造制御
6518	ITOターゲットのノジュール生成機構	酒見 俊之、牛神 善博、粟井 清	50	9	770	1999	3:解説	B01.化学蒸着(CVD)	ITO, ノジュール
6519	イオンプレーティングによるITO成膜技術	伴 厚志	50	9	776	1999	3:解説	A01.物理蒸着(PVD)	イオンプレーティング, ITO
6520	ITOドライエッチングとパターンニング技術	板谷 謹悟	50	9	782	1999	3:解説	C04.気相エッチング	ドライエッチング, ITO, パターンニング
6521	原子レベルで制御された電極反応	馬場 宣良	50	9	786	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	電極反応
6522	光学顕微鏡の正しい使い方(2) - 表面マイクロトポグラフィーの観察 -	小松 啓	50	9	791	1999	9:シリーズ-2	A10.その他(新技術を含む)	電気化学
6524	化学電池と物理電池	宇井 幸一	50	9	801	1999	9:シリーズ-2	B09.その他(新技術を含む)	マイクロトポグラフィー
6525	アルカリ浸漬脱脂での脱脂要因と効果	須山 總	50	9	809	1999	10:比べてみよう	C07.その他(新技術を含む)	電池
6526	電解コンデンサ用アルミニウム箔の交流エッチング時の初期ピット形成に及ぼすTi	大沢 伸夫、福岡 潔	50	9	813	1999	5:原著論文	C06.洗浄	アルカリ, 脱脂
6527	電解コンデンサ用高純度アルミニウム箔のピット形成に及ぼす電解液浸漬時間の	大沢 伸夫、本居 徹也、福岡 潔	50	9	819	1999	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	電解コンデンサ, アルミニウム, チタンエッチング
6528	アルミニウムアノード酸化 / レーザ照射 / 電気めっきを用いた微細回路板の作製	菊地 竜也、坂入 正敏、高橋 英明、阿部 芳彦、片山 日野 実、平松 実、山脇 巧、金谷 吉本 信子、石川 正司、森田 昌行	50	9	824	1999	5:原著論文	C03.化学エッチング・電解エッチング	電解コンデンサ, アルミニウム, ピット
6529	界面活性剤を添加したZn - Ni合金めっき皮膜の組成分布	海老名延郎	50	9	829	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	アノード酸化, レーザ, 微細回路
6530	有機溶媒電解液中でのマグネシウムの電気化学的挙動	大見 忠弘	50	9	836	1999	13:研究ノート	B02.電気めっき・電鍍	界面活性剤, Zn, Ni, 合金めっき
6531	表面技術協会の魅力とは	若山 恵英、小林 貞雄	50	9	839	1999	7:速報論文	A10.その他(新技術を含む)	有機溶媒, マグネシウム
6532	半導体製造プロセスにおけるクリーン化技術	菅野 至	50	10	847	1999	1:巻頭言	C06.洗浄	半導体, クリーン化
6533	クリーンルーム空気質の制御技術		50	10	848	1999	1:巻頭言	C07.その他(新技術を含む)	クリーンルーム
6534	ウエハ洗浄技術		50	10	855	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	ウエハ
			50	10	861	1999	3:解説	C06.洗浄	ウエハ

6535	ウェットプロセスで用いられている高性能薬液	板野 充司、毛塚 建彦	50	10	867	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	ウェットプロセス
6536	超純水技術(製造・分析技術と機能水)	森田 博司	50	10	873	1999	3:解説	C06.洗浄	超純水
6537	ウェーハ表面の欠陥検査システム	服部 寿	50	10	879	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	ウェーハ、検査
6538	化学汚染の評価分析技術	竹田 菊男	50	10	887	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	化学汚染
6539	新電気化学入門(No.7.最終回)	馬場 宣良	50	10	894	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	電気化学
6540	半導体プロセス評価に対する表面分析技術	黒川 博志	50	10	901	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	半導体
6541	TiC, TiN, c - BN	伊藤 滋	50	10	907	1999	10:比べてみよう		TiC, TiN, c - BN
6542	混合原子価モリブデンオキシ水酸化物皮膜の電析とそのキャラクタリゼーション	金野 英隆、伊藤 隆史、尾谷 賢、笹木 圭子	50	10	909	1999	4:技術解説	B02.電気めっき・電鍍	混合原子価、モリブデン
6543	Pd / Sn混合触媒を用いた銅ダイレクトブレーティングにおける導体化過程の解析	飯塚 淳、中本 剛輔、内藤 和久、本間 敬之、中尾 英弘、奥野 和義、達 纒、舟 秀美、池田 一輝、芝 一博、水本省三、武内 孝夫、青木 和博、縄 秀美、城口 慶子、谷久保正人、水本 省三、小橋 康人、武内 孝夫、牧野 英司、中村 晃久、柴田 隆久	50	10	915	1999	5:原著論文	B03.無電解めっき	Pd, Sn, 触媒、銅
6544	メタンスルホン酸浴からのスズ - 銅合金めっき	一輝 芝 一博、水本省三、武内 孝夫、青木 和博、縄 秀美、城口 慶子、谷久保正人、水本 省三、小橋 康人、武内 孝夫、牧野 英司、中村 晃久、柴田 隆久	50	10	923	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	スズ、銅、合金めっき
6545	2 - アミノエタノールを還元剤とする無電解銀めっき	慶子、谷久保正人、水本 省三、小橋 康人、武内 孝夫、牧野 英司、中村 晃久、柴田 隆久	50	10	928	1999	5:原著論文	B03.無電解めっき	無電解めっき、銀
6546	金有機化合物のレーザ熱分解によるグレースアルミナ基板上の配線パターン形溶射アルミナ皮膜における耐はく離性の非破壊的評価	伊藤 亨、肥田 昭	50	10	933	1999	5:原著論文	C07.その他(新技術を含む)	金、レーザ、アルミナ
6547	アルミニウム合金のCO2レーザ溶融性に及ぼすポリシラザン被膜の影響	西田 典秀、国次 真輔、金谷 輝人、大塚 利彦、米田 福島 誠、植木 裕、滝沢貴久男、須 斎 嵩、山下 嗣人	50	10	941	1999	7:速報論文	C07.その他(新技術を含む)	アルミニウム、レーザ、CO2
6549	熱交換器用銅合金の腐食挙動	須 斎 嵩、山下 嗣人	50	10	943	1999	7:速報論文	A10.その他(新技術を含む)	銅合金
6550	アトムレベルでの表面技術	板谷 謹悟	50	11	949	1999	1:巻頭言		
6551	マイクロファブリケーション	牧野 英司	50	11	950	1999	2:総説	B09.その他(新技術を含む)	
6552	厚膜レジストSU - 8によるLIGAライクブ	川畑 達央	50	11	956	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	レジスト、LIGA
6553	ダイヤモンド薄膜のマイクロマシニング	柴田 隆行	50	11	961	1999	3:解説	C05.電解加工	ダイヤモンド薄膜、マイクロマシニング
6554	光造形によるマイクロファブリケーション	山口 勝美、中本 土居 陽	50	11	968	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	光造形、マイクロファブリケーション
6555	薄膜形成装置の開発動向(エピタキシャル装置など)	土居 陽	50	11	975	1999	3:解説	C07.その他(新技術を含む)	
6556	ドライブプロセス技術と地球環境	和佐 清孝	50	11	979	1999	3:解説	A01.物理蒸着(PVD)	ドライブプロセス、環境
6557	化学反応制御のための表面と表面技術	西山 諒行	50	11	984	1999	12:武井記念シリーズ	B01.化学蒸着(CVD)	化学反応
6558	レーザ照射型チャンネルフロー電極法による水溶液中の鉄電極表面反応の解析	板垣 昌幸	50	11	991	1999	9:シリーズ-2	C07.その他(新技術を含む)	レーザ、鉄
6559	高温酸化によりTi窒化物上に作製したTiO2皮膜の光アノード分極特性	原 基、三好 徹治、真山 恵次、阿部 吉次、米山 孝夫、井上 和之、牛戸 美樹、瀬尾 眞浩	50	11	997	1999	5:原著論文	B06.熱処理(酸化・窒化・炭化)	高温酸化、TiN、TiO2、アノード分極
6560	めっきで形成した銅パンプとはんだとの接合部の高温耐久性	真山 恵次、阿部 吉次、米山 孝夫、井上 和之、牛戸 美樹、瀬尾 眞浩	50	11	1005	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	銅パンプ、はんだ
6561	電気化学的に合成したNi(OH)2膜およびNiOOH膜の選択的イオン透過性	真浩	50	11	1010	1999	5:原著論文	B09.その他(新技術を含む)	Ni、イオン透過性
6562	銀の無電解めっき反応における磁場効果	真一、岩坂 奉倫、青柿 良一	50	11	1015	1999	5:原著論文	B03.無電解めっき	銀、無電解めっき、磁場効果
6563	プラズマソースイオン注入法によるTiO2薄膜の作製	畑田 瑠璃子、馬場 恒明、山田 耕太、長谷川 淳一、佐藤 修彰、藤野 威男	50	11	1019	1999	7:速報論文	A08.イオン注入	イオン注入、TiO2
6564	静電噴霧法を用いたTa2O5薄膜作製におけるCO2レーザによる熱処理の効果	山田 耕太、長谷川 淳一、佐藤 修彰、藤野 威男	50	11	1021	1999	8:Letters	A10.その他(新技術を含む)	Ta2O5、CO2レーザ、熱処理
6565	魅力ある表面技術協会への期待	美浦 隆	50	12	1027	1999	巻頭言		
6566	'特集 / 環境と表面技術' 企画に当たって	土橋 誠	50	12	1028	1999			
6567	欧州(ドイツ)における環境規制の動向	福田 勲	50	12	1029	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	
6568	日本における環境規制の動向	矢部 賢	50	12	1037	1999	3:解説		環境規制
6569	無廃水処理エコーレーティング	久米 道之	50	12	1045	1999	3:解説		廃水処理、エコーレーティング
6570	環境カウンセラー登録制度とその活動状況	波村 多門	50	12	1052	1999	3:解説		
6571	環境先進国ドイツにおけるスラッジ処理及び排ガス処理	松尾 隆	50	12	1058	1999	3:解説		スラッジ、排ガス
6572	鉛フリーはんだ開発の現状	菅沼 克昭	50	12	1063	1999	3:解説	B02.電気めっき・電鍍	鉛、はんだ
6573	光触媒反応を利用する環境浄化	橋本 和仁、野口 寛、渡部 俊也	50	12	1071	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	触媒、環境
6574	労働災害における眼表面の傷害	仁木 高志	50	12	1078	1999	3:解説		労働災害
6575	自動車分野の環境に対応する表面処理	別所 毅	50	12	1085	1999	3:解説		自動車
6576	電子機器・OA機器のリサイクル化 - クローズドループリサイクルシステムによるゼロ・エミッションへの挑戦	小波 弘明	50	12	1091	1999	3:解説	A10.その他(新技術を含む)	クローズドシステム、ゼロエミッション
6577	インドの電気めっきと廃水処理の現状	笠原 暢順	50	12	1096	1999	19:寄稿		廃水処理
6578	無電解ニッケルめっき浴用次亜リン酸ニッケルの製造	堀川 健、三田 宗雄、中尾 英弘、笹岡 正伸、和 田 泰一、松本 幹治、小林 健吾、文村 邦浩、和 田 洋六、黒田 弘弘	50	12	1103	1999	6:技術論文	B03.無電解めっき	次亜リン酸、ニッケル、無電解めっき
6579	逆洗を伴うクロスフロー精密ろ過による重金属水酸化物の分離	和 田 泰一、松本 幹治、小林 健吾、文村 邦浩、和 田 洋六、黒田 弘弘	50	12	1108	1999	6:技術論文	A10.その他(新技術を含む)	精密ろ過、重金属
6580	クローズド型水系洗浄システム	和 田 洋六、黒田 弘弘	50	12	1113	1999	6:技術論文	C06.洗浄	クローズドシステム、洗浄
6581	逆浸透膜法とイオン交換法による表面処理廃水のリサイクル	和 田 洋六、黒田 弘弘	50	12	1118	1999	5:原著論文	C06.洗浄	イオン交換、リサイクル
6582	鉛フリーはんだ用Sn - Cu合金めっき	福田 光修、平川 康一、松本 泰道	50	12	1125	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Sn, Cu, 合金めっき
6583	鉛浴浸漬による溶融亜鉛めっきドロスからの亜鉛の分離回収	沖 猛雄、兼松 秀行、市野 良一	50	12	1130	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	溶融亜鉛、回収
6584	硝酸イオン除去に及ぼす銅 - 白金触媒の表面組成の影響	柴田 正実、高山 綾子、古屋 長一、中村 誠、田中 浩和、吉原 佐知雄、白 櫻 高史	50	12	1137	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	硝酸イオン、Cu, Pt, 触媒
6585	鉛フリーはんだにおけるイオンマイグレーションの水晶振動子マイクロバランス法によるin situ評価	柴田 正実、高山 綾子、古屋 長一、中村 誠、田中 浩和、吉原 佐知雄、白 櫻 高史	50	12	1142	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	水晶振動子、マイクロバランス、はんだ

6586	冷却水系での腐食抑制剤としてのカルボキシル基を有する高分子系の効果:分子構造と腐食抑制能の相関	湯浅 真、押部 哲治、石井 辰宏、鈴木 篤、相沢 匡、矢島 秀治、秋山 一成、関根 功、今浜 敏信、和氣 敏治、村田 浩	50	12	1147	1999	5:原著論文	A04.吸着	腐食抑制剤、分子構造
6587	3価Crめっき浴からのCr-P-C合金めっき皮膜の耐食性	中出 卓男、森河 務、佐藤 幸弘、横井 昌幸	50	12	1153	1999	5:原著論文	B02.電気めっき・電鍍	Cr, P, C, 耐食性、合金めっき
6588	陰極析出酸化亜鉛皮膜の電解条件による光触媒機能への影響	飯村 修志、千葉 晁生、吉原佐知雄、白樫 高史、伊崎	50	12	1158	1999	5:原著論文	A10.その他(新技術を含む)	光触媒、酸化亜鉛、被膜
6589	電気透析によるスルファミン酸銅/スルファミン酸ニッケル合金多層膜めっき水洗水からのニッケル、銅および水の回収	矢嶋 恭子、久米 道之	50	12	1162	1999	5:原著論文	C07.その他(新技術を含む)	Cu, Ni, 多層膜、電気透析
6590	無電解めっきにより析出させたPd粒子のメタン燃焼触媒活性に対するリン含有量の影響	小早川絃一、数野 敦史、千葉 史、米倉喜一郎、佐藤 祐一、福原 長寿、五十嵐 哲	50	12	1167	1999	7:速報論文	B03.無電解めっき	Pd, リン酸、燃焼触媒
6591	電気Ni-W合金めっきの超寿命化	森河 務、中出 卓男、佐藤 幸弘、横井 昌幸、石田 伊藤征司郎、倉木 淳、多田 弘明、岩崎 光伸	50	12	1171	1999	7:速報論文	B02.電気めっき・電鍍	Ni, W, 合金めっき
6592	光触媒活性を有するチタン陽極酸化皮膜材の作製	藤原 裕、檜木 洋介、榎本 英彦、植原泰栄子、船田	50	12	1171	1999	8:Letters	B07.アノード酸化	Ti, 陽極酸化、光触媒
6593	Agナノ粒子懸濁ピロリン酸浴からのSn-Ag合金めっき	藤原 裕、檜木 洋介、榎本 英彦、植原泰栄子、船田	50	12	1173	1999	8:Letters	B02.電気めっき・電鍍	Ag, Sn, ピロリン酸、ナノ粒子